高分子溶液熱力学 — 相平衡の理解 —

奈良女子大学名誉教授 榮永 義之



平成21年7月2日

まえがき

高分子溶液における相平衡、相分離の問題は古くからの課題である。この書き物は熱力学現象論に基礎において、高分子溶液に観測される相図の 記述法を解説したものである。

第1章は、一般に相平衡の問題を取り扱うにあたって基礎となる熱力学の基本的事柄を纏めた章である。

第2章では、単分散高分子と溶媒の2成分系を対象として、相平衡を扱うのに2つの現象論的方法があることを示す。その1つはFlory-Huggins 理論に基いて相互作用パラメータを温度と溶液濃度の函数とする方法であ り、もう1つは浸透圧に対する van't Hoff の式を基準とし、相互作用パラ メータとして濃度の函数とする見かけの第2ビリアル係数を用いる方法で ある。この章ではそれらの相互作用函数が光散乱法から決定できること、 およびその結果、それらの函数が温度のみならず溶液濃度ならびに高分子 の分子量にも依ることを示す。それらの函数を用いると2成分溶液の曇点 曲線、共存組成曲線などが定量的に記述できることを説明する。さらに、 第2の方法の方が相互作用函数はより簡単な式となることを示す。

第3章では、化学種が同じで分子量のみ異なる高分子2成分と溶媒の3 成分系および一般に分子量分布を持つ溶質高分子と溶媒から成る準2成分 系を対象とする。第2章の見かけの第2ビリアル係数を拡張することによ り、相互作用函数についての比較的簡単な式を用いて3成分系の相図が定 量的に表しうることを説明する。また、分子量が大きく異なる3成分溶液 では、理論が予測するとおり、3相が現れることを示す。

第4章では、化学種の異なる異種高分子2成分と溶媒の3成分系を取り 扱う。この3成分系の相互作用函数は、各高分子と溶媒の2成分系に対す る相互作用函数とその溶媒中における高分子間相互作用を表す函数を用い て表せること、それらが対応する2成分溶液および3成分溶液に対する光 散乱測定から決定できることを説明する。その結果を用いると異種高分子 3成分溶液の相図(曇点曲線、双交曲線など)がほぼ定量的に再現できる ことを示す。 この短い書き物は、著者らが行ってきた現象論的手法による高分子溶液の相平衡の研究を中心に、古くから多くの著名な研究者によって成されて きた研究を簡潔に纏めたものである。

繰り返し、繰り返し、繰り返し試みよ これこそは、汝の守るべき教訓なり。 初めに成功することなくとも 繰り返し、繰り返し、繰り返し試みよ。 されば、勇気も湧き起こるべし たゆまず、屈せず、やむことなくば、 ついに勝利をうべし、恐るるなかれ、 繰り返し、繰り返し、繰り返し試みよ。 ーヒクソンー 目 次

目 次

1章	熱力学の基本事項	1
1.1	定義	1
1.2	熱力学第一法則	4
1.3	熱力学第二法則	6
1.4	平衡判定条件	8
1.5	特性函数 (母函数)	11
1.6	開放系	14
	1.6.1 部分モル量 - 化学ポテンシャルー	14
	1.6.2 組成変数と濃度変数	20
1.7	多成分多相系の相平衡条件....................	23
1.A	「火の動力に関する考察」―サディ・カルノー―	25
2章	2 成分高分子溶液の相平衡	33
2.1	2 成分系の相平衡	38
	2.1.1 Flory-Huggins 理論	39
	2.1.2 Flory-Huggins 理論に基く現象論	46
2.2	現象論1............................	48
	2.2.1 アタクチックポリスチレン + シクロヘキサン系	50
	2.2.2 ポリイソプレン + ジオキサン 系	61
2.3 現象論 2		64
		69
$2.\mathrm{B}$	揺らぎと光散乱	76
$2.\mathrm{C}$	関連する人々 (溶液論・光散乱理論)	85
3章	高分子多成分溶液の相平衡	89
3.1	一般論	89
3.2	準2成分系の相平衡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
	3.2.1 分離因子	97
3.3	同種高分子3成分系の相平衡	99
	3.3.1 3相平衡	107
3.4	同種高分子多成分系の現象論..................	110

	3.A	3成分系の化学ポテンシャルと混合 Gibbs 自由エネルギー	113
	$3.\mathrm{B}$	系の安定性	118
	$3.\mathrm{C}$	曇点、尖点、臨界点の決定...............	123
41	章	異種高分子3成分溶液の相平衡	129
	4.1	曇点曲線と双交曲面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	131
	4.2	一般論	136
	4.3	3 成分系の光散乱	139
	4.4	現象論による相図の表現	146
	4.A	3成分系に対する相互作用函数の導出	150
	4.B	3成分系に対する光散乱式の導出	152
	$4.\mathrm{C}$	3 成分系に含まれる各2成分系の相互作用函数の経験式	155
	4.D	混合溶媒と高分子から成る3成分系の相平衡	158

1章 熱力学の基本事項

熱力学は物質の状態変化を取り扱う一般的な現象理論である。この理論は 実質的にエネルギーおよびエントロピーに関する2つの基本法則を基礎に しており、極めて普遍的なものである。よく引用されている Einstein の 言葉を借りると¹

"A theory is the more impressive the greater the simplicity of its premises, the more varied the kinds of things that it relates and the more extended the area of its applicability. Therefore classical thermodynamics has made a deep impression on me. It is the only physical theory of universal content which I am convinced, within the areas of the applicability of its basic concepts, will never be overthrown."

- A. Einstein (1949) -

「理論というものは、その前提が単純であるほど、また理論が関係づけ る事柄が多様であるほど、そしてその適用範囲が広いほど、より印象深く なる。それゆえ、古典熱力学は私に深い感銘を与えた。熱力学は、その基 本概念の適用範囲内では決して覆されることがないだろうと私が確信して いる普遍的内容を持つ唯一の物理理論である。」

ということである。

この章では高分子溶液の熱力学、特に相平衡の取り扱い、に向かって必要になるであろう熱力学における基本的事項を纏める。熱力学の詳細については適切な書物を参照されたい。^{2,3,4,5,6}

1.1 定義

熱力学では自然界 (宇宙) を 2 つの部分に分ける。その 1 つは考察の対
 象領域で系 (system) と呼ばれる。残りの部分は外界 (surroundings) と云



☑ **1.1** Albert Einstein (1879/3/14−1955/4/18)

う。系の状態変化はその系と外界との相互作用によって引き起こされる。 この相互作用の有り方によって系は3種類に分類される。

- 「閉鎖系」(closed system)外界との間でエネルギーのやりとりはす るが、物質のやりとりは無い系。
- 「開放系」(open system) 外界との間にエネルギーと物質両方のや りとりがある系。
- 「孤立系」(isolated system) 外界との間にエネルギーのやりとりも 物質のやりとりも無い系。

系はまたそれを構成する成分の数によって、1成分系、2成分系、・・、 多成分系に分かれる。ここで、成分(component)とは独立にその物質量 を変化させることができる化学種のことを云う。

系の状態を規定する量あるいは系の状態によって決まる量を状態量(state propery)と云う。状態量には2種類がある。その1つは系の大きさに依らない量で示強性状態量(intensive property)と呼ばれる。もう1つは系の大きさによる(比例する)量で、示量性状態量(extensive property)と呼ばれる。前者には温度、圧力、密度、濃度、屈折率、誘電率等があり、後者には体積、質量、エネルギー、エントロピー等がある。2つの示量性状態量の比は示強性状態量になる。例えば、系の質量と体積の比である密度、

ある成分の量と全成分の量の比である濃度(あるいは分率)は示強性状態 量である。

系はまたそれが含んでいる相の数によって、相が単一のとき単相系 (single phase system)、2 つ以上のとき多相系 (multiphase system) と分類され る。前者はまた均一系 (homogeneous system) と呼ばれ、後者は不均一系 (heterogeneous system) と呼ばれる。ここで、相 (phase) とは示強性状態 量が均一すなわち一定値を持っている空間領域を云う。典型的な相には気 相、液相、固相がある。また、2 つ以上の成分を含む多成分系では組成を 異にするいくつかの液相あるいは固相が存在しうる。相境界では少なくと も 1 つの示強性状態量の値が不連続になっている。

系が含むいずれの相においても示強性状態量が均一すなわち場所によらず 一定値を持ち、それが時間によって変化しない状態を平衡状態 (equilibrium state) と云う。平衡状態にある系を平衡系と云い、その他の系を非平衡系 と云う。非平衡系では示強性状態量は場所により異なった値を持ち、一般 に時間とともに変化する。

系の状態を表すのに必要かつ充分な数の状態量を状態変数 (state variable) と云う。状態変数は状態量のうちから随意に選んでよい。必要な示強性状態変数の数は平衡状態にある系が含む成分数と相の数に依る。この関係を与えるのが Gibbs の相律 (Gibbs' phase rule) である。

$$\Phi = C + 2 - P \tag{1.1}$$

ここで、 Φ は独立な示強性状態変数の数で自由度と呼ばれる。また、C は 成分数、P は相の数である。なお、Gibbs の相律は系に含まれる全ての相 に全ての成分が存在する単純系についてのみ成立する。この関係による と、あらゆる状態量は Φ 個の示強性状態変数の函数として表される。ち なみに、示量性状態変数については必要かつ充分な数は $\Phi + 1$ 個である。

系を平衡状態に保つためには外界の状態変数を一定にする。これを外的 束縛条件 (external constraints) と云う。この束縛条件を変更すると、系 は新たな平衡状態へと移行する。



☑ **1.2** James Prescott Joule (1818/12/24−1889/10/11)

1.2 熱力学第一法則

熱力学第一法則は系と外界とをあわせた全エネルギーは一定不変である というエネルギー保存則を表す。系の内部エネルギー(internal energy)を *U*、系と外界とでやりとりする熱(heat)を*Q*、仕事を*W*とすると、微分 形では

$$\mathrm{d}U = \bar{\mathrm{d}}Q + \bar{\mathrm{d}}W \tag{1.2}$$

と表される。この法則は系が平衡状態にあるか否かを問わず、また、系 を構成する物質の種類や量を問わず成立する普遍的関係である。ここで、 熱と熱エネルギー (thermal energy) は区別されねばならない。熱エネル ギーは系を構成する物質の運動エネルギーの総和で示量性状態量である。 これに対して熱は空間を移動した熱エネルギーであって、状態量ではな い。内部エネルギーは系を構成する物質が持つあらゆるエネルギーの総和 である。これには熱エネルギー (運動エネルギー)、位置エネルギー (ポテ ンシャルエネルギー)、化学結合エネルギー、分子間相互作用エネルギー、 原子核内の結合エネルギー等が含まれる。極端な場合、相対論から導かれ る $E = mc^2(E:$ エネルギー、m:質量、c:光速)によると c^2 を係数として、 物質の質量はエネルギーと同等であるので物質そのものも含まれる。ただ し、熱力学では系の状態変化を取り扱うので、状態変化に伴って変化する エネルギーのみを内部エネルギーに含め、変化しないエネルギーは対象外 とする。式 (1.2) で、U は状態量であるので dU はその微分量を表してお り、この d は完全微分 (exact differential あるいは total diferential) と呼



☑ **1.3** Julius Robert von Mayer (1814/11/25−1878/3/20)

ばれる。一方、 $Q \geq W$ は状態量ではなく、系と外界とでやりとりをする 量であり、dQ、dWは単にそれらが無限小であることを示しているにす ぎない、したがって、dは微分ではなく、不完全微分 (inexact differential) と呼ばれる。式 (1.2) において、これらの量は系が吸収する方向を正にと ることにする。

いま、仕事 W が系の体積変化に伴う力学的仕事のみであるとする。外 界の圧力 p'の下で、系の体積 V が dV だけ変化したとすると

$$\bar{\mathrm{d}}W = -p'\mathrm{d}V \tag{1.3}$$

である。この式で、仕事に関係するのは外界の圧力であることに注意されたい。この変化の過程では系は不均一であり、一般には系の圧力 *p* は定義できない。式 (1.3) を式 (1.2) に代入すると

$$\mathrm{d}U = \bar{\mathrm{d}}Q - p'\mathrm{d}V \tag{1.4}$$

となる。変化の過程において、系内の圧力分布が均一で一定であるとき、 この一定値で圧力 p を定義する。また、p が定義でき、それが外界の圧力 p' と一致しているとき、力学平衡が成り立つと云い、その過程を定圧過程 (isobaric process) と云う。このとき、式 (1.4) で p' = p とおいて

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q - p\mathrm{d}V \tag{1.5}$$

が得られる。



☑ 1.4 Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822/1/2−1888/8/24)

1.3 熱力学第二法則

熱力学第二法則は系の状態変化の方向に対する指針を与える重要な法則 である。その表現には有名な次の2つがある。

- 「Clausius の原理」何の影響も残すことなく、熱を低温から高温へ 移すことはできない。
- 「Kelvin(Thomson)の原理」熱源から吸収した全ての熱を仕事に転 化するサイクル(機関)(第二種永久機関)は存在しない。

第二法則が云っていることを理解するために次の2つの過程を考える。 1つは系の状態がひとりでに有限の速度で変化していく過程で、自発過程 (spontaneous process)と呼ばれる。この過程は制御不能で、一般に不可 逆過程 (irreversible process)である。もう1つは外的束縛条件を制御して 系が平衡状態をたどるように変化させる過程で、準静的過程と呼ばれる。 準静的過程は可逆過程 (reversible process) に準じる。可逆過程とは、系 がある状態から他の状態に移り、また元の状態に戻ったとき、系と外界と もに原状に戻る過程を云う。これに対して、不可逆過程では系、外界とも には原状に復しない。大抵の場合、系を元に戻したとき、外界への熱の移 動あるいは仕事のやりとりを伴う。

熱力学第二法則の数学的表現はこれら2つの過程に対し、エントロピー Sを用いて次のように与えられる。



☑ 1.5 William Thomson (Lord Kelvin) (1824/6/26−1907/12/17)

自発過程に対して

$$\mathrm{d}S > \frac{\mathrm{\bar{d}}Q}{T'} \tag{1.6}$$

準静的過程に対して

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T} \tag{1.7}$$

ここで、系は温度 T'の外界から微少の熱 dQを受け取った過程を想定 している。ただし、準静的過程では系は平衡状態をたどるので、当然系 と外界の間に熱平衡が成立している。したがって系の温度 T が定義でき、 T = T'である。式 (1.6) は Clausius の不等式、式 (1.7) は Clausius の 等式と呼ばれる。これら 2 つの式を熱力学第二法則として認めると熱力学 の展開が容易になる。また、これらの式から上記の clausius の原理あるい は Kelvin の原理を証明するのはそれほど困難ではない。ただし、逆はそ れほど容易ではない。

先にも述べたように、エントロピー*S*は示量性状態量である。これは元来 可逆過程 (Carnot サイクル) に対して Q/T が状態量であることを Clausius が発見して導入した量である。その意味で式 (1.7) はエントロピー*S* の熱 力学的定義であると云える。(この式はまた温度 *T* の熱力学的定義と見る こともある。)

式 (1.6) と (1.4) より、不可逆過程に対して

$$\mathrm{d}U < T'\mathrm{d}S - p'\mathrm{d}V \tag{1.8}$$

が得られる。また、式 (1.7) を式 (1.5) に代入すると

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V \tag{1.9}$$

が得られる。この式を熱力学恒等式と云う。

孤立系の場合、dU = 0、dV = 0であるので、式 (1.8) より

$$\mathrm{d}S > 0 \tag{1.10}$$

となる。この式を言葉に直すと「孤立系の不可逆変化はエントロピーが増 大する方向に進む」ということになる。

1.4 平衡判定条件

系が平衡状態にある場合、束縛条件の変更なしには自発的に変化することはない。対象とする系が平衡状態にあるか否かを判定するには、束縛条件を固定し、仮想的な微少変化を想定する。この仮想微少変位を δ あるいは $\bar{\delta}$ で表す。系が平衡状態にあるためには、あらゆる仮想微少変位に対して Clausius の不等式 (1.6) が成立してはならない。逆にこの不等式が成り立つ場合、その仮想変位は熱力学第二法則を満たし、仮想ではなく実現することになる。つまり、仮想微少変位に対して

$$\delta S \neq \frac{\bar{\delta}Q}{T'} \tag{1.11}$$

でなければならない。これが平衡判定条件である。仮想微少変位に対する 熱力学第一法則

$$\delta U = \bar{\delta}Q - p'\delta V \tag{1.12}$$

を代入すると

$$T'\delta S \neq \delta U + p'\delta V \tag{1.13}$$

が得られる。

孤立系の場合

束縛条件より、 $\delta U = 0$ 、 $\delta V = 0$ であるから、式 (1.13) は

$$\delta S \neq 0 \tag{1.14}$$



☑ 1.6 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821/8/31−1894/9/8)

を与える。つまり、系が平衡状態にあるためには仮想変位に対してエント ロピーが増大してはならない。

温度と体積が一定の系

この場合、熱平衡が成立しており T' = T で、束縛条件より $\delta V = 0$ で ある。式 (1.13) より

$$T\delta S \not> \delta U$$
 (1.15)

となる。いま、

$$A \equiv U - TS \tag{1.16}$$

で定義する Helmholtz 自由エネルギー (Helmholtz free energy) を導入 するとこの式は

$$\delta A \not< 0 \tag{1.17}$$

と表される。すなわち、温度 T と体積 V が一定の系が平衡状態にあるためにはあらゆる仮想変位に対して Helmholtz 自由エネルギーが減少してはならない。Helmholtz 自由エネルギー A は示量性状態量である。

温度と圧力が一定の系

この場合、熱平衡および力学平衡が成り立っており、T' = T、p' = pであってそれらはいずれも一定である。したがって、式 (1.13) より

$$\delta(U + pV - TS) \not< 0 \tag{1.18}$$



☑ 1.7 Josiah Willard Gibbs (1839/2/11-1903/4/28)

が得られる。ここで、以下の式で定義するエンタルピー (enthalpy)H と Gibbs 自由エネルギー (Gibbs free energy)G を導入する。

$$H \equiv U + pV \tag{1.19}$$

$$G \equiv U + pV - TS = H - TS \tag{1.20}$$

Gibbs 自由エネルギー G を用いると式 (1.18) は

$$\delta G \not< 0 \tag{1.21}$$

と書き直される。すなわち、温度 T と圧力 p が一定の系が平衡状態であ るためにはあらゆる仮想変位に対して Gibbs 自由エネルギーが減少して はならない。ここで、エンタルピー H および Gibbs 自由エネルギー G は いずれも示量性状態量である。

[応用例]

温度 T と圧力 p が一定の 1 成分系で気相と液相が共存している系を考 える。この条件下で考えうる仮想変位は気相と液相間の物質の移動のみで ある。T = -定、p = -定であるので、この系の平衡条件は式 (1.21) で与 えられる。液相の物質量を n_l モル、Gibbs 自由エネルギーを G_l 、モル当 たりの Gibbs 自由エネルギーを \bar{G}_l とする。同様に、気相の物質量を n_g モル、Gibbs 自由エネルギーを G_q 、モル当たりの Gibbs 自由エネルギー を \bar{G}_q とする。

$$G_l = n_l \bar{G}_l(T, p), \qquad G_g = n_g \bar{G}_g(T, p) \tag{1.22}$$

の関係がある。

いま、仮想的に δn_l モルの物質を液相から気相へ移したとする。この変位に伴う G_l の減少は $\delta n_l \bar{G}_l(T,p)$ であり、 G_g の増加は $\delta n_l \bar{G}_g(T,p)$ である。したがって、系全体の Gibbs 自由エネルギー G の変化は

$$\delta G = [\bar{G}_g(T, p) - \bar{G}_l(T, p)]\delta n_l \tag{1.23}$$

となる。平衡条件式(1.21)にこの式を代入すると

$$[\bar{G}_g(T,p) - \bar{G}_l(T,p)]\delta n_l \neq 0 \tag{1.24}$$

が得られる。この関係が、正負を問わず如何なる δn_l に対しても成り立つ ためには

$$\bar{G}_q(T,p) = \bar{G}_l(T,p) \tag{1.25}$$

でなければならない。この式は、1 成分系で気相と液相の平衡が成り立つ ためには、両相の温度、圧力、モル Gibbs 自由エネルギーが等しくなけれ ばならないことを示している。

1.5 特性函数(母函数)

熱力学第二法則は、温度 T と体積 V が一定の系および温度 T と圧力 p が 一定の系における不可逆過程は、それぞれ Helmholtz 自由エネルギー A、 Gibbs 自由エネルギー G が減少する方向に進行し、A あるいは G の極小 値に至って平衡状態に入ることを示している。このことから、状態変数の 組 (T, V) に対しては A が、状態変数の組 (T, p) に対しては G が重要な意 味を持つことが推察できる。実際、状態変数 T、V の函数として A(T, V)が与えられたとき、あるいは状態変数 T、p の函数として G(T, p) が与え られたとき他の全ての状態量はそれらの函数から T と V あるいは T と pの函数として計算できる。この意味で、変数の組 (T, V) に対する A を、 あるいは変数の組 (T, p) に対する G を特性函数 (characteristic function) あるいは母函数 (generating function) と云う。特性函数にはこれらの他 に、状態変数の組 (S, V) に対する内部エネルギーU(S, V)、組 (S, p) に対 するエンタルピー H(S, p) がある。

纏めると

表1.系と特性函数

	1.4.1= 1.1.1.1
系	特性函数
(T, p)	G(T, p)
(T, V)	A(T,V)
(S, p)	H(S,p)
(S, V)	U(S, V)

である。

例を挙げる。

Gibbs 自由エネルギー G の定義式 (1.20) よりその全微分をとると

$$dG = dU + pdV + VdP - TdS - SdT$$
(1.26)

この式で、d は極めて近い2つの平衡状態の間で差をとることを意味する。 この式と熱力学恒等式 (1.9) より、

$$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T\tag{1.27}$$

が得られる。この式から

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \tag{1.28}$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p \tag{1.29}$$

であることが解る。式 (1.29) を *G* の定義式 (1.20) に代入すると、エンタ ルピー *H* に対して

$$H = G - T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = \left[\frac{\partial (G/T)}{\partial (1/T)}\right]_p \tag{1.30}$$

を得ることができる。この式は Gibbs - Helmholtz の関係と呼ばれる。



☑ 1.8 James Clerk Maxwell (1831/6/13−1879/11/5)

エンタルピー H の定義式 $H \equiv U + pV$ から全微分をとり、熱力学恒等式 (1.9) を用いると

$$dH = TdS + Vdp \tag{1.31}$$

が得られる。したがって、

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V + T \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T \tag{1.32}$$

である。式 (1.28) と (1.29) より

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{\partial^2 G}{\partial p \partial T} = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T \tag{1.33}$$

の Maxwell の関係が導かれる。式 (1.32) と (1.33) から

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \tag{1.34}$$

となる。この式はまた、

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V(1 - \alpha T) \tag{1.35}$$

と書き直せる。ここで、α は定圧熱膨張率で

$$\alpha \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \tag{1.36}$$

である。

熱力学恒等式 (1.9) より

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -p + T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \tag{1.37}$$

が得られる。この式は、 $(\partial U/\partial V)_T \equiv p_i$ で定義する内部圧 (internal pressure) と $(\partial p/\partial T)_V \equiv \beta$ で定義する圧温度係数 (thermal pressure coefficient) を用いて

$$p_i = -p + T\beta \tag{1.38}$$

と書ける。

式 (1.34) と(1.37) は熱的状態方程式 (thermal equation of state) と呼 ばれる。以上はそれぞれ状態変数の組が与えられた系で、対応する特性函 数から種々の状態量を導出できるという例である。

1.6 開放系

ここでは、系は一般に多成分系とし、各成分の物質量は変化しうるものとする。物質量の変化には化学反応による場合、系と外界で物質のやりとりによる場合等があるが、簡単のため、化学反応は起こっていないとする。成分は0、1、 \cdots 、r or r+1 成分系とする。ここで、r+1 成分系とするのは系が溶液の場合、成分0を特別に扱い、主溶媒 (principal solvent)とする場合があることによる。成分i ($i = 0, 1, \cdots, r$)の物質量を n_i モルとすると全物質量n モルは

$$n = \sum_{i=0}^{r} n_i \tag{1.39}$$

である。

1.6.1 部分モル量 - 化学ポテンシャルー

温度 T と圧力 p が一定の (T, p) 系を例にとり、一般に示量性状態量を Y とする。Y は T、p、 n_0 、 n_1 、…、 n_r の函数である。いま、各成分の物 質量 n_i $(i = 0, 1, \dots, n_r$ を一律に λ 倍にしたとき、Y も λ 倍になる。す なわち、Y は

$$Y(T, p, \lambda n_0, \lambda n_1, \cdots, \lambda n_r) = \lambda Y(T, p, n_0, n_1, \cdots, n_r)$$
(1.40)

の性質を持つ。部分モル量 (partial molar quantity) Y_i を

$$Y_i \equiv \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j(j\neq i)} \tag{1.41}$$

で定義すると、以下の関係が成り立つ。

$$Y = \sum_{i=0}^{r} n_i Y_i$$
 (1.42)

各成分の Y_i は互いに独立ではない。Yの全微分をとると

$$dY = \left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial Y}{\partial p}\right)_{T,n_i} dp + \sum_{i=0}^r Y_i dn_i$$
(1.43)

となる。式 (1.42 の全微分は

$$dY = \sum_{i=0}^{r} (n_i dY_i + Y_i dn_i)$$
(1.44)

である。これら2つの式から

$$\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_{p,n_i} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial Y}{\partial p}\right)_{T,n_i} \mathrm{d}p - \sum_{i=0}^r n_i \mathrm{d}Y_i = 0 \tag{1.45}$$

が得られる。*T* と *p* が一定の下では

$$\sum_{i=0}^{r} n_i (\mathrm{d}Y_i)_{T,p} = 0 \tag{1.46}$$

この式を n で割ると

$$\sum_{i=0}^{r} x_i (\mathrm{d}Y_i)_{T,p} = 0 \tag{1.47}$$

となる。ただし、 $x_i \; (\equiv n_i/n) \;$ はモル分率 (後述) である。

前述のように Y_i は示強性状態量であるから、 $(Y_i)_{T,p}$ は x_i 、 x_2 、…、 x_r のみに依存する。 $(\sum_{i=0}^r x_i = 1$ より、モル分率 x_i は r 個のみ独立であ る。) したがって、

$$(\mathrm{d}Y_i)_{T,p} = \sum_{j=i}^r \left(\frac{\partial Y_i}{\partial x_j}\right)_{T,p,x_k(k\neq j)} \mathrm{d}x_j \tag{1.48}$$

この式を式 (1.47) に代入すると

$$\sum_{j=1}^{r} \left[\sum_{i=0}^{r} x_i \left(\frac{\partial Y_i}{\partial x_j} \right)_{T,p,x_k(k \neq j)} \right] \mathrm{d}x_j = 0 \tag{1.49}$$

この式が如何なる dx_i に対しても成立するには

$$\sum_{i=0}^{r} x_i \left(\frac{\partial Y_i}{\partial x_j}\right)_{T,p,x_k(k\neq j)} = 0 \qquad (j=1,2,\cdots,r)$$
(1.50)

でなければならない。つまり、各成分*i*についての*Y_i*の変化は独立には 起こりえず、相互の関係がこの式で規定されている。

(S,V)系の特性函数はUであり、開放系に対してその変化は

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=0}^{r} \mu_i dn_i$$
(1.51)

と書ける。ここで、 μ_i は成分 *i* の化学ポテンシャル (chemical potential) と呼ばれる示強性状態量で、

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_j(j\neq i)} \tag{1.52}$$

で定義される。歴史的に化学ポテンシャルは、エネルギーの変化量 dU は 物質量の変化 dn_i ($i = 0, 1, 2, \dots, r$) に比例するとして、Gibbs によって 導入された。式 (1.51) より、 μ_i の他に

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n_i} \tag{1.53}$$

1.6 開放系

$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n_i} \tag{1.54}$$

が得られる。

式 (1.51) を書き直すと

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \sum_{i=0}^{r} \frac{\mu_{i}}{T} dn_{i}$$
$$= \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,n_{i}} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,n_{i}} dV + \sum_{i=0}^{r} \left(\frac{\partial S}{\partial n_{i}}\right)_{U,V,n_{j}(j\neq i)} dn_{i}$$
(1.55)

$$\mu_i = -T \left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{U,V,n_j(j \neq i)} \tag{1.56}$$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,n_i} \tag{1.57}$$

$$p = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,n_i} \tag{1.58}$$

が得られる。

U は示量性状態量であり、

$$U = TS - pV + \sum_{i=0}^{r} \mu_i n_i$$
 (1.59)

と書ける。この式の全微分をとると

$$dU = TdS + SdT - Vdp - pdV + \sum_{i=0}^{r} (\mu_i dn_i + n_i d\mu_i)$$
(1.60)

この式と式 (1.51) より

$$SdT - Vdp + \sum_{i=0}^{r} n_i d\mu_i = 0$$
 (1.61)



☑ 1.9 Pierre Maurice Marie Duhem (1861/6/10−1916/9/14)

が得られる。 $T \ge p$ が一定のとき、この式から

$$\sum_{i=0}^{r} \left[\sum_{j=0}^{r} n_i \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n_j} \right)_{T,p} \right] \mathrm{d}n_i = 0 \tag{1.62}$$

が導かれる。任意の dn_i に対してこの式が成り立つためには

$$\sum_{i=0}^{r} n_i \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n_j}\right)_{T,p} = 0 \tag{1.63}$$

でなければならない。式 (1.45)、(1.50)、(1.61)、(1.63) はいずれも Gibbs - Duhem の式と呼ばれる。

同様に、

(S, p)系について、特性函数はHであり、その変化は

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{i=0}^{r} \mu_i dn_i$$
(1.64)

と表される。この式より

$$\mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_j(j\neq i)} \tag{1.65}$$

$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,n_i} \tag{1.66}$$

1.6 開放系

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,n_i} \tag{1.67}$$

が導かれる。

(T,V)系について、特性函数Aの変化は

$$\mathrm{d}A = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V + \sum_{i=0}^{r} \mu_i \mathrm{d}n_i \tag{1.68}$$

となる。したがって、

$$\mu_i = \left(\frac{\partial A}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_j(j\neq i)} \tag{1.69}$$

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n_i} \tag{1.70}$$

$$p = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n_i} \tag{1.71}$$

(T, p) 系について、特性函数はGで、その変化は

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum_{i=0}^{r} \mu_i \mathrm{d}n_i \tag{1.72}$$

となる。ここから、

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j(j\neq i)} \tag{1.73}$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} \tag{1.74}$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} \tag{1.75}$$

が導出される。

Gibbs 自由エネルギー G には化学ポテンシャルとの関係において重要 な性質がある。G の定義式 G = U + pV - TS に内部エネルギー U の定 義式 (1.59) を代入すると

$$G = \sum_{i=0}^{r} \mu_i n_i \tag{1.76}$$

となる。純物質では $G = \mu n$ であり、モル Gibbs 自由エネルギー G_m ($\equiv G/n$) は化学ポテンシャル μ と同じ意味を持つことになる。また、一般に多成分系では

$$G_m = \sum_{i=0}^r \mu_i x_i \tag{1.77}$$

である。化学ポテンシャル μ_i は T、 p、 $x_i (i = 1, 2, \cdots, r)$ の函数、 $\mu_i = \mu_i (T, p, x_1, x_2, \cdots, x_r)$ である。

1.6.2 組成変数と濃度変数

ここでは主として溶液の取り扱いにおいてよく用いられる組成変数ある いは種々の濃度変数の定義とそれらの間の換算関係を纏める。

 モル分率 (mole fraction)x_i 各成分の物質量 n_i モルと全物質量 n モルの比

$$x_i \equiv \frac{n_i}{n} \tag{1.78}$$

で定義する。 $\sum_{i=0}^{r} x_i = 1$ で、独立に選べるのはr 個である。

2. 重量分率 (weight fraction) w_i 成分 i の重量を q_i 、全物質の重量を q として

$$w_i \equiv \frac{q_i}{q} = \frac{q_i}{\sum_{j=0}^r q_j} \tag{1.79}$$

で定義する。 $\sum_{i=0}^{r} w_i = 1$ であり、独立な数は r 個である。モル分率 x_i との関係は、成分 i のモル質量 (molar mass) を M_i とすると $q_i = n_i M_i$ であるので

$$w_i = \frac{x_i M_i}{\sum_{j=0}^r x_j M_j}, \quad x_i = \frac{w_i / M_i}{\sum_{j=0}^r (w_j / M_j)}$$
 (1.80)

となる。

3. 体積分率 (volume fraction) ϕ_i 純成分 i のモル体積 (molar volume) V_i° 、あるいは比容 (specific volume) v_i° ($v_i^{\circ} \equiv V_i^{\circ}/M_i$)を用いて、モル分率 x_i あるいは重量分率 w_i から次式で定義する。

$$\phi_i \equiv \frac{x_i V_i^{\circ}}{\sum_{j=0}^r x_j V_j^{\circ}} = \frac{w_i v_i^{\circ}}{\sum_{j=0}^r w_j v_j^{\circ}}, \qquad \sum_{i=0}^r \phi_i = 1$$
(1.81)

独立な数はr個である。ここで、 V_i° 、 v_I° の代わりに部分モル体積 (partial molar volume) V_i や部分比容 (partial specific volume) $v_i(v_i \equiv V_i/M_i)$ を用いてはならない。 $V_i \geq v_i$ は組成に依存する量で、負になることもある。ただし、組成による体積変化が無い場合は $V_i^{\circ} = V_i$ であり、どちらを用いてもよい。

 4. 質量モル濃度 (molarity)m_i 主溶媒の単位質量あたりの各成分の物 質量 (単位はモル) で定義する。

$$m_i \equiv \frac{n_i}{n_0 M_0} = \frac{x_i}{x_0 M_0} \tag{1.82}$$

 $m_0 \equiv M_0^{-1}$ と約束すると、

$$x_i = \frac{m_i}{M_0^{-1} + \sum_{j=1}^r m_j} = \frac{m_i}{\sum_{j=0}^r m_j}$$
(1.83)

となる。

 5. 体積モル濃度 (volume molarity)C_i 単位体積あたりの成分 i の物 質量 (単位はモル) で定義する。

$$C_i \equiv \frac{n_i}{V} = \frac{x_i}{V_m} = \frac{m_i}{v_M} \tag{1.84}$$

ここで、 V_m は系全体のモル体積 ($\equiv V/n$) で、 v_M は

$$v_M \equiv \frac{V}{n_0 M_0} \tag{1.85}$$

で定義する主溶媒の単位質量あたりの体積である。系の体積 V は部 分モル体積 V_i を用いて

$$V = \sum_{i=0}^{r} n_i V_i, \quad V_i \equiv \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j (j \neq i)}$$
(1.86)

と表されるので、両辺を n_0M_0 で割って

$$v_M = v_0 + \sum_{i=1}^r m_i V_i \tag{1.87}$$

が得られる。各成分の C_i の間には

$$\sum_{i=0}^{r} C_i V_i = 1 \tag{1.88}$$

の関係がある。

 6. 質量濃度 (mass concentration)c_i 単位体積あたりの成分 i の質量 で定義する。

$$c_i \equiv \frac{n_i M_i}{V} = \frac{x_i M_i}{V_m} = \frac{m_i M_i}{v_M} = C_i M_i \tag{1.89}$$

系の密度 ρ は

$$\rho = \sum_{i=0}^{r} \rho_i = \sum_{i=0}^{r} c_i = \frac{\sum_{i=0}^{r} n_i M_i}{V}$$
(1.90)

と表される。また、

$$\sum_{i=0}^{r} \frac{c_i V_i}{M_i} = \sum_{i=0}^{r} c_i v_i = 1$$
(1.91)

の関係がある。

以上の組成変数あるいは濃度変数で系あるいは成分の体積が定義に含ま れている変数の取り扱いは注意を要する。熱力学では温度、圧力の変化す る場合が多いが、そのとき系や各成分の体積はそれによって変化し、それ に伴ってそれらの変数も変化してしまうからである。

これらの組成変数あるいは濃度変数を用いると、Gibbs-Duhemの式 (1.50) は以下のように表すことができる。

$$\sum_{i=0}^{r} \frac{w_i}{M_i} \left(\frac{\partial Y_i}{\partial w_j}\right)_{T,p,w_k(k\neq j)} = 0 \qquad (j=1,2,\cdots,r)$$
(1.92)

$$\sum_{i=0}^{r} \frac{\phi_i}{V_i^{\circ}} \left(\frac{\partial Y_i}{\partial \phi_j}\right)_{T,p,\phi_k(k\neq j)} = 0 \quad (j = 1, 2, \cdots, r)$$
(1.93)

$$\sum_{i=0}^{r} m_i \left(\frac{\partial Y_i}{\partial m_j}\right)_{T,p,m_k(k\neq j)} = 0 \qquad (j=1,2,\cdots,r)$$
(1.94)

$$\sum_{i=0}^{r} C_i \left(\frac{\partial Y_i}{\partial C_j}\right)_{T,p,C_k(k\neq j)} = 0 \quad (j=1,2,\cdots,r)$$
(1.95)

$$\sum_{i=0}^{r} \frac{c_i}{M_i} \left(\frac{\partial Y_i}{\partial c_j}\right)_{T,p,c_k(k\neq j)} = 0 \quad (j=1,2,\cdots,r)$$
(1.96)

これらをいずれも Gibbs-Duhem の式と云う。

1.7 多成分多相系の相平衡条件

系はr + 1成分から成り、簡単のため2相 (α 相と β 相) を含んでいる とする。また、外温と外圧は一定で、各相間にも熱平衡と力学平衡が成り 立っているものとする。すなわち

$$T^{\alpha} = T^{\beta} = T \tag{1.97}$$

$$p^{\alpha} = p^{\beta} = p \tag{1.98}$$

が成立しているとする。考えうる仮想微少変位として、 α 相から β 相へ成 分 $i \in \delta n_i (i = 0, 1, \dots, r)$ モル移す。このとき、平衡条件は $\delta G \not< 0$ であ る。 α 相における G の変化 G^{α} と β 相における G の変化 G^{β} は

$$\delta G^{\alpha} = -\sum_{i=0}^{r} \mu_i^{\alpha} \delta n_i \tag{1.99}$$

$$\delta G^{\beta} = \sum_{i=0}^{r} \mu_i^{\beta} \delta n_i \tag{1.100}$$

である。ここで、 μ_i^{α} 、 μ_i^{β} はそれぞれ α 相と β 相における成分 i の化学ポテンシャルである。 $\delta G = \delta G^{\alpha} + \delta G \beta$ であるから、 $\delta G = -\sum_{i=0}^{r} (\mu_i^{\alpha} - \mu_i^{\beta}) \delta n_i$ であり、平衡条件は

$$\sum_{i=0}^{\prime} (\mu_i^{\alpha} - \mu_i^{\beta}) \delta n_i \neq 0$$
(1.101)

となる。この式が、正負を問わず如何なる δn_i に対しても成り立つため には

$$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta} \quad (i = 0, 1, \cdots, r)$$
 (1.102)

でなければならない。これは系の中で、成分の移動によるエネルギーの流 れが生じない条件で、拡散平衡の条件と呼ばれる。

化学ポテンシャルはT、p、 $\{x\}$ ($\{x\} \equiv x_1, x_2, \dots, x_r$)の函数であるか ら、上の条件式 (1.97)、(1.98)、(1.102) は

$$\mu_i^{\alpha}(T, p, \{x^{\alpha}\}) = \mu_i^{\beta}(T, p, \{x^{\beta}\})$$
(1.103)

と纏められる。

いま、系の中で Pの相が共存している場合、平衡条件は一般に

$$\mu_{0}^{\alpha}(T, p, \{x^{\alpha}\}) = \mu_{0}^{\beta}(T, p, \{x^{\beta}\}) = \dots = \mu_{0}^{P}(T, p, \{x^{P}\})$$

$$\mu_{1}^{\alpha}(T, p, \{x^{\alpha}\}) = \mu_{1}^{\beta}(T, p, \{x^{\beta}\}) = \dots = \mu_{1}^{P}(T, p, \{x^{P}\})$$

$$\mu_{2}^{\alpha}(T, p, \{x^{\alpha}\}) = \mu_{2}^{\beta}(T, p, \{x^{\beta}\}) = \dots = \mu_{2}^{P}(T, p, \{x^{P}\})$$

$$\dots$$

$$\mu_{r}^{\alpha}(T, p, \{x^{\alpha}\}) = \mu_{r}^{\beta}(T, p, \{x^{\beta}\}) = \dots = \mu_{r}^{P}(T, p, \{x^{P}\})$$
(1.104)

となる。この条件式の導出において、

- 全ての相に全ての成分が存在する。
- 全ての相間に、成分の通過を妨げる膜(半透膜等)、熱の流れを妨げる膜(断熱膜等)、圧力差を支える膜(圧力隔壁等)の存在しない。

ことが暗黙の前提になっている。この前提が成り立つ単純系について、平 衡条件式の数から前述の Gibbs-Duhem の式が導かれる。高分子溶液で、 基本的な浸透圧の測定における浸透平衡の系は単純系ではない。この場 合、各相の圧力は異なっており、溶質成分の欠けている相がある。



☑ 1.10 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796/6/1−1832/8/24)

1.A 「火の動力に関する考察」―サディ・カルノー―

熱力学の法則を確立する元となったカルノーの考察⁷ はあまり目にする 機会がないと思われるのでここに引用しておくことにする。なお、この考 察は熱力学第2法則の原型となったもので、当時熱力学第1法則であるエ ネルギー保存則は未だ発見されていなかった。したがって、第2法則のほ うが第1法則に先立って現れている。カルノーの死後間もなく、Joule に よって熱と仕事との当量関係が見出され、熱を含めた一般的なエネルギー 保存則が Mayer や Helmholtz によって確立された。「考察」は蒸気機関を 念頭に置いたものである。その後の展開は具体的な事例から一般的な熱力 学理論へと発展した好例と云える。「考察」の中で、サイクルに関する記 述は以下のとおりである。

「円筒容器の abcd の部分に、ある弾性流体、たとえば空気が閉じ込め られているものとし、cd は可動の仕切り、すなわちピストンであるとす る。また、そのほかに、2つの物体 A、B があり、おのおのは一定の温度 に保たれていて、A の温度は B より高いとする。ここで以下にのべるよ うな一連の操作を行うものとしよう。

物体 A を abcd 部分に閉じ込められた空気に接触させる。つまりその部分の壁面に接触させるのである。その壁は、熱を滞りなく伝えるようなものであるとする。その接触によって、空気は物体 A と同じ温度になる。cd は、こうなった時のピストンの位置を表している。



図 1.11 カルノーの記述に基くカルノーサイクル (エンジン)

- ピストンがだんだん引き上げられ、efの位置に来る。この間、物体 A は絶えず空気と接触しており、このために、空気は膨張する間も 一定の温度に保たれる。温度を一定に保つのに必要な熱を物体 A が 供給するのである。
- 3. 物体 A は取り除かれ、もはや空気は、熱を供給してくれるものには 接触していない。その間もピストンは移動を続け、efの位置から gh の位置に来る。空気は熱を受け取ることなく膨張するので、温度が 下がる。その温度が物体 B と同じところまで下がったとしよう。そ の時点でピストンが止まり、gh の位置に止まっている。
- 空気を物体 B に接触させる。ピストンが逆運動を起こして gh の位置から cd の位置まで戻り、空気は圧縮される。ところが、空気は物体 B に接触しているために温度は一定に保たれる。この時空気は物体 B に熱を与えることになる。
- 5. 物体 B が取り除かれるが、空気の圧縮は続く。空気は他との接触を



☑ **1.12** James Watt (1736/1/19−1819/8/25)

断たれているので温度が上がる。こうして、空気の温度が物体 A と同じになるまで圧縮する。この間、ピストンは cd の位置から ik の位置まで移動する。

- 6. 再び空気を物体 A に接触させる。ピストンは ik の位置から ef の位 置まで戻る。温度は一定に保たれる。
- 7. 上記の(3)の段階が繰り返され、続いて(4)、(5)、(6)、(3)、(4)、(5)、(6)、(3)、(4)、(5)というふうに繰り返しが起こる。

上記の諸過程において、ピストンがシリンダー内に閉じ込められた空気 から受ける力の大きさは、いつも同じではない。この空気の弾性力は、体 積の変化によっても変わるし、温度の変化によっても変わるからである。 しかし大事な点は、同じ体積においては、つまりピストンの位置が同じで あるところで比べると、膨張しつつある時のほうが圧縮しつつある時より も温度が高ということである。そうすると、前者の場合の方が空気の弾性 力は大きいことになり、したがって、膨張運動によって生み出される動力 は、圧縮運動を行わせるために消費される動力を上回ることになる。こう して、差し引き余剰の動力が取り出され、この余剰分は何にでも使うこと ができる。したがって、ここで空気は熱機関としての働きをするわけであ る。そして、実は、上記の場合は、これが可能な限り最も有効に用いられ たことになる。なぜならここでは、熱に関する釣り合いを無駄に回復させ る過程は含まれていないからである。

上記の操作は、すべて、順序や向きを逆にして行うこともできる。たと

えば、第6段階の終わり、すなわちピストンが ef の位置に来たところで、 空気と物体 A の接触を保ちながらピストンを ik の位置まで戻したとしよ う。この時、第6段階が行われる過程で物体 A から供給された熱はもと の物体 A に戻され、第5段階が終わった時とまったく同じ状態になる。こ こで物体 A を取り除き、ピストンを ik から cd まで動かすと、空気の温 度はちょうど第5段階の間に増えた分だけ減り、物体 B の温度に達する ことになろう。こうして、明らかに先に述べた一連の操作は逆向きにも続 けられるのである。それにはおのおのの段階で、先と同じ条件のもとに、 膨張運動の代わりに圧縮運動を、圧縮の代わりに膨張運動を行えばよい。

初めの一連の操作の結果として一定量の動力が取り出され、物体 A から物体 B に熱が移される。これと逆向きの操作を行うと、先に取り出された動力が消費され、熱は物体 B から物体 A に戻る。したがって、この2種類の操作は互いに打ち消しあい、いわば片方がもう一方を中和するような関係にある。」

「初めの操作が終わった段階では動力が取り出され、同時に物体 A から 物体 B に熱が移されている。逆向きの操作を行うと動力が消費され、熱 は物体 B から物体 A に戻る。両方の場合について同じ量の蒸気を用いる ものとし、動力も熱も外に逃がさないとすると、初めの段階で生成された 動力の量は第二の段階で消費される動力量に等しく、また、初めに物体 A から物体 B に移った熱の量も、次に物体 B から物体 A に戻される量と等 しくなるであろう。そうすると、こういう二つの操作は、最終的に、動力 の生成や片方の物体から他方への熱の移動を起こさずに、交互に何回でも 繰り返せることになる。

さて、もしも、上に述べたものよりももっと有利な熱の利用法があると すると、つまり熱が、上記の初めの一連の操作以上に多量の動力を生み出 せるような何らかの方法があるものとすると、先述のやり方により、この 動力の一部を用いて物体 B の熱を物体 A に、すなわち冷却器から熱源に 熱を戻して最初の状態にもってくることができるはずであり、それによっ て前とまったく同じ操作を繰り返していくこともできることになる。これ は、単に永久運動が実現されるだけではなく、熱なり何なりの消費を伴わ ずに、無限に動力が生み出されることにもなる。こういう動力の生成が行



☑ 1.13 Benoit Paul Emile Clapeyron (1799/2/26−1864/1/28)



☑ 1.14 Count von Rumford (Benjamin Thompson)(1753/3/26−1814/8/21)

われるということは、今日受け入れられている考え方に反するものであ る。それは力学、そして確立されている物理学の法則に反する。それは承 認し難いことがらである。したがって次のような結論を下すべきである。 蒸気を用いて得られる動力の上限は、他のいかなる方法によって実現され る動力の上限とも相等しい。」

なお、カルノーは、熱素説に基いて記述しているので、上の文中の「熱」 のところに「カロリック」という語を用いている。この「考察」に基いて、 横軸が体積 V 縦軸が圧力 p のグラフ上にカルノーサイクルを初めて図示 したのは Clapeyron である。Clapeyron はまた、多くの実験を行い、集め たデータを用いてカルノーの主張に対する裏付けを得ている。カルノーは 熱素説を信じていたわけではないらしく、摩擦熱と仕事との密接な関係を 示唆する Rumford の実験に刺激を受け、後に Joule が行ったのと同様の 実験を予定していたようであるが、その前に36歳でコレラに倒れた。

カルノーの原理⁸

「熱機関の効率は用いる作業物質に依らず、熱素(カロリック)が最終的に移動する2つの物体の温度のみで決まる。最高の効率は温度の異なる物体が接触しない可逆過程(準静的過程)で熱機関が運転されるときに得られる。」

は無から有は生じない、すなわち永久機関は存在しないということに基い て証明されている。この原理から、温度の絶対的な定義を得ることができ ることに気づいたのが Kelvin(William Thomson)で、彼は実際に絶対温 度の定義を得ている。

しかし、熱素説を採るとカルノーの主張には、Jouleの指摘した誤りが ある。熱素(カロリック)が元素の一種とすると、熱機関の運転によって それが移動する際増減することは考えられないので、高温熱源から低温熱 源への移動中に熱素の増減はないということが暗黙の了解事項になってい る。したがって、カルノーの言う永久機関の否定は第1種の永久機関(熱 力学第1法則を破る機関)の否定ということになる。熱と仕事との当量関 係あるいは熱力学第1法則が発見された後ではこの証明は成り立たない。 熱は高温熱源から低温熱源へ移動する際仕事をし、その分だけ減少するこ とになる。これは第1種永久機関とは矛盾しない。

この苦境を救ったのは Clausius である。エネルギー保存則 (熱力学第1 法則) を認めた上で、新たな法則

「循環過程 (サイクル) によって、ひとつの物体から熱を取り出しそれ を当量の仕事に変えるような機関はありえない」

を認めれば、カルノーの原理はそのまま成立することを Clausius は示した。このようにして、熱力学第2法則が発見された。この法則は第2種永久機関が存在しないことを主張する。つまり、熱力学第1法則と第2法則の2つがあれば、カルノーの原理はそのまま成り立つので、カルノーの言う永久機関を第2種永久機関と解釈すればよいということである。このような理論展開の過程で、熱と温度との比が新たな状態量になることが発見され、Clausius はそれをエントロピーと名付けた。

熱力学第2法則は時間の進む方向を規定する法則と云える。文献8⁸に


☑ 1.15 Walther Hermann Nernst (1864/6/25−1941/11/18)

よると、Kelvin(William Thomson)の結論は以下のとおりである。

- 1. 現在、物質世界には力学エネルギーが散逸する普遍的傾向が存在 する。
- 力学エネルギーの回復は、どんな物的過程によっても、原状回復を 上まわる散逸をもたらすことなしにそれを行うことは不可能である。 そして、植物的生命をそなえたものであれ、はたまた動物の意思に 支配されるものであれ、およそいかなる有機体をもってしても、お そらく事情は変わらないであろう。
- 物質世界で現在生起する種々の作用を統括する法則から見てとても あり得ないような、そういう未知の作用が何か行われないかぎり、 いまのままの体質をもった人類にとってこの地球は、過去の一定期 間に生存が不可能であったに違いなく、来るべき有限の時間内に、 再び居住には全く適しないものになるに違いない。

また、Clausius の終末論は以下のとおりである。

- 1. 宇宙のエネルギーは一定である。
- 2. 宇宙のエントロピーは極大に向かって突き進む。

なお、「1つの物質のエントロピーは絶対0度では状態に依らず同一値 (0)をとる。」あるいは「絶対0度に到達することはできない。」という熱 力学第3法則がNernstによって提唱されている。後者の表現においては、 絶対温度は対数尺度で考えねばならない。

熱力学はわずか(実質的に2つ)の法則によって森羅万象を解明する見 事な体系である。ここで、ひとつ注意すべき点は「法則」は証明されたも のではないということである。それ故、法則であると云える。それらが理 論の出発点(公理)として用いられるのは、世の中で起こる出来事との間に 未だ矛盾が見出されたことがないということに基いている。したがって、 法則そのものに対して何故と問うことはあまり意味がない。それをする人 は新たな熱力学体系を組む覚悟が要るだろう。

参考文献

- A. Einstein, "Autobiographical Notes" in "Albert Einstein: Philosopher Scientist," P. A. Schilpp, Ed., Cambridge University Press, London, 1970. 「アインシュタイン新自伝ノート」、金子務 編訳「未知への旅立ち」小学館、1991 所収.
- 2. 藤田博 「初等化学熱力学」朝倉書店、1980.
- イリア・プリゴジン、ディリプ・コンデプディ著「現代熱力学」妹尾
 学、岩元和敏 訳、朝倉書店、2001.
- 4. M. Planck, "Treatise on Thermodynamics," Dover, New York, 1945.
- 5. Kenneth Denbigh 著「化学熱力学」(上、下), 榊友彦、野村昭之助、安田元夫 訳、廣川書店、1973.
- 6. 倉田道夫、「高分子工業化学 III」、朝倉書店、1975.
- 7. エミリオ・セグレ「古典物理学を創った人々」、久保亮五・矢崎裕二訳、 みすず書房、1992.
- 8. 「物理学とは何だろうか」上、朝永振一郎、岩波新書、1979.

2章 2成分高分子溶液の相平衡

この章では成分0と1から成る2成分溶液の相分離、相平衡を取り扱う。 これらの成分のうち、成分0は溶媒、成分2は高分子とする。高分子溶液 の熱力学に関しては良い成書^{1,2,3}があるので是非参照されたい。

系の温度 *T* と圧力 *p* が与えられているとすると、第1章で述べたよう に系の熱力学的性質は Gibbs 自由エネルギー *G* を用いて表される。いま、 系が相分離を起こして 2 相から成っているとすると、成分 1 のモル分率 x_1 の函数としてのモル Gibbs 自由エネルギー G_m 曲線の一部が上に凸と なる。このような G_m 対 x_1 の曲線を図 2.1 における温度 T_1 の曲線で模式 的に示す。式 (1.77) から解るようにこの曲線の $x_1 = 0$ の切片は成分 0 の 純状態における化学ポテンシャル μ_0° 、 $x_1 = 1$ の切片は成分 1 の純状態に おける化学ポテンシャル μ_1° である。このように 2 相が存在する場合、 G_m 曲線に 2 点 P' と P'' で接する共通接線を引くことができる。点 P' と P'' の組成を x_1' 、 x_1'' とすると、この共通接線の $x_1 = 0$ の切片は

$$\mu_0(x_1') = \mu_0(x_1'') \tag{2.1}$$

を、また、 $x_1 = 1$ の切片は

$$\mu_1(x_1') = \mu_1(x_1'') \tag{2.2}$$

を与える。これらの関係は 2 相の平衡条件 (1.102) を満たしており、点 P' と P" の組成を持つ 2 相が共存し、平衡状態にあることを保証する。なお、 $G_{\rm m}$ 対 x_1 の曲線に対する接線の $x_1 = 0$ における切片が μ_0 を与え、 $x_1 = 1$ における切片が μ_1 を与えることは以下のように示すことができる。

一般に、組成 x₁の2成分系に対して、式 (1.77) は

$$G_{\rm m}(x_1) = (1 - x_1)\mu_0(x_1) + x_1\mu_1(x_1)$$
(2.3)



図 2.1 モル Gibbs 自由エネルギー G_m (相平衡概念図)

と書ける。この式を x_1 で微分し、部分モル量 Y_i を μ_i とした式 (1.50) を 用いると

$$\left(\frac{\partial G_{\rm m}}{\partial x_1}\right)_{T,p} = \mu_1(x_1) - \mu_0(x_1) \tag{2.4}$$

が導かれる。これらの連立方程式を解くと

$$\mu_0(x_1) = G_{\rm m}(x_1) - x_1 \left(\frac{\partial G_{\rm m}}{\partial x_1}\right)_{T,p}$$
(2.5)

$$\mu_{1}(x_{1}) = G_{m}(x_{1}) + (1 - x_{1}) \left(\frac{\partial G_{m}}{\partial x_{1}}\right)_{T,p}$$
(2.6)

が得られる。これらの式中 $(\partial G_m/\partial x_1)_{T,p}$ は x_1 での G_m 曲線に対する接線の勾配であるから、式 (2.5) は接線の $x_1 = 0$ の切片が $\mu_0(x_1)$ を、式 (2.6) は $x_1 = 1$ の切片が $\mu_1(x_1)$ を与えることを示している。

図 2.1 における温度 T_1 のような G_m 対 x_1 曲線には一般に点 N' と N" で 示す変曲点が存在する。これらの点は尖点 (spinodal point) と呼ばれる。



図 2.2 安定、準安定、不安定について

尖点は G_m曲線の変曲点であることから次式が成り立つ。

$$\left(\frac{\partial^2 G_{\rm m}}{\partial x_1^2}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial x_1}\right)_{T,p} = 0 \tag{2.7}$$

温度 T_1 の曲線のうち $x_1 = 0$ から点 P'までと点 P"から $x_1 = 1$ までの組成範囲では系は安定、点 P'から点 N'までと点 N"から点 P"までの範囲では系は準安定、点 N'から点 N"の組成範囲では系は不安定である。これらの事柄は以下のように理解できる。

図 2.2 において、点 Q で表す溶液が仮想的に点 Q' と Q" で示す 2 つの 相に分離する仮想変位を考える。ここで、点 Q、Q'、および Q" で示す相 の物質量をそれぞれ n、n'、n'' モルとする。また、それぞれの相における 成分 1 のモル分率を x_1^0 、 x_1' 、 x_1'' とする。全物質および成分 1 の物質保存 則から

$$n = n' + n'' \tag{2.8}$$

$$nx_1^0 = n'x_1' + n''x_1'' \tag{2.9}$$

が成り立つ。これらの式から

$$\frac{n'}{n} = \frac{x_1'' - x_1^0}{x_1'' - x_1'} \tag{2.10}$$

$$\frac{n''}{n} = \frac{x_1^0 - x_1'}{x_1'' - x_1'} \tag{2.11}$$

となる。

点 Q'の相のモル Gibbs 自由エネルギーを G'_{m} 、点 Q''の相のモル Gibbs 自由エネルギーを G''_{m} とし、これら 2 つの相から成る系のモル Gibbs 自 由エネルギーを G_{m}^{*} とすると

$$nG_{\rm m}^* = n'G_{\rm m}' + n''G_{\rm m}'' \tag{2.12}$$

である。この式と式 (2.10) および (2.11) より

$$G_{\rm m}^* = G_{\rm m}' + \frac{x_1^0 - x_1'}{x_1'' - x_1'} (G_{\rm m}'' - G_{\rm m}')$$
(2.13)

となる。

図 2.2(a) のように G_m 対 x_1 曲線が下に凸の場合、 G_m^* に対応する点は 式 (2.13) より点 Q の真上で点 Q' と点 Q'' を結ぶ直線上にある。したがっ て、 G_m^* は点 Q に対応するモル Gibbs 自由エネルギー G_m^0 より大きい。こ の結果は第 1 章の平衡判定条件 (1.21) を満たしており、ここで想定した 仮想相分離は実現せず、点 Q の 1 相溶液が安定な平衡状態にあることが 解る。

図 2.2(b) のように G_m 対 x_1 曲線が上に凸である場合、 G_m^* に対応する 点は点 Q の真下で点 Q' と Q'' を結ぶ線上にくることが式 (2.13) から解 る。したがって、 G_m^* は点 Q に対応する G_m^0 より小さく、この関係は平衡 判定条件 (1.21) を満たさない。これは想定した仮想相分離が仮想ではな く、実際に進行することを意味している。したがって、点Qで表す1相 溶液は平衡状態では存在しえず、不安定であると云える。

図 2.1 の温度 T_1 の曲線における点 P' と N' の間、点 P'' と N' の間の領 域は準安定 (metastable) と呼ばれる。図 2.2 の点 Q' と Q'' が共に下に凸 のこの狭い領域にある場合は図 2.2(a) と同様の結果が期待でき、点 Q の 1 相溶液は暫定的に安定平衡状態と云える。ただし、図 2.2(c) に示すよう に点 Q'' が点 Q から大きく離れたとき、点 Q' と Q'' で表す 2 相からなる 系の G_m^* は点 Q の 1 相溶液の G_m^0 よりも小さくなりうる。したがって、 この領域の溶液は最終的に相分離を起こす。この意味で、この組成範囲は 準安定領域であると云う。

図 2.1 の温度 T_1 での G_m 対 x_1 曲線における上に凸の部分は温度を変 えると変化し、消滅する温度が存在する。この温度を臨界共溶点 (critical solution point) と云う。臨界共溶点は式 (2.7) および次式から求めること ができる。

$$\left(\frac{\partial^3 G_{\rm m}}{\partial x_1^3}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial^2 \mu_1}{\partial x_1^2}\right)_{T,p} = 0 \tag{2.14}$$

図 2.1 の点 P' と P'' および点 N' と N'' の温度 T と成分 1 のモル分率 x_1 との関係を表したのが図 2.3 である。このような図を相図 (phase diagram) と云う。温度 T が異なる点 P' あるいは点 P'' を結んだ曲線 (図 2.3 の太い 実線)を共存曲線 (coexistence curve) あるいは双交曲線 (binodal) と云う。 図 2.3 では、共存曲線より高温側が1相領域、低温側が2相領域である。 例えば温度 T_1 の点 P で表す 1 相溶液は存在しえず、この溶液は点 P'と P"で表す2つの相に直ちに分離する。このとき、相P'とP"を構成する 物質量の比 n'/n" は式 (2.10) と (2.11) から、線分 PP" と P'P の比に等 しいことが解る。これを梃子の法則(lever rule)と云う。また、共存する 2相 P'と P"を結ぶ線分を連結線 (tie line) と云う。共存曲線より高温側 である濃度の透明な均一1相溶液をとり、温度を下げていくといずれ共存 曲線とぶつかる。そこでは、相分離が起こり始め、初めの均一溶液とは離 れた別の濃度の相が微少量発生して溶液が濁る。この温度を曇点 (cloud point) あるいは沈澱点 (precipitation point) と云う。また、曇点と組成の 関係を表す曲線は曇点曲線 (cloud point curve) と呼ばれる。2 成分系では 曇点曲線と共存曲線は一致する。(次章で述べるように多成分系では両者



図 2.3 2 成分溶液の相図

は一致しない。) 温度 T の異なる点 N' あるいは点 N'' を結んだ曲線 (図 2.3 の破線) は尖点曲線 (spinodal) と呼ばれる。 尖点曲線の低温側は不安 定領域であり、尖点曲線と共存曲線の間は準安定領域である。

共存曲線と尖点曲線はある温度 T_c で互いに接する。この点が臨界共溶点 である。図 2.3 では臨界共溶点の低温側で 2 相分離領域を持つが、このよ うな場合その臨界共溶点を上限臨界共溶点 (upper critical solution point) と呼ぶ。逆に臨界共溶点の高温側に 2 相分離領域を持つ場合下限臨界共溶 点 (lower critical solution point) と呼ぶ。先にも述べたように、臨界共溶 点は式 (2.7) と (2.14) から求めることができる。系によっては上限臨界共 溶点と下限臨界共溶点を併せ持つものもある。その場合、低温側で 2 相分 離を起こし、温度を上昇させると1 相となり、さらに温度を上げると再び 2 相分離を起こす。

2.1 2 成分系の相平衡

ここでは、成分1を高分子とする2成分高分子溶液の相平衡を取り扱う。高分子は一般に分子量分布を持つので、完全な2成分高分子溶液は存

在しないかも知れないが、ここでは簡単のため単一の分子量を持つ高分子 成分と溶媒からなる2成分系をまず対象とする。上述の議論から解るよう に、温度と組成の函数としてのモル Gibbs 自由エネルギー Gm、より詳し くは混合の Gibbs 自由エネルギー ΔG 、が解れば相図に関する全ての量を 計算することができる。 G_{m} (ΔG) を得るには大きく分けて 2 つの方法が ある。1 つは適切なモデルを用いてそれに統計力学を適用して $G_{\rm m}$ (ΔG) を定式化する方法である。この方法は理想的ではあるが、そのためには高 分子溶液はあまりに複雑すぎるため、完全に定量的な相図の記述を達成す ることは期待できない。もう1つは熱力学的あるいは現象論的手法と呼ば れる方法である。この方法では、熱力学的考察、経験、あるいは理論に基 づいて $G_{
m m}$ あるいは ΔG の現象論式を設定し、それに含まれるパラメー タを対象とする系の熱力学データから決定する。得られた現象論式による 計算結果と実際の相図との比較から、 G_{m} の式が満たすべき条件を知るこ とができる。式 (2.7)、(2.14) からも解るように、相図の正確な記述には $G_{\rm m}$ の3次微分までの極めて精密な定式化が要求される。この意味で、後 者の方法が今のところより見込みのある方法であり、現実にもよく用いら れている。

2.1.1 Flory-Huggins 理論

ー般に溶媒の低分子と溶質の高分子とでは分子のサイズに大きな違い がある。この違いを取り入れた統計熱力学理論に有名な Flory-Huggins 理論がある。^{4,5} この理論は Huggins と Flory が独立にほぼ同時期に発表 したものである。(Flory がこの理論を組み上げたとき、Huggins が既に同 様の理論を完成していることを知って共著での発表を申し入れたところ、 Huggins は独立に発表せよと言ったという話がある。)

いま、純状態における溶媒分子と溶質高分子のモル体積をそれぞれ V_0° 、 V_1° とする。それらを用いて、高分子の相対的な鎖長 P_1 を

$$P_1 \equiv \frac{V_1^{\circ}}{V_0^{\circ}} \tag{2.15}$$

で定義する。したがって、高分子鎖は体積 V₀°の構成要素が繋がったもの として表される。この構成要素をセグメントと称することにする。これら



図 2.4 高分子溶液の格子模型

のセグメントと溶媒分子を図 2.4 に示す格子上に配置する。格子点の体積 はいずれも V_0° である。全格子点数を N、溶媒分子数を N_0 、高分子数を N_1 とすると

$$N = N_0 + P_1 N_1 \tag{2.16}$$

である。また、系の体積 V は

$$V = (N_0 + P_1 N_1) V_0^{\circ} \tag{2.17}$$

となる。ここで、 V_0 および V_1 は温度 T と溶液の組成には依らないものと する。溶質高分子の体積分率 ϕ_1 と溶媒の体積分率 ϕ_0 は

$$\phi_1 = \frac{P_1 N_1}{N_0 + P_1 N_1} \tag{2.18}$$

$$\phi_0 = 1 - \phi_1 = \frac{N_0}{N_0 + P_1 N_1} \tag{2.19}$$

と表される。

まず、格子上に溶媒分子と高分子を配置する仕方の数 Ω を求める。溶 媒分子と高分子にそれぞれ 1、2、…、 N_0 および 1、2、…、 N_1 と番号を 付す。高分子には頭尾の区別があるものとする。各高分子のセグメントに は頭から 1、2、…、 P_1 と番号を付ける。いま、1番目の高分子鎖の1番 目のセグメントは N 個の格子点のどこにでも置ける。各格子点の最近接 格子点の数を z とすると2番目のセグメントを置きうる格子点の数は z で ある。3番目のセグメントのそれは z - 1 である。これは z 個の最近接格 子点1つが既に占められているからである。以下これを繰り返すと1番目 の高分子鎖のセグメント P_1 個を配置する仕方の数 ν_1 は

$$\nu_1 = N z (z-1)^{P_1 - 2} \tag{2.20}$$

となる。i - 1番目まで高分子鎖を配置し終えたとき、残っている格子点の数は $N - P_1(i - 1)$ である。そこにi番目の高分子鎖を配置する仕方の数 ν_i は、上と同様にして

$$\nu_i = [N - P_1(i-1)] \left[\frac{N - P_1(i-1)}{N} \right]^{P_1 - 1} z(z-1)^{P_1 - 2}$$
(2.21)

である。ここで、因子 $[N - P_1(i-1)]/N$ は i 番目の高分子鎖の 2 番目以降のセグメントを配置するとき、当該の各格子点が空である確率を表す。 これは一つの近似であり、平均場近似と呼ばれる。

 N_1 個の高分子を全て配置し終えたとき、残っている格子点の数は N_0 であり、そこに溶媒分子 N_0 個を配置する仕方の数は N_0 ! である。ただし、各溶媒分子ならびに各高分子には区別はないので、上記で求めた高分子鎖と溶媒分子の配置の仕方の数は最終的に $N_0!N_1!$ で割っておかねばならない。また、高分子鎖に頭尾の区別がなければさらに 2^{N_1} で割っておく必要がある。ここから、

$$\Omega = \frac{1}{N_1! \sigma^{N_1}} \prod_{i=1}^{N_1} \nu_i \tag{2.22}$$

が得られる。ただし、 σ は高分子鎖の対称数で、高分子鎖に頭尾の区別が ある場合は 1、無い場合は 2 である。式 (2.22) に式 (2.21) を代入すると

$$\Omega = \frac{N!}{N_0!(P_1N_1)!} \left(\frac{P_1N_1}{N}\right)^{(P_1-1)N_1} \omega^{N_1}$$
(2.23)

が得られる。ここで、

$$\omega \equiv \frac{P_1 z (z-1)^{P_1 - 2}}{\sigma e^{P_1 - 1}}$$
(2.24)

である。ただし、式 (2.23) の導出には Stirling の式

$$x! = \left(\frac{x}{e}\right)^x \tag{2.25}$$

を用いている。

エントロピー S に関する Boltzmann の式

$$S = k_{\rm B} \ln \Omega \tag{2.26}$$

を用いると、系の分子配置に対するエントロピー S は

$$S = -k_{\rm B}(N_0 \ln \phi_0 + N_1 \ln \phi_1) + k_{\rm B} N_1 \ln \omega \qquad (2.27)$$

となる。混合前の溶媒と高分子が独立に存在しているときのエントロピー S°は

$$S^{\circ} = S(N_1 = 0) + S(N_0 = 0) = k_{\rm B} N_1 \ln \omega \qquad (2.28)$$

であるから、混合エントロピー (mixing entropy) ΔS は

$$\Delta S = S - S^{\circ}$$

= $-k_{\rm B}(N_0 \ln \phi_0 + N_1 \ln \phi_1)$
= $-R(n_0 \ln \phi_0 + n_1 \ln \phi_1)$ (2.29)

と表せる。ただし、 n_0 と n_1 はそれぞれ溶媒と高分子の物質量 (単位はモル) である。

溶媒と高分子を混合したとき、2組の最近接格子対で溶媒分子と高分子 セグメントの位置の交換が起こる。これに伴うエネルギー増加を2∆*u* と

$$(\bigcirc -\bigcirc)+(\bigcirc -\bigcirc)\longrightarrow(\bigcirc -\bigcirc)+(\bigcirc -\bigcirc)$$

する。溶媒分子間、高分子セグメント間、溶媒分子とセグメント間の相互 作用エネルギーをあおれぞれ *u*₀₀、*u*₁₁、*u*₀₁ とすると

$$\Delta u \equiv u_{01} - \frac{1}{2}(u_{00} + u_{11}) \tag{2.30}$$

である。溶液中の $\bigcirc - \bullet$ 対の総数を zX と表すと、混合エネルギー (mixing energy) ΔU は

$$\Delta U = z X \Delta u \tag{2.31}$$

で与えられる。溶液中の最近接格子点対の数は zN/2 であり、ある選んだ格子点を溶媒分子、高分子セグメントが占める確率はそれぞれ ϕ_0 、 ϕ_1 である。したがって、完全な無秩序混合が起こっているとすれば、zX は

$$zX = zN\phi_0\phi_1 \tag{2.32}$$

となる。これら2つの式より、

$$\Delta U = N z \Delta u \phi_0 \phi_1 \tag{2.33}$$

が得られる。混合による体積変化はないとしているので、 ΔU は混合エンタ ルピー (mixing enthalpy) ΔH と等置できる。式 (2.33)(ただし $\Delta U = \Delta H$ とする) と式 (2.29) を第 1 章の式 (1.20) に代入して、混合 Gibbs 自由エ ネルギー (mixing Gibbs free energy) ΔG を

$$\Delta G = RT[n_0 \ln \phi_0 + n_1 \ln \phi_1 + (n_0 + P_1 n_1) \chi_H \phi_0 \phi_1]$$
(2.34)

と得ることができる。ただし、

$$\chi_H \equiv \frac{z\Delta u}{k_{\rm B}T} \tag{2.35}$$

である。

当初、溶媒と溶質高分子のセグメント間の分子間相互作用を表すためエ ンタルピーパラメータとして χ_H が導入されたが、その後このパラメータ にはエントロピー項が含まれねばならないことが判明したため、自由エネ ルギーパラメータ *chi* として再定義された。これを χ パラメータと云う。 そのエントロピー項を χ_S とすると χ は

$$\chi \equiv \chi_H + \chi_S \tag{2.36}$$

と書ける。 χ は温度 T の函数であり、 χ 、 χ_H 、 χ_S の間には次の関係がある。

$$\chi_H = -T \left(\frac{\partial \chi}{\partial T}\right)_{p,\phi_1} \tag{2.37}$$

$$\chi_S = \chi + T \left(\frac{\partial \chi}{\partial T}\right)_{p,\phi_1} \tag{2.38}$$

以上のようにして、2成分高分子溶液の Gibbs 自由エネルギー G は

 $G = n_0 \mu_0^{\circ} + n_1 \mu_1^{\circ} + RT[n_0 \ln \phi_0 + n_1 \ln \phi_1 + (n_0 + P_1 n_1) \chi \phi_0 \phi_1] \quad (2.39)$

と表されることになる。ここで、 μ_i° は成分 i の純状態における化学ポテンシャルである。また、モル Gibbs 自由エネルギー $G_{\rm m}$ は

$$G_{\rm m} = \phi_0 \mu_0^{\circ} + \frac{\phi_1}{P_1} \mu_1^{\circ} + RT \left(\phi_0 \ln \phi_0 + \frac{\phi_1}{P_1} \ln \phi_1 + \chi \phi_0 \phi_1 \right)$$
(2.40)

と表される。

式 (2.39) を用いると式 (1.73) より、溶媒の化学ポテンシャル μ_0 と溶質 高分子の化学ポテンシャル μ_1 は以下の式のように求められる。

$$\mu_0 = \mu_0^{\circ} + RT \left[\ln(1 - \phi_1) + \left(1 - \frac{1}{P_1}\right) \phi_1 + \chi \phi_1^2 \right]$$
(2.41)

$$\mu_1 = \mu_1^{\circ} + RT[\ln\phi_1 - (P_1 - 1)(1 - \phi_1) + P_1\chi(1 - \phi_1)^2]$$
 (2.42)

式 (1.102) より、相平衡条件は

$$\mu_0(\phi_1') = \mu_0(\phi_1''), \quad \mu_1(\phi_1') = \mu_1(\phi_1'')$$
(2.43)

で与えられる。この式に式 (2.41) と (2.42) を代入して計算すれば共存曲 線を得ることができる。また、尖点曲線は式 (2.7) より

$$\phi_1^2 - \left(1 - \frac{P_1 - 1}{2P_1\chi}\right)\phi_1 + \frac{1}{2P_1\chi} = 0$$
(2.44)

ただし、具体的に温度 T と体積分率 ϕ_1 の関係としての共存曲線、尖点曲 線を得るためには χ と温度 T との関係が必要となる。なお、式 (2.44) を導 く計算では式 (1.81) の x_1 と ϕ_1 の関係を使用している。臨界共溶点 ϕ_{1c} 、 χ_c を求める式は式 (2.7) と (2.14) から

$$-\frac{1}{1-\phi_{1c}} + \left(1-\frac{1}{P_1}\right) + 2\chi_c\phi_{1c} = 0$$
(2.45)



図 2.5 アタクチックポリスチレンーシクロヘキサン溶液の相図

$$-\frac{1}{(1-\phi_{1c})^2} + 2\chi_c = 0 \tag{2.46}$$

と得られる。この計算にも式 (1.81) を使用している。これらの連立方程式 を解いて

$$\phi_{1c} = \frac{1}{1 + P_1^{1/2}} \tag{2.47}$$

$$\chi_c = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{P_1^{1/2}} \right)^2 \tag{2.48}$$

が得られる。これらの式から、 $P_1 \rightarrow \infty$ の極限で $\phi_{1c} = 0$ 、 $\chi_c = 1/2$ となることが解る。これが実現する温度はシータ温度 (theta temperature) と呼ばれ、 Θ で表される。ここから、 χ と温度 T の関係はよく

$$\chi = \frac{1}{2} - \psi + \frac{\Theta}{T}\psi \tag{2.49}$$

と表される。当然、 $T = \Theta$ でこの式は $\chi = 1/2$ を与える。

Flory-Huggins 理論は溶媒分子と溶質高分子のサイズの違いならびに高 分子鎖の屈曲性をうまく取り入れており、高分子溶液の熱力学的性質の特 徴をかなり良く表すことができる。しかしながら、相図に関して計算結果 と実在の系に対する実験結果とのずれは非常に大きい。一例を図 2.5 に挙 げる。これはアタクチックポリスチレンのシクロヘキサン溶液に対する曇 点曲線の結果で、丸印と実線が観測結果、破線が計算結果である。^{6,7} こ の計算では $\Theta = 307.2$ K、 $\psi = 1.056$ としている。図中、 M_v は (粘度平均) 分子量である。この図から明らかなように、計算による双交曲線 (曇点曲 線) は体積分率 ϕ_1 が低く、狭い範囲の相分離領域を与えており、実験によ る曇点曲線との差はあまりにも大きい。これは、理論の誘導のために用い られているいくつかの仮定が荒すぎるかあるいは現実の系にそぐわないこ とを示唆する。

2.1.2 Flory-Huggins 理論に基く現象論

Flory-Hugginsの理論において、混合エントロピー ΔS の定式化では溶 媒分子と高分子の完全な無秩序混合が計算の前提になっている。また、混 合エンタルピー ΔH あるいは χ パラメータの導出では溶媒分子と高分子 セグメントとのかんぜんな無秩序混合が前提となっている。後者におい て、高分子セグメントと溶媒分子間の分子間相互作用によるエネルギーを 取り入れることは、高分子あるいは高分子セグメントと溶媒分子との無秩 序混合の仮定と矛盾する。高分子セグメントと溶媒分子の接触によって相 互作用エネルギーに増減がある限り、両者の無秩序な混合は起こり得ない だろう。また上述のように、溶媒分子と高分子セグメントによる隣接分子 対の組み換えが起こった場合、各分子の熱運動も影響を受ける。さらに、 理論は混合による体積変化はないものとして展開されている。この前提は 大なり小なり実在の高分子溶液とは合わない。これらの不備を解消するた めに、各々の影響を理論に厳密に組み入れることは容易ではない。

Flory-Huggins 理論による混合エントロピー ΔS の式あるいはそれに基 く混合 Gibbs 自由エネルギー ΔG の式を基礎として用いる場合、それら と実在高分子溶液に対する ΔS あるいは ΔG の差は全てパラメータ χ に 押し付けられることになる。それにより、 χ は想定されているように温度 T のみの函数ではなくなり、組成 (高分子濃度)、高分子鎖長等も変数とし て含むことになる。実際、理論が適用されるようになったかなり初期の段 階から、 χ が高分子濃度の函数になることが知られていた。

しかしながら、Flory-Huggins 理論は高分子溶液における相図の特徴を かなりの程度よく再現する。例えば、低分子溶液とは異なり、高分子溶液 の相分離領域が低濃度領域に偏在することを正しく予測する。そのため、 この理論を基準として用いた熱力学現象論がしばしば用いられてきてい る。^{8,9} そこでは、 χ について導入された元来の物理的意味は捨て、それ を現象論的なパラメータ(函数)と見做す。したがって、 χ パラメータは再 定義する必要があるが、 χ は高分子濃度(体積分率 ϕ_1)の函数であるので、 Gibbs 自由エネルギー *G* の式中で定義するか、成分 0 あるいは成分 1 の 化学ポテンシャル μ_0 、 μ_1 の式中で定義するかによって定式化が異なって くる。最もよく行われているのは、 μ_0 に対する式 (2.41)をそのまま χ の 定義に用いる方法である。これは μ_0 が実験的に直接決定しうる量であり 便利であることによるものだろう。改めて χ の定義式を書くと

$$\mu_0 = \mu_0^\circ + RT \left[\ln(1 - \phi_1) + \left(1 - \frac{1}{P_1}\right) \phi_1 + \chi \phi_1^2 \right]$$
(2.50)

である。勿論、この χ は温度 T のみならず、圧力 p、高分子濃度 ϕ_1 、高 分子鎖長 P_1 の函数である。一方、高分子成分 1 の化学ポテンシャルは式 (2.42) とは異なって

$$\mu_1 = \mu_1^{\circ} + RT[\ln\phi_1 - (P_1 - 1)(1 - \phi_1) + P_1\chi_P(1 - \phi_1)^2] \qquad (2.51)$$

と書ける。部分モル量 $Y_i \geq \mu_i$ とする Gibbs-Duhem の式 (1.93) から、 χ と χ_P の関係として

$$\chi_P (1 - \phi_1)^2 = -\chi \phi_1 (1 - \phi_1) + \int_{\phi_1}^1 \chi \mathrm{d}\phi_1$$
 (2.52)

が得られる。式 (1.76) より、この 2 成分系の Gibbs 自由えねるぎー G は

$$G = n_0 \mu_0^{\circ} + n_1 \mu_1^{\circ} + nRT \left[\phi_0 \ln \phi_0 + \frac{\phi_1}{P_1} \ln \phi_1 + g \phi_0 \phi_1 \right]$$
(2.53)

$$n \equiv n_0 + P_1 n_1 \tag{2.54}$$

$$g \equiv \frac{1}{\phi_0} \int_{\phi_1}^1 \chi \mathrm{d}\phi_1 \tag{2.55}$$

となる。この式から逆に χ を相互作用パラメータgで表すと

$$\chi = g - \phi_0 \left(\frac{\partial g}{\partial \phi_1}\right)_{T,p} \tag{2.56}$$

となる。相互作用パラメータ χ および g を高分子成分 1 の体積分率 $\phi_1 = 0$ から展開すると

$$\chi = \chi_0 + \chi_1 \phi_1 + \chi_2 \phi_1^2 + \cdots$$
 (2.57)

$$g = g_0 + g_1 \phi_1 + g_2 \phi_1^2 + \cdots$$
 (2.58)

のように書ける。各展開係数の間には次の換算関係がある。

$$g_i = \sum_{j=i}^{\infty} \frac{\chi_j}{j+1} \tag{2.59}$$

$$\chi_i = (i+1)(g_i - g_{i+1}) \tag{2.60}$$

これが高分子溶液の熱力学に対する一つの現象論的記述法である。相互 作用パラメータ χ あるいはgは熱力学測定からT、 ϕ_1 の函数として実験 的に決定することになる。

2.2 現象論1

パラメータ g あるいは χ を臨界点のデータから決定する手法がしばし ば採られてきた。そのため、Koningsveld ら¹⁰ は式 (2.58) で与えられる g の級数を ϕ_1^2 で打ち切った式

$$g = g_{00} + \frac{g_{01}}{T} + g_1\phi_1 + g_2\phi_1^2 \tag{2.61}$$

を採用した。この場合、 χ は

$$\chi = g_{00} + \frac{g_{01}}{T} - g_1 + 2(g_1 - g_2)\phi_1 + 3g_2\phi_1^2$$
(2.62)

と表される。彼らは g_{00} 、 g_{01} 、 g_1 、 g_2 は温度 T と鎖長 P_1 に依らないとしている。このように g あるいは χ の級数を ϕ_1^2 の項までに止めたのは決定

できる係数の数が限られているためである。式 (2.7) と (2.14) から臨界点 に対する式は一般に

$$X_c \equiv \frac{1}{1 - \phi_{1c}} + \frac{1}{P_1 \phi_{1c}} = 2\chi_c + \left(\partial \chi \partial \phi_1\right)_c \phi_{1c}$$
(2.63)

$$Y_c \equiv \frac{1}{(1-\phi_{1c})^2} - \frac{1}{P_1\phi_{1c}^2} = 3\left(\frac{\partial\chi}{\partial\phi_1}\right)_c + \left(\frac{\partial^2\chi}{\partial\phi_1^2}\right)_2$$
(2.64)

と与えられる。ここで、添え字 *c* は臨界点での値であることを示す。これ らの式に式 (2.62) を代入すると以下の式が得られる。

$$X_c = 2\left(g_{00} + \frac{g_{01}}{T_c}\right) - 2g_1(1 - 3\phi_{1c}) - 6g_2\phi_{1c}(1 - 2\phi_{1c})$$
(2.65)

$$Y_c = 6(g_1 - g_2) + 24g_2\phi_{1c} \tag{2.66}$$

これらの式における X_c 、 Y_c 、 T_c 、 ϕ_{1c} は実験で得られる相図から求める ことができる。種々の P_1 について得た Y_c の χ_{1c} に対するプロットが従 う直線の勾配と $\phi_{1c} = 0$ n 切片から、式 (2.66)を用いて $g_1 \ge g_2$ を決定 することができる。式 (2.65)を用いると、これらの値を用いて、 X_c の T_c に対するプロットから同様に $g_{00} \ge g_{01}$ を評価できる。このようにして、 Konigsveld ら ¹⁰ はアタクチックポリスチレン+シクロへキサン系の g の式

$$g = 0.4099 + \frac{90.65}{T} + 0.2064\phi_1 + 0.0518\phi_1^2 \tag{2.67}$$

を得ている。この式から χ は

$$\chi = 0.2035 + \frac{90.65}{T} + 0.3092\phi_1 + 0.1554\phi_1^2 \tag{2.68}$$

と表される。また、Koningsveld と kleintjens¹¹ は若干の分子論的考察か ら次の閉じた形の式

$$g = \alpha + \frac{\beta_0 + \beta_1/T}{1 - \gamma\phi_1} \tag{2.69}$$

を提案し、上と同様にしてアタクチックポリスチレン+シクロヘキサン系 に対して、 $\alpha = -0.1596$ 、 $\beta_0 = 0.4987$ 、 $\beta_1 = 111.74$ K、 $\gamma = 0.2365$ の値 を得ている。式 (2.68) あるいは式 (2.69 を使った臨界点の計算値が実測の 臨界点を再現することは当然として、Flory-Huggins 理論の予測に比べて 極端に広い相分離領域が計算によってかなりよく表されることも事実である。これは、gあるいは χ を ϕ_1 の増加函数としたことに依っている。

しかしながら、上記の計算は実測の相図を厳密には記述できていない。 これは仮定した g あるいは χ の ϕ_1 を変数とする函数形が必ずしも正確で ないことを意味している。この意味で、相分離領域の近傍における熱力学 測定から、温度 T と濃度 ϕ_1 の函数として g あるいは χ を直接決定するこ とが望ましい。その方向に対する著者らの試みを以下に述べる。

2.2.1 アタクチックポリスチレン+シクロヘキサン系

補遺 2.B に記しているように、溶媒成分 0 の化学ポテンシャル μ_0 は光 散乱法によって次の式から求めることができる。

$$\frac{K_{\phi}}{\Delta R_0} = -\left(\frac{1}{RT\phi}\right) \left(\frac{\partial\Delta\mu_0}{\partial\phi}\right)_{T,p} \tag{2.70}$$

ここで、*K* は光学定数で

$$K_{\phi} \equiv \frac{4\pi^2 \tilde{n}^2 V_0}{N_A \lambda_0^4} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial \phi}\right)_{T,p} \tag{2.71}$$

である。また、 ΔR_0 は散乱角 $\theta = 0$ における過剰 Rayleigh 比、 $\Delta \mu_0$ は溶 媒成分 0 の過剰化学ポテンシャル ($\Delta \mu_0 \equiv \mu_0 - \mu_0^\circ$)、 \tilde{n} は溶液の屈折率、 λ_0 は真空中における入射光の波長である。なお、溶質高分子成分 1 の体 積分率 ϕ_1 の代わりに、ここで改めて高分子成分の体積分率 ϕ を

$$\phi = \frac{1}{1 + \frac{v_0^{\circ}}{v_p^{\circ}} \left(\frac{1}{w} - 1\right)}$$
(2.72)

と定義する。この式中、w は高分子成分の重量分率、 v_0° と v_p° はそれぞれ 純状態における溶媒成分と溶質高分子成分の比容である。この式のよる ϕ は換算重量分率とも云うべき変数であり、この再定義は温度によって体積 分率が変化するという煩雑さを避けるための定義である。式 (2.50) を式 (2.70) に代入すると

$$Z \equiv \chi + \frac{1}{2} \frac{\partial \chi}{\partial \phi} \phi$$



図 2.6 アタクチックポリスチレンーシクロヘキサン溶液の光散乱結果

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1-\phi} + \frac{1}{P\phi} - \frac{K_{\phi}}{\Delta R_0} \right]$$
(2.73)

が得られる。この式で定義する函数 Z は実験的に決定できる量である。ここで、相対鎖長 P は溶質高分子の分子量 M から

$$P \equiv \frac{v_p}{V_0} M \tag{2.74}$$

で定義する。

 ϕ の函数としての $-(1/RT)(\partial \Delta \mu_0 / \partial \phi)_{T,p}$ の一例をアタクチックポリ スチレン+ シクロヘキサン系 (重量平均分子量 $M_w = 43600$) について 図 2.6 に示す。¹² いずれの温度でもデータは下に凸の曲線に従っており、



図 2.7 Z 函数

 $\phi=0$ では共通切片を持っている。この切片は鎖長Pの逆数を与える。測定は難しいが、さらに温度を下げると $-(1/RT)(\partial\Delta\mu/\partial\phi)_{T,p}$ 対 ϕ の曲線は $-(1/RT)(\partial\Delta\mu_0/\partial\phi)_{T,p}=0$ の線 (横軸)と2箇所で交わることになる。それらの点がその温度における尖点の体積分率 $\phi_{\rm sp}$ である。図には示さないが、 ϕ を一定としたとき、 $-(1/RT)(\partial\Delta\mu_0/\partial\phi)_{T,p}$ は殆ど直線的に小さくなり、その直線に沿って $-(1/RT)(\partial\Delta\mu_0/\partial\phi)_{T,p}=0$ へ外挿すると、その ϕ での尖点温度 $T_{\rm sp}$ を得ることができる。

図 2.6 の結果から式 (2.73) を用いて求めた Z が図 2.7 である。図中、温度 T は上から順に 15.0、18.0、20.0、22.0、25.0、28.0、30.0、32.0、34.5 °C である。この Z 函数には次の特徴が見られる。

高濃度側 (φ > 0.1) では、各温度の Z はわずかに下の凸の曲線に従う。異なる温度の曲線は互いに平行に近く、それらの勾配は 1/2 に近い。

2.2 現象論1

2. 稀薄領域では、Zの曲線は上に反るがその程度は温度が下がるにつれて大きくなる。

以下、この図の結果から Z 函数を定式化する。その道筋はかなり煩雑 であるが、我慢していただきたい。上記の特徴 2 に基いて χ を 2 つに分 ける。

$$\chi(T,\phi;P) = \chi_{\rm conc}(T,\phi;P) + [\chi_{\rm dil}(T,\phi;P) - \chi_{\rm conc}(T,\phi;P)]Q(T,\phi;P)$$
(2.75)

ただし、[] 内の χ_{dil} と χ_{conc} はそれらの無限稀釈での値 $\chi_{dil}^{\circ}(T; P)$ と $\chi_{conc}^{\circ}(T; P)$ で近似することにする。また、函数 Q は重なり濃度 (overlap concentration) ϕ^* を用いて、 ϕ/ϕ^* の函数とする。重なり濃度 ϕ^* は

$$\phi^* = \frac{D}{P^{1/2}} \tag{2.76}$$

と書ける。ただし、Dは定数である。Qは $\phi \rightarrow 0$ で1に近づき、 ϕ の増加 と共に減少する函数である。式 (2.75)をZの定義式 (2.73)に代入すると

 $Z(T,\phi;P) = Z_{\rm conc}(T,\phi;P) + [\chi^{\circ}_{\rm dil}(T;P) - \chi^{\circ}_{\rm conc}(T;P)]R(\phi/\phi^{*}) \quad (2.77)$ が得られる。ここで、

$$Z_{\rm conc} = \chi_{\rm conc} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \chi_{\rm conc}}{\partial \phi} \right)_{T,p} \phi \qquad (2.78)$$

$$R(\phi/\phi^{*}) = Q(\phi/\phi^{*}) + \frac{1}{2} \frac{\phi}{\phi^{*}} \frac{\mathrm{d}Q(\phi/\phi^{*})}{\mathrm{d}(\phi/\phi^{*})}$$
(2.79)

である。式 (2.78) より、

$$\lim_{\phi \to 0} Z_{\rm conc} = \chi^{\circ}_{\rm conc}(T; P) \tag{2.80}$$

である。また、 $\phi \to 0$ では $R(\phi/\phi^*) \to 1$ であるから、式(2.77)より

$$\lim_{\phi \to 0} Z = \chi^{\circ}_{\text{dil}}(T; P) \tag{2.81}$$

である。したがって、 $\chi_{\rm dil}^{\rm o}$ はZを $\phi \to 0$ へ外挿することによって求めることができる。



図 2.8 Y 函数

次に、*Z*函数の具体的な経験式を、まず図 2.6 あるいは図 2.7 の試料 (鎖 長 *P*₄) について求める。そのために、上記の特徴 1 を利用して *Z*_{conc} を

$$Z_{\rm conc}(T,\phi;P) = \chi_{\rm conc}^{\circ}(T;P) + \frac{1}{2}\phi + f(T,\phi;P)$$
(2.82)

とおく。新たな函数 Y を

$$Y = Z - \frac{1}{2}\phi \tag{2.83}$$

と定義し、式 (2.82) を式 (2.88) に代入すると

$$Y(T,\phi;P) = Y_{\rm dil}(T,\phi;P) + Y_{\rm conc}(T,\phi;P)$$
(2.84)

が得られる。ここで、 Y_{dil} と Y_{conc} は

$$Y_{\rm dil}(T,\phi;P) = [\chi^{\circ}_{\rm dil}(T;P) - \chi^{\circ}_{\rm conc}(T;P)]R(\phi/\phi^*)$$
(2.85)

$$Y_{\text{conc}}(T,\phi;P) = \chi^{\circ}_{\text{conc}}(T;P) + f(T,\phi;P)$$
(2.86)

で定義する。図 2.7 のデータから式 (2.83) によって得た Y を図 2.8 に示す。 図中、温度 T は上から順に 15.0、18.0、20.0、22.0、25.0、28.0、30.0、32.0、 34.5 °C である。この図から Y は温度 T に依らず一定の濃度 ($\phi = 0.1$) の



図 2.9 Xconc 函数

近傍で極小値をもつことが分かる。そこで、Yは ϕ の増加と共に単調に 減少する函数と、単調に増加する関数の2つから成っているとし、前者を Y_{dil} 、後者を Y_{conc} とする。さらに、大胆であるが、 Y_{dil} は極小値付近の ϕ で0になるものとする。この仮定から極小値より高濃度のYは Y_{conc} を表 していることになる。このようにして、次の Y_{conc} の経験式を得ることが できる。

$$Y_{\rm conc}(T,\phi;P_4) = \chi^{\circ}_{\rm conc}(T;P_4) + \frac{10\phi^4}{1+b(T;P_4)\phi^2}$$
(2.87)

この式中の $\chi^{\circ}_{conc}(T; P_4)$ と $b(T; P_4)$ を示したのが図 2.9 の丸印である。な お、図 2.9 には他の試料に対する χ°_{conc} も示してある。(四角: $M_w = 10000$ 、 三角: $M_w = 180000$)

図 2.9 の結果から得た $\chi^{\circ}_{conc}(T; P_4)$ と $b(T; P_4)$ は

$$\chi_{\rm conc}^{\circ}(T; P_4) = 0.4930 + 0.345 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + 0.0029 \exp\left[-30 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right]$$
(2.88)



図 2.10 χ[°]_{dil} 函数

$$b(T; P_4) = 50.5 \exp\left[-18\left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right]$$
 (2.89)

と表される。これらの式から計算した $Y_{\text{conc}}(T, \phi; P_4)$ と Y のデータから、 式 (2.84)を用いて $Y_{\text{dil}}(T, \phi; P_4)$ を求め、それを $[\chi^{\circ}_{\text{dil}}(T; P_4) - \chi^{\circ}_{\text{conc}}(T; P_4)]$ で割ると $R(\phi/\phi^*)$ を得ることができる。このようにして、試料 P_4 につい て得た経験式は

$$R = \exp(-20\phi - 2150\phi^3) \tag{2.90}$$

である。なお、ここで必要とする $\chi^{\circ}_{dil}(T; P)$ は図 2.10 に示すように実際 には P に依らず、温度 T のみの函数である。この図中異なるシンボルは 異なる P を表している。

図の結果は

$$\chi^{\circ}_{\rm dil}(T) = 0.5 + 0.26 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + 4.6 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2$$
 (2.91)

と表される。図2.8、2.9、2.10中の実線はいずれも計算値を表しているが、 それらは実測の結果をよく再現していることが分かる。

鎖長 *P* が異なる他の試料の *Z* についても同様の解析ができる。それらの結果を纏めると

$$\chi^{\circ}_{\text{conc}}(T; P) = 0.4930 + 0.345 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$

$$+(-0.075P^{-1/2} - 45P^{-2} + 0.0070) \times \exp\left[-(40 - 520P^{-2/3})\left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right]$$
(2.92)

$$R(\phi/\phi^*) = \exp(-P^{1/2}\phi - 0.3P^{3/2}\phi^3)$$
(2.93)

となる。

以上を纏めると、Z 函数の経験式は

$$Z(T,\phi;P) = \chi_{\rm conc}^{\circ}(T;P) + \frac{1}{2}\phi + \frac{A(P)\phi^4}{1+B(T;P)\phi^2} + [\chi_{\rm dil}^{\circ}(T) - \chi_{\rm conc}^{\circ}(T;P)]R(P^{1/2}\phi)$$
(2.94)

と表される。ただし、 $\chi^{\circ}_{dil}(T)$ 、 $\chi^{\circ}_{conc}(T; P)$ 、 $R(P^{1/2}\phi)$ はそれぞれ式 (2.91)、 (2.92)、 (2.93) で与えられる。また、 $A(P) \ge B(T; P)$ は

$$A(P) = 1.4P^{1/3} \tag{2.95}$$

$$B(T; P) = 7P^{1/3} \exp\left[-18\left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right]$$
 (2.96)

である。

Z の定義式 (2.73) より、χは

$$\chi = \frac{2}{\phi^2} \int_0^{\phi} Z\phi \mathrm{d}\phi \tag{2.97}$$

である。この式に式 (2.94) を代入すると

$$\chi(T,\phi;P) = \chi_{\rm conc}^{\circ}(T;P) + \frac{1}{3}\phi + \frac{A(P)}{B(T;P)} \times \left\{ \frac{\phi^2}{2} - \frac{1}{B(T;P)} + \frac{\ln[1+B(T;P)\phi^2]}{B(T;P)^2\phi^2} \right\} + [\chi_{\rm dil}^{\circ}(T) - \chi_{\rm conc}^{\circ}(T;P)]Q(P^{1/2}\phi)$$
(2.98)

となる。ここで、

$$Q(x) \equiv \frac{0.754}{x^2} [1 - (1 + 1.875x + 0.864x^2 + 0.525x^3) \times \exp(-1.875x - 0.432x^2 - 0.175x^3)]$$
(2.99)



図 2.11 臨界濃度 ϕ_c の鎖長依存性

である。なお、この式は $(2/x^2) \int_0^x R(x) x \mathrm{d}x$ の数値計算の結果に合わせた式である。

Z 函数を用いて臨界点の式を表すと

$$\frac{1}{1 - \phi_c} + \frac{1}{P\phi_c} = 2Z_c \tag{2.100}$$

$$\frac{1}{(1-\phi_c)^2} - \frac{1}{(P\phi_c)^2} = 2\left(\frac{\partial Z}{\partial\phi}\right)_c \tag{2.101}$$

となる。添え字cは臨界点であることを示す。これらの式に式(2.94)を代入すると

$$\frac{\phi_c^2}{2(1-\phi_c)} + \frac{1}{2P\phi_c} = \chi_{\text{conc}}^\circ(T_c; P) - \frac{1}{2} + \frac{A(P)\phi_c^4}{1+B(T_c; P)\phi_c^2} + [\chi_{\text{dil}}^\circ(T_c) - \chi_{\text{conc}}^\circ(T_c; P)]R(P^{1/2}\phi_c) (2.102)$$

$$\frac{\phi_c(2-\phi_c)}{2(1-\phi_c)^2} - \frac{1}{2P\phi_c^2} = \frac{2A(P)[2+B(T_c;P)\phi_c^2]\phi_c^3}{[1+B(T_c;P)\phi_c^2]^2} -P^{1/2}[\chi_{\rm dil}^\circ(T_c) - \chi_{\rm conc}^\circ(T_c;P)] \times (1+0.9P\phi_c^2)R(P^{1/2}\phi_c)$$
(2.103)



図 2.12 臨界温度 T_c の鎖長依存性

となる。これらの式による計算結果と種々の P に対する実測の臨界点の データとの比較が図 2.11 と 2.12 である。図中の実線が計算結果で、実験 結果をよく表すことが分かる。なお、これらの結果は Flory-Huggins 理論 の式 (2.47) および式 (2.48) と (2.49) とは大きく異なっていることに注意 されたい。

式 (2.97)の χ を用いて相平衡条件より計算した共存曲線を図 2.13の実 線で示す。この図中の点は共存組成を表す点あるいは沈澱点である。(重 量平均)分子量 M_w は上から順に 1560000、4980000、200000、103000、 45300 である。丸印は共存組成を表す点あるいは沈澱点である。多少のず れは見られるが、計算値は実測値をよく再現していると云える。

同じく式 (2.97) の χ を用いた μ_0 から計算した尖点曲線が図 2.14 の実 線である。図中の丸印は実験値で、 M_w は上から順に 520000、163000、 110000、51000、43600 である。どの分子量の場合も、計算値と実測値と の一致は良好である。



図 2.13 アタクチックポリスチレン+シクロヘキサン溶液の曇点曲線



図 2.14 アタクチックポリスチレン+シクロヘキサン溶液の尖点曲線



図 2.15 ポリイソプレン+ジオキサン溶液の光散乱結果

2.2.2 ポリイソプレン+ジオキサン系

もう 1 つの例を挙げる。対象とするのはポリイソプレンのジオキサン 2 成分溶液である。図 2.15 に $-(1/RT)(\partial\mu_0/\partial\phi)_{T,p}$ 対 ϕ のプロットを示 す。¹³ 試料 P-5 の分子量 M_w は 53300 で、測定温度は上から順に 40.0、 37.0、34.0、32.5、31.5、29.0、27.0、25.0、23.0、21.0 °C である。また、 試料 P-13 の M_w は 133000 で、測定温度は上から 40.0、37.0、34.0、32.5、 31.5、29.0、27.0、26.0 °C である。

試料 P-5、P-13 のどちらの場合も温度 *T* を一定とするデータ点は下に 凸の曲線に従っている。 $-(1/RT)(\partial \mu_0/\partial \phi)_{T,p}$ は温度の低下と共に小さく なり、ある濃度 ϕ で横軸に接近する。特に試料 P-13 の場合、T = 26.0 °C ではデータ点が横軸と殆ど接している。

これらの結果から求めた $Z & \epsilon \phi$ の函数として示したのが図 2.16 である。 図の特徴はアタクチックポリスチレン+ シクロヘキサン 2 成分系の場合 と類似している。したがって、先と同様 Z は

$$Z(T,\phi;P) = \chi^{\circ}_{\text{conc}}(T;P) + \frac{1}{2}\phi + \frac{A(P)\phi^4}{1+B(T;P)\phi^2} + [\chi^{\circ}_{rmdil}(T) - \chi^{\circ}_{\text{conc}}(T;P)]R(\phi;P)$$
(2.104)



図 2.16 ポリイソプレン+ジオキサン溶液の Z 函数

と表すことができる。

また、χは

$$\chi(T,\phi;P) = \chi_{\text{conc}}^{\circ}(T;P) + \frac{1}{3}\phi + \frac{A(P)}{B(T;P)} \left\{ \frac{\phi^2}{2} - \frac{1}{B(T;P)} \ln[1 + B(T;P)\phi^2] \right\} + [\chi_{\text{dil}}^{\circ}(T) - \chi_{\text{conc}}^{\circ}(T;P)]Q(\phi;P)$$
(2.105)

と書ける。これらの式で、 χ°_{dil} は

$$\chi^{\circ}_{\rm dil}(T) = 0.5 + 0.33 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + 4.1 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2$$
 (2.106)

 $\chi^{\circ}_{
m conc}$ lt

$$\chi_{\rm conc}^{\circ}(T;P) = 0.5 - \frac{0.19}{P^{1/2}} + 0.35 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$
(2.107)

A(P) lt

$$A(P) = 2P^{1/3} \tag{2.108}$$

B(T;P) lt

$$B(T;P) = 8.73P^{1/3} - 600\left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$
(2.109)



図 2.17 ポリイソプレン+ジオキサン溶液の曇点曲線と尖点曲線

R t

$$R = \exp(-3.3P^{1/3}\phi) \tag{2.110}$$

Q t

$$Q(\phi; P) = \frac{2}{(3.3P^{1/3}\phi)^2} [1 - (1 + 3.3P^{1/3}\phi)\exp(-3.3P^{1/3}\phi)] \quad (2.111)$$

である。図 2.16 の実線はこれらの式を用いた計算値で、実験値をよく表 している。

また、これらの式から計算した共存曲線と尖点曲線が図 2.17 の実線で ある。この図において、白丸は曇点の実験値を、黒丸は尖点の実験値であ る。計算値と実験値との一致は非常によい。これは Z あるいは χ に濃度 依存性および鎖長依存性を正しく取り入れたことによっている。

以上の結果から解ることは、(1) 濃度 ϕ の函数としての χ は明確に濃度 依存性をことにする 2 つの函数を ϕ の増加と共に乗り移ること、(2) 高分 子鎖が重なり合う濃厚領域でも χ は分子量に依存することである。



図 2.18 溶媒の化学ポテンシャル μ_0 (アタクチックポリスチレン+シクロヘキサン系)

2.3 現象論2

ここでは、もう1つの全く別の現象論的方法を述べる。¹⁴ アタクチッ クポリスチレン+シクロヘキサン2成分系について、式 (2.98)の χ を用 いて計算した溶媒の過剰化学ポテンシャル $\Delta\mu_0(=\mu_0 - \mu_0^\circ)$ を図 2.18 に 実線で示している。ただし、分子量 M = 200000の場合である。図中の 破線は Flory-Huggins 理論の無熱溶液の $\Delta\mu_0$ 、つまり、混合エントロピー に基く値を示す。図から、Flory-Huggins 無熱溶液の $\Delta\mu_0$ が Θ 温度以下 の(相分離が起こる)温度領域における実在高分子溶液の $\Delta\mu_0$ から遠く離 れていることが分かる。この差が $\chi\phi^2$ で表されることになる。上記のよ うに、 χ の表現が複雑になるのは、一因としてこの差が大きすぎることに ある。図中の鎖線は van't Hoff の式

$$\Delta \mu_0 = \mu_0 - \mu_0^\circ = -RT \frac{\phi}{P}$$
 (2.112)

を表したものである。この式による $\Delta \mu_0$ は当然ながら実在溶液の $\Delta \mu_0$ に近い。そこで、van't Hoff の式に従う溶液を、van't Hoff 溶液と称するこ

とにし、それを基準とする現象論を以下に展開する。

まず、溶媒成分0の化学ポテンシャル μ_0 を

$$\mu_0 = \mu_0^\circ - RT\left[\frac{\phi}{P} + \Gamma(T,\phi;P)\phi^2\right]$$
(2.113)

と表して、見掛けの第 2 ビリアル係数 Γ を定義する。 *Gamma* は Flory-Huggins 理論に基く現象論における χ と

$$\Gamma = -\chi - \frac{\ln(1-\phi) + \phi}{\phi^2}$$
 (2.114)

の関係がある。図 2.18 から分かるように Γ は小さい量であるから、この 式は χ の大きな部分が右辺の第 2 項と打ち消しあっていることを示して いる。言い換えると、Flory-Huggins 理論による混合エントロピーと実在 高分子溶液のそれとのずれによる影響が χ に現れていることになる。こ れが、Flory-Huggins 理論を基準とするのが得策ではない理由である。

式 (2.113) を用いると、Gibbs-Duhem の式 (1.93) より、溶質高分子成 分 1 の化学ポテンシャル μ_1 は

$$\mu_1 = \mu_1^{\infty} + RT[\ln\phi - \phi + \Gamma P\phi(1-\phi) + P\int_0^{\phi} \Gamma d\phi]$$
(2.115)

と表される。ここで

$$\mu_1^{\infty} \equiv \lim_{\phi \to 0} (\mu_1 - RT \ln \phi) \tag{2.116}$$

である。式 (2.113) と (2.115) から、Gibbs 自由エネルギー G は

$$G = (n_0 + Pn_1) \left\{ (1 - \phi) \mu_0^\circ + \frac{\phi}{P} \mu_1^\infty + RT \left[-\frac{\phi}{P} + \frac{\phi \ln \phi}{P} + \phi \int_0^\phi \Gamma d\phi \right] \right\}$$
(2.117)

と表される。

ここで、新たな函数 Jを

$$J \equiv \Gamma + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial \phi} \right) \phi \tag{2.118}$$



図 2.19 アタクチックポリスチレン+シクロヘキサン溶液の J 函数

で定義する。*J*は先に定義した *Z* と

$$J = -Z + \frac{1}{2(1-\phi)} \tag{2.119}$$

の関係がある。図 2.7 の *Z* から *J* を求めた結果を示したのが図 2.19 である。*Z* 函数の場合と同様、*J* は 2 つの函数の和で表せる。

$$J = J_{\rm conc} + (J^{\circ}_{\rm dil} - J^{\circ}_{\rm conc})Q \qquad (2.120)$$

式中の 3 つの量 J°_{dil} 、 J_{conc} 、 Q の内、 J°_{dil} は式 (2.91) の χ°_{dil} と

$$J_{\rm dil}^{\circ} = \frac{1}{2} - \chi_{\rm dil}^{\circ}$$
 (2.121)

の関係があり、

$$J_{\rm dil}^{\rm o} = -0.26 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) - 4.6 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2$$
(2.122)

と表される。 J_{conc} と Q について、試行錯誤の後得た式は

$$J_{\rm conc} = J_{c0} + J_{c1}\phi^2 \tag{2.123}$$


図 2.20 アタクチックポリスチレン+シクロヘキサン溶液の曇点曲線

$$Q = \exp(-P^{1/2}\phi)$$
 (2.124)

である。なお、 $J_{
m conc}^{\circ}=J_{c0}$ である。ここで、

$$J_{c0} = \frac{0.036}{P^{1/3}} - 0.23 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$
(2.125)

$$J_{c1} = 0.47 - 3.5 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) \tag{2.126}$$

と表せる。図 2.19 の破線は式 (2.123) による J_{conc} の計算値を、実線は式 (2.120) による計算値である。破線と実線の差が式 (2.120) の右辺第 2 項に なる。実線は実験結果をよく表していると云える。

式 2.118 より、

$$\Gamma = \frac{1}{\phi^2} \int_0^{\phi} J\phi^{\rm d}\phi \qquad (2.127)$$

であり、

$$\Gamma = J_{c0} + \frac{1}{2}J_{c1}\phi^2$$

$$+2(J_{\rm dil}^{\circ} - J_{c0})\frac{1 - (1 + P^{1/2}\phi)\exp\left(-P^{1/2}\phi\right)}{p\phi^2} \qquad (2.128)$$

と書ける。この式を μ_0 に対する式 (2.113) と μ_1 に対する式 (2.115) に代 入して、相平衡条件より計算した共存曲線の結果が図 2.20 の実線である。 計算による共存曲線は丸印で示す曇点あるいは共存組成の実験結果とよい 一致を示している。

2.A 電磁気学と光散乱

出発点は以下の Maxwell 方程式である。

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{\tilde{c}} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{4\pi}{\tilde{c}} \mathbf{j}$$
 (2.A.1)

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{\tilde{c}} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$
 (2.A.2)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi \tilde{\rho} \tag{2.A.3}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2.A.4}$$

ここで、H は磁気べくとる、E は電気ベクトル、D は電気変位、B は磁気 誘導、j は電流密度、 $\tilde{\rho}$ は電荷密度、 \tilde{c} は真空中における光速である。D,B,j に対する物質方程式が

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \tag{2.A.5}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \tag{2.A.6}$$

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \tag{2.A.7}$$

のように表される。ここで、 ϵ は誘電率、 μ は透磁率、 σ は電導度である。 誘電体の場合 $\mu = 1$ 、 $\sigma = 0$ である。

誘起振動双極子による電場を求めてみよう。原点近傍の点電荷をq、その位置を \mathbf{r}' とすると、双極子能率 P は

$$\mathbf{P} = q\mathbf{r}' \tag{2.A.8}$$

と書ける。以下、位置 R の点 A でのこの双極子による場を求める。媒体 の誘電率を ϵ とする。R \gg r' より、R \simeq r (r は位置 r' と点 A を結ぶ Vector) である。この場合

$$\mathbf{j} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \tag{2.A.9}$$

$$\tilde{\rho} = -\bigtriangledown \cdot \mathbf{P} \tag{2.A.10}$$

式 (2.A.5) から (2.A.10) を式 (2.A.1) から (2.A.4) に代入すると以下の式 が得られる。

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\epsilon}{\tilde{c}} \dot{\mathbf{E}} = \frac{4\pi}{\tilde{c}} \dot{\mathbf{P}}$$
 (2.A.11)

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{\tilde{c}}\dot{\mathbf{H}} = 0$$
 (2.A.12)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{4\pi}{\epsilon} \nabla \cdot \mathbf{P} \tag{2.A.13}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \tag{2.A.14}$$

ただし, $\cdot=\partial/\partial t$ は時間微分を表す。

いま、ベクトルポテンシャル A を導入して

$$\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A} \tag{2.A.15}$$

とおくと,式(2.A.14)は常に成立する.式(2.A.12)より、

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{1}{\tilde{c}}\dot{\mathbf{A}}\right) = 0 \tag{2.A.16}$$

である。したがって,スカラーポテンシャル ϕ を用いて

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{\tilde{c}}\dot{\mathbf{A}} - \nabla\phi \qquad (2.A.17)$$

とおくと、式 (2.A.12) は自動的に成立する。

残っている式 (2.A.11) と (2.A.13) より、

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\epsilon}{\tilde{c}^2} \ddot{\mathbf{A}} - \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{\epsilon}{\tilde{c}} \dot{\phi}) = -\frac{4\pi}{\tilde{c}} \dot{\mathbf{P}}$$
(2.A.18)

$$\nabla^2 \phi - \frac{\epsilon}{\tilde{c}^2} \ddot{\phi} + \frac{1}{\tilde{c}} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{\epsilon}{\tilde{c}} \dot{\phi}) = \frac{4\pi}{\epsilon} \nabla \cdot \mathbf{P}$$
(2.A.19)

と書ける。これらの式を用いて式 (2.A.11)-(2.A.14) から H, E を求める のは, Lorentz 条件

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{\epsilon}{\tilde{c}} \dot{\phi} = 0 \tag{2.A.20}$$

を満たす $\mathbf{A} \ge \phi$ を

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\epsilon}{\tilde{c}} \ddot{\mathbf{A}} = -\frac{4\pi}{\tilde{c}} \dot{\mathbf{P}}$$
(2.A.21)

$$\nabla^2 \phi - \frac{\epsilon}{\tilde{c}} \ddot{\phi} = \frac{4\pi}{\epsilon} \nabla \cdot \mathbf{P}$$
 (2.A.22)

から求めることに帰着する.

ここで,

$$\mathbf{A} \equiv \frac{1}{\tilde{c}} \dot{\Pi} \tag{2.A.23}$$

2.A 電磁気学と光散乱

$$\phi \equiv -\frac{1}{\epsilon} \nabla \cdot \Pi \tag{2.A.24}$$

で定義する Hertz ベクトル II を用いると, Lorentz 条件 (2.A.20) が成立 する。式 (2.A.21) と (2.A.22) は共に

$$\nabla^2 \Pi - \frac{\epsilon}{\tilde{c}^2} \ddot{\Pi} = -4\pi \mathbf{P} \tag{2.A.25}$$

となる。この式の解は

$$\Pi = \frac{P(t - r/\tilde{c}')}{r}\mathbf{e}$$
(2.A.26)

で与えられる。ここで、eはPの方向の単位ベクトルである。

.

Hertz ベクトル (2.A.26 は以下のようにして求められる。いま、P を

$$\mathbf{P} \equiv P(t)\delta(\mathbf{r})\mathbf{e} \tag{2.A.27}$$

とする。 Π の \mathbf{e}_x 成分を $\psi(\mathbf{r},t)$ とおくと、式(2.A.25)より

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) - \frac{\epsilon}{\tilde{c}^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(\mathbf{r}, t) = -4\pi P(t)\delta(\mathbf{r})$$
(2.A.28)

が得られる。Fourier 変換

$$\psi(\mathbf{r},\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\mathbf{r},t) \exp(-i\omega t) dt \qquad (2.A.29)$$

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(t) \exp(-i\omega t) dt \qquad (2.A.30)$$

を用いて式 (2.A.28) を

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r},\omega) + k^2 \psi(\mathbf{r},\omega) = -4\pi P(\omega)\delta(\mathbf{r}) \qquad (2.A.31)$$

と変換する。ここで、

$$k^2 \equiv \epsilon \omega^2 / \tilde{c}^2 \tag{2.A.32}$$

である。

 ψ は原点のまわりで球対称であるとすると式 (2.A.31) は

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}(r\psi) + k^2\psi = -4\pi P(\omega)\delta(\mathbf{r}) \qquad (2.A.33)$$

と書ける。 $r \neq 0$ では右辺は 0 である。したがって、 $r\psi = Af(r)$ とおき、 f(r)を求めると、 $f(r) = \exp(-ikr)$ となる。ここから

$$\psi = A \frac{\exp(-ikr)}{r} \tag{2.A.34}$$

と表される。A は原点で ψ が式 (2.A.33)を満たすように決定する。結果 は $A=P(\omega)$ である。結果として、

$$\psi(\mathbf{r},\omega) = P(\omega) \frac{\exp(-ikr)}{r}$$
(2.A.35)

となる。 Fourier 逆変換

$$\psi(r,t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P(\omega) \frac{\exp(-ikr)}{r} \exp(i\omega t) d\omega$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} P(\omega) \frac{\exp[i\omega(t-r/\tilde{c}')]}{r} d\omega \qquad (2.A.36)$$

より、

$$\psi(r,t) = P(t-r/\tilde{c}')/r \qquad (2.A.37)$$

が得られる。 $\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ 成分についても \mathbf{e}_x 成分と同様であり、それら3方向の式を纏めると式 (2.A.26) となる。

.

式 (2.A.26) を

$$\Pi = \frac{\{P\}}{r} \mathbf{e} \qquad \text{or} \qquad \Pi = \frac{\{\mathbf{P}\}}{r} \tag{2.A.38}$$

と書くことにする . ただし , \tilde{c}' は誘電率 ϵ の媒体中での光速とする。媒体の屈折率を \tilde{n} とすると

$$\tilde{c}' = \tilde{c}/\tilde{n}, \quad \epsilon = \tilde{n}^2$$
 (2.A.39)

である。式 (2.A.15)、(2.A.17)、(2.A.23) と (2.A.24) より、

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\tilde{c}} \nabla \times \dot{\Pi} \tag{2.A.40}$$

2.A 電磁気学と光散乱

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon} \nabla \times \nabla \times \Pi - \frac{4\pi}{\epsilon} \mathbf{P}$$
(2.A.41)

となる。原点近傍以外 $(r \neq 0)$ では、 $\mathbf{P} = 0$ であるから、

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon} \nabla (\nabla \cdot \Pi) - \frac{1}{\tilde{c}^2} \ddot{\Pi}$$
(2.A.42)

である。式 (2.A.26) を式 (2.A.40) と (2.A.42) に代入して、具体的に計算 すると、

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon} \left[\frac{\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \{\vec{\mathbf{P}}\})}{\tilde{c}'^2 r^3} + \frac{\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \{\vec{\mathbf{P}}\} + 2\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \{\vec{\mathbf{P}}\}))}{\tilde{c}' r^4} + \frac{\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \{\mathbf{P}\}) + 2\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \{\mathbf{P}\})}{r^5} \right]$$
(2.A.43)

$$\mathbf{H} = -\frac{1}{\tilde{c}} \left(\frac{\mathbf{r} \times \{\vec{\mathbf{P}}\}}{\tilde{c}' r^2} + \frac{\mathbf{r} \times \{\vec{\mathbf{P}}\}}{r^3} \right)$$
(2.A.44)

となる。 $r \gg \lambda$ (λ : 波長) のとき

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon} \frac{\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \{\ddot{\mathbf{P}}\})}{\tilde{c}^{\prime 2} r^3}$$
(2.A.45)

$$\mathbf{H} = -\frac{\mathbf{r} \times \{\ddot{\mathbf{P}}\}}{\tilde{c}\tilde{c}'r^2} \tag{2.A.46}$$

である。

次に以上の結果から、Rayleigh 比 R_{θ} を求める。

P を x 方向にとり、r 方向の単位ベクトルを \mathbf{e}_r 、x 方向と r 方向のなす 角を θ_x とすると

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r \tag{2.A.47}$$

$$\mathbf{e} = \cos\theta_x \mathbf{e}_r - \sin\theta_x \mathbf{e}_{\theta_x} \tag{2.A.48}$$

である。したがって、式 (2.A.45) より

$$\mathbf{E} = \frac{\{\dot{P}\}\sin\theta_x}{\epsilon \tilde{c}'^2 r} \mathbf{e}_{\theta_x} \equiv E_{\theta_x} \mathbf{e}_{\theta_x}$$
(2.A.49)

$$E_{\theta_x} = \frac{\{\ddot{P}\}\sin\theta_x}{\tilde{c}^2 r} \tag{2.A.50}$$

2章 2成分高分子溶液の相平衡

が得られる。また、式 (2.A.46) より

$$\mathbf{H} = \frac{\{\ddot{P}\}\sin\theta_x}{\tilde{c}\tilde{c}'r}\mathbf{e}_{\phi} \equiv H_{\phi}\mathbf{e}_{\phi}$$
(2.A.51)

$$H_{\phi} = \frac{\{\tilde{P}\}\sin\theta_x}{\tilde{c}\tilde{c}'r} = \tilde{n}E_{\theta_x}$$
(2.A.52)

となる。

r方向に単位面積を通過するエネルギーを表す Poynting ベクトルSは

$$\mathbf{S} \equiv \frac{\tilde{c}}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \tag{2.A.53}$$

で定義され、

$$\mathbf{S} = \frac{\tilde{n}\tilde{c}}{4\pi} E_{\theta_x}^{\ 2} \mathbf{e}_r = \frac{\tilde{n}\{\vec{P}\}^2 \sin^2\theta_x}{4\pi\tilde{c}^3 r^2} \mathbf{e}_r \tag{2.A.54}$$

と計算できる。時間平均をとると

$$\bar{S} = \frac{\tilde{n}\tilde{c}}{4\pi} \overline{E_{\theta_x}}^2 \equiv \frac{\tilde{n}\tilde{c}}{8\pi} I \qquad (2.A.55)$$

となる。この式は強度 I の定義を与える。 $I = 2\overline{E_{\theta_x}^2}$ 、 $E_{\theta_x} = E_{0\theta_x} \exp(i\omega t)$ と書けるとき、

$$I = E_{0\theta_r}^2 \tag{2.A.56}$$

である。

入射光がx方向のみの電気ベクトルを持つ平面偏光のとき、 $\mathbf{E}^0 = \mathbf{E}_0^0 \times \exp(i\omega t)$ (z方向) とすると

$$\mathbf{P} = \alpha \mathbf{E}_0^{\ 0} \exp(i\omega t) \tag{2.A.57}$$

と書ける。ここで、*α*はスカラー分極率とする。式 (2.A.50) より

$$E_{\theta_x} = -\frac{\sin\theta_x}{\tilde{c}^2 r} \omega^2 \alpha E_0^{\ 0} \exp[i\omega(t-r/\tilde{c}')] \qquad (2.A.58)$$

である。したがって、式 (2.A.56) より

$$I = \alpha^2 (E_0^{\ 0})^2 \frac{16\pi^4}{\lambda^4} \frac{\sin^2 \theta_x}{r^2}$$
(2.A.59)

が得られる。この式は、入射光強度 $I_0 = (E_0^0)^2$ より

$$\frac{I}{I_0} = \frac{16\pi^4}{\lambda^4} \alpha^2 \frac{\sin^2 \theta_x}{r^2}$$
(2.A.60)

と書ける。

入射光が自然光 (非偏光)の場合、入射光の方向を z軸とすると、 \mathbf{E}^0 、 **P** は x軸と y軸の成分を持つ。この場合、

$$\mathbf{S} = \frac{\tilde{n}\tilde{c}}{4\pi} (E_{\theta_x}^2 + E_{\theta_y}^2) \mathbf{e}_r \tag{2.A.61}$$

であり、

$$\bar{S} = \frac{\tilde{n}\tilde{c}}{4\pi} (\overline{E_{\theta_x}^2} + \overline{E_{\theta_y}^2}) \equiv \frac{\tilde{n}\tilde{c}}{8\pi} I \qquad (2.A.62)$$

となる。したがって、

$$I = 2(\overline{E_{\theta_x}^2} + \overline{E_{\theta_y}^2}) = (E_{0\theta_x}^2 + E_{0\theta_y}^2)$$
(2.A.63)

となる。 $I_0 = 2(E_0^{\ 0})^2$ より

$$\frac{I}{I_0} = \frac{8\pi^4 \alpha^2}{\lambda^4 r^2} (\sin^2 \theta_x + \sin^2 \theta_y) = \frac{8\pi^4 \alpha^2}{\lambda^4 r^2} (1 + \cos^2 \theta)$$
(2.A.64)

を得ることができる。ここで、 θ は r と z 軸 (入射光方向)のなす角で、散 乱角と呼ばれる。

散乱体積 V 中に N 個の独立で等価な等方散乱体があるとすると

$$\frac{I}{I^0} = \frac{8\pi^4 \alpha^2}{\lambda^4 r^2} N(1 + \cos^2 \theta)$$
(2.A.65)

である。ここで、Rayleigh 比 R_{θ} を

$$R_{\theta} \equiv \frac{I}{VI_0} \frac{r^2}{1 + \cos^2\theta} \tag{2.A.66}$$

と定義する。したがって、

$$R_{\theta} = \frac{8\pi^4 \alpha^2}{\lambda^4} \frac{N}{V} = \frac{8\pi^4 \alpha^2}{\lambda^4} \rho \qquad (2.A.67)$$

と表される。 $\rho \equiv N/V$ は散乱体の数密度である。

2.B 揺らぎと光散乱

溶液中に体積 V の領域を考える.領域 V の径は入射光波長に比べて小さく,分子多数を含むのに充分な大きさとする.この領域の瞬間的過剰誘電 率 $\Delta \epsilon$ は

$$\Delta \epsilon = \epsilon - \langle \epsilon \rangle \tag{2.B.1}$$

と書ける。この体積 V をもつ領域を, $\Delta \epsilon$ をもつ粒子と見なすと,補遺 2.A の議論がそのまま適用できる.瞬間的過剰分極率を $\Delta \alpha = \alpha - \langle \alpha \rangle$ と すると、

$$\Delta \alpha = \frac{V}{4\pi} \Delta \epsilon = \frac{V}{2\pi} \tilde{n} \Delta \tilde{n}$$
(2.B.2)

である。ここで 〈〉 は平均値を表す。したがって,式 (2.A.67) の α^2 を $\overline{(\Delta \alpha)^2}$ (時間平均) で, ρ を V^{-1} で置き換え,時間平均=Ensemble 平均と すると, Rayleigh 比は

$$R_{\theta}^{*} = \frac{2\pi^2 \tilde{n}^2 V}{\lambda^4} \langle (\Delta \tilde{n})^2 \rangle \tag{2.B.3}$$

と表される。 R_{θ}^* は溶質、溶媒による散乱全てを含んでいる。 R_{θ}^* を求めるには、密度および組成のゆらぎによる \hat{n} のゆらぎを求めればよい。

まず、 R_{θ}^* の一般式を導く。系は、温度 T と圧力 p が一定で、主溶媒 (Species 0)の分子数は一定とする。この系では、エネルギー E、 体積 V、 化学種 r の分子数 (N_1, N_2, \dots, N_r) はそれぞれの平均値 $\langle E \rangle, \langle V \rangle, \langle N_1 \rangle,$ $\dots, \langle N_r \rangle$ のまわりで揺らぐ。系を規定する独立な状態変数は、T、p、 N_0 、 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ である。これを Hybrid Ensemble と云う。

$$\mathbf{N} = N_0, N_1, \cdots, N_r$$
$$\mathbf{N}' = N_1, N_2, \cdots, N_r$$
$$\boldsymbol{\mu}' = \mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_r$$
(2.B.4)

と書くことにする.

Hybrid Ensemble に対する分配関数 $\Gamma(T, p, N_0, \mu')$ は

$$\Gamma(T, p, N_0, \boldsymbol{\mu}') = \sum_{V} \sum_{\mathbf{N}' \ge 0} e^{-pV/kT} e^{\mathbf{N}' \cdot \boldsymbol{\mu}'/kT} Q(T, V, \mathbf{N})$$
(2.B.5)

と書ける。ここで、*Q*はNが一定の閉じた系に対する分配関数 (Canonical Ensemble) である。*Q*は Helmholtz 自由エネルギー *A* と

$$A = -kT\ln Q \tag{2.B.6}$$

の関係がある。与えられた $T、 p、 N_0、\mu'の下で、系が<math display="inline">V$ 、N'をとる確率 $P(V,\mathbf{N}';T,p,N_0,\mu')$ は

$$P(V, \mathbf{N}') = \Gamma^{-1} \exp[(-pV + \sum_{i=1}^{r} N_i \mu_i - A)/kT]$$
(2.B.7)

$$A \equiv A(T, V, \mathbf{N}) \tag{2.B.8}$$

で与えられる。 $(-pV + \sum N_i\mu_i - A)$ を $\langle V \rangle$ 、 $\langle N_i \rangle$ のまわりで展開する。 ここで、 $\Delta V = V - \langle V \rangle$ 、 $\Delta N_i = N_i - \langle N_i \rangle$ とおく。 ΔV 、 ΔN_i は小さく、 最確値 (most probable value)のまわりに Gauss 分布するとしてよい。高 次項は無視すると、

$$P(V, \mathbf{N}') = C \exp(-\varphi/kT)$$
(2.B.9)

$$\varphi \equiv \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 A}{\partial V^2} \right)_{T,\mathbf{N}} (\Delta V)^2 + \sum_{i=1}^r \left(\frac{\partial^2 A}{\partial V \partial N_i} \right)_{T,V,N_k} \Delta V \Delta N_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r \left(\frac{\partial^2 A}{\partial N_i \partial N_j} \right)_{T,V,N_k} \Delta N_i \Delta N_j \qquad (2.B.10)$$

となる。ただし、Cは規格化定数である。熱力学関係式より,

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,\mathbf{N}} = -p, \qquad \left(\frac{\partial A}{\partial N_i}\right)_{T,V,N_k} = \mu_i$$
 (2.B.11)

$$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial V^2}\right)_{T,\mathbf{N}} = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,\mathbf{N}} = \frac{1}{\kappa \langle V \rangle}$$
(2.B.12)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 A}{\partial V \partial N_i} \end{pmatrix}_{T,V,N_k} = -\left(\frac{\partial p}{\partial N_i}\right)_{T,V,N_k} = \frac{(\partial V/\partial N_i)_{T,P,N_k}}{(\partial V/\partial p)_{T,\mathbf{N}}} = -\frac{V_i}{\kappa \langle V \rangle}$$
(2.B.13)

2章 2成分高分子溶液の相平衡

である。ただし、 V_i は成分 i の部分分子体積であり、 κ は等温圧縮率で

$$\kappa \equiv -\frac{1}{\langle V \rangle} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T, \mathbf{N}} \tag{2.B.14}$$

で定義される。次の関係

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 A}{\partial N_i \partial N_j} \end{pmatrix}_{T,V,N_k} = \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial N_j} \right)_{T,V,N_k} = \left(\frac{\partial \mu_j}{\partial N_i} \right)_{T,V,N_k}$$
$$= \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial N_j} \right)_{T,p,N_k}$$
$$+ \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{T,\mathbf{N}} \left(\frac{\partial p}{\partial N_j} \right)_{T,V,N_k}$$
(2.B.15)

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{N}} = V_i, \qquad m_i = \frac{M_i N_i}{M_0 N_0} \tag{2.B.16}$$

を用いると、

$$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial N_i \partial N_j}\right)_{T,V,N_k} = \frac{V_i V_j}{\kappa \langle V \rangle} + \frac{M_j}{M_0 N_0} \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial m_j}\right)_{T,p,m_k}$$
(2.B.17)

と書ける。ここで、 M_0 、 M_j はそれぞれ成分0とjの分子量である。 いま、

$$\xi \equiv -\frac{\Delta V}{\langle V \rangle} + \sum_{i=1}^{r} \frac{V_i \Delta N_i}{\langle V \rangle}$$
(2.B.18)

$$x_i \equiv \frac{\Delta N_i}{\langle N_i \rangle} = \frac{\Delta m_i}{\langle m_i \rangle} \quad (i = 1, 2, \cdots, r)$$
 (2.B.19)

とおくと、式 (2.B.13)、 (2.B.14)、 (2.B.17) より , 式 (2.B.10) は

$$\varphi = \frac{V}{2\kappa}\xi^2 + \frac{M_0N_0}{2}\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r \frac{m_im_j}{M_i} \left(\frac{\partial\mu_i}{\partial m_j}\right)_{T,p,m_k} x_i x_j \qquad (2.B.20)$$

と書ける。ただし、 $\langle V \rangle = V$ 、 $\langle m_j \rangle = m_j$ とした。 $P(V, \mathbf{N}')$ は変数を V、 N_i から ξ 、 x_i に変換して、

$$P(\xi, x_1, \cdots, x_r) = C \exp\left(-\frac{V}{2\kappa kT}\xi^2 - \frac{M_0 N_0}{2}\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r \psi_{ij} x_i x_j\right) (2.B.21)$$

$$\psi_{ij} = \frac{m_i m_j}{M_i k T} \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial m_j}\right)_{T,p,m_k} = \frac{m_i m_j}{M_j k T} \left(\frac{\partial \mu_j}{\partial m_i}\right)_{T,p,m_k} = \psi_{ji} \qquad (2.B.22)$$

となる。後述のように、光散乱で必要になるのは $\langle \xi^2 \rangle$ と $\langle x_i x_j \rangle$ である。 以下、 $\langle \xi^2 \rangle$ と $\langle x_i x_j \rangle$ を求める。このためにまず、規格化定数 C を決定 する。 ψ_{ij} を要素とする行列 ψ は対称行列であり、直交行列 Q で対角化で きる。すなわち、

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}} \tag{2.B.23}$$

$$\mathbf{Q}^{-1}\boldsymbol{\psi}\mathbf{Q} = \boldsymbol{\Lambda} \tag{2.B.24}$$

である。ここで、 Λ は要素 λ_i の対角行列で、 $|\psi| = |\Lambda|$ である。Q による x の $\boldsymbol{\xi}$ への変換

 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\boldsymbol{\xi} \qquad \boldsymbol{\xi} = \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_r \qquad (\boldsymbol{\xi} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{x})$ (2.B.25)

を用いると、

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\mathbf{x} = (\mathbf{Q}\boldsymbol{\xi})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}(\mathbf{Q}\boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}(\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\psi}\mathbf{Q})\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\xi}$$
(2.B.26)

となる。したがって、*P*は

$$P = C \exp\left(-\frac{V}{2\kappa kT}\xi^2 - \frac{M_0 N_0}{2}\sum_{i=1}^r \lambda_i \xi_i^2\right)$$
(2.B.27)

と表される。 $\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} Pd\xi d\xi_1 d\xi_2 \cdots d\xi_r = 1$ より

$$C = \left[\frac{V(M_0 N_0/2)^r}{2\pi^{r+1}\kappa kT} \mid \psi \mid\right]^{1/2}$$
(2.B.28)

が求まる。

式(2.B.27)と(2.B.28)より、

$$\langle \xi^2 \rangle = \frac{\kappa kT}{V} \tag{2.B.29}$$

$$\langle \xi_i^2 \rangle = \frac{1}{M_0 N_0 \lambda_i}, \qquad \langle \xi_i \xi_j \rangle = 0$$
 (2.B.30)

となる。 $x_i x_j = \sum_k \sum_l Q_{ik} Q_{jl} \xi_k \xi_l$ と書けるので、式 (2.B.30) より、

$$\langle x_i x_j \rangle = \sum_k Q_{ik} Q_{jk} \langle \xi_k^2 \rangle$$
$$= \frac{1}{M_0 N_0} \sum_k \frac{Q_{ik} Q_{jk}}{\lambda_k}$$
(2.B.31)

と書ける。ここで、

$$\sum_{k} \frac{Q_{ik} Q_{jk}}{\lambda_k} = (\mathbf{Q} \mathbf{\Lambda}^{-1} \mathbf{Q}^{\mathrm{T}})_{ij}$$
$$= (\boldsymbol{\psi}^{-1})_{ij} = \frac{\psi^{ij}}{|\boldsymbol{\psi}|}$$
(2.B.32)

より、

$$\langle x_i x_j \rangle = \frac{\psi^{ij}}{M_0 N_0 \mid \boldsymbol{\psi} \mid} \tag{2.B.33}$$

と表される。ただし、 ψ^{ij} は ψ_{ij} の余因子である。 $\langle x_i x_j \rangle$ は x_i の定義より、組成 (濃度)の揺らぎであることがわかる。

 $\langle \xi^2 \rangle$ の意味は次のように得られる。組成一定 ($\Delta N_i = 0$ 、閉じた系) のとき、式 (2.B.18) より、

$$\xi = -\frac{\Delta V}{\langle V \rangle} \tag{2.B.34}$$

である。

$$\rho = \frac{\langle N \rangle}{\langle V \rangle} = \frac{\sum_{i=0}^{r} N_i}{V} = \frac{N}{V} \longrightarrow \ln \rho = \ln N - \ln V \qquad (2.B.35)$$

より、

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta \rho}{\rho} \tag{2.B.36}$$

で、

$$\langle \xi^2 \rangle = \frac{\langle (\Delta \rho)^2 \rangle}{\langle \rho \rangle^2} \tag{2.B.37}$$

となる。ここから、 $\langle \xi^2 \rangle$ は組成一定での密度の揺らぎを表すことがわかる。 Hybrid Ensemble において、屈折率 \tilde{n} の変動は

$$\Delta \tilde{n} = \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial V}\right)_{T,\mathbf{N}} \Delta V + \sum_{i=1}^{r} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial N_{i}}\right)_{T,V,N_{k}} \Delta N_{i}$$
(2.B.38)

と書ける。T、p、Nを独立な状態変数としたとき、

$$d\tilde{n} = \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{m}} dp + \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial T}\right)_{p,\mathbf{m}} dT + \sum_{i=0}^{r} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial N_{i}}\right)_{T,p,N_{k}} dN_{i} \quad (2.B.39)$$

である。この式から、

$$\left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial V}\right)_{T,\mathbf{N}} = \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{m}} \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,\mathbf{N}} = -\frac{1}{\kappa V} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{m}}$$
(2.B.40)

および、

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{n}}{\partial N_i} \end{pmatrix}_{T,V,N_k} = \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial N_i} \right)_{T,p,N_k} + \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p} \right)_{T,\mathbf{m}} \left(\frac{\partial p}{\partial N_i} \right)_{T,V,N_k}$$
$$= \frac{M_i}{M_0 N_0} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_i} \right)_{T,p,m_k} + \frac{V_i}{\kappa V} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p} \right)_{T,\mathbf{m}}$$
(2.B.41)

が得られる。式 (2.B.38)、(2.B.40)、(2.B.41) より、

$$\Delta \tilde{n} = -\frac{\Delta V}{\kappa V} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{m}} + \frac{1}{\kappa V} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{m}} \sum_{i=1}^{r} V_i \Delta N_i$$
$$+ \frac{1}{M_0 N_0} \sum_{i=1}^{r} M_i \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_i}\right)_{T,p,m_k} \Delta N_i$$
$$= \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{m}} \xi + \sum_{i=1}^{r} m_i \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_i}\right)_{T,p,m_k} x_i \qquad (2.B.42)$$

と書ける。

この式と式 (2.B.29) および (2.B.33) より、

$$\begin{split} \langle (\Delta \tilde{n})^2 \rangle &= \frac{1}{\kappa^2} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p} \right)_{T,\mathbf{m}}^2 \langle \xi^2 \rangle \\ &+ \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r m_i m_j \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_i} \right)_{T,p,m_k} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_j} \right)_{T,p,m_k} \langle x_i x_j \rangle \\ &= \frac{kT}{\kappa V} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial p} \right)_{T,\mathbf{m}}^2 \\ &+ \frac{1}{M_0 N_0} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r m_i m_j \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_i} \right)_{T,p,m_k} \times \end{split}$$

$$\left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_j}\right)_{T,p,m_k} \frac{\psi^{ij}}{|\boldsymbol{\psi}|} \tag{2.B.43}$$

を得ることができる。この式を式 (2.B.3) に代入して、

$$R_{\theta}^{*} = \frac{2\pi^{2}\tilde{n}^{2}kT}{\lambda^{4}\kappa} \left(\frac{\partial\tilde{n}}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{m}}^{2} + \frac{2\pi^{2}\tilde{n}^{2}V}{\lambda^{4}M_{0}N_{0}} \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} m_{i}m_{j} \left(\frac{\partial\tilde{n}}{\partial m_{i}}\right)_{T,p,m_{k}} \times \left(\frac{\partial\tilde{n}}{\partial m_{j}}\right)_{T,p,m_{k}} \frac{\psi^{ij}}{|\boldsymbol{\psi}|}$$

$$(2.B.44)$$

の最終結果が得られる。右辺の第1項は密度揺らぎによる散乱 $R_{\theta,0}$ を表し、第2項は濃度揺らぎによる散乱 R_{θ} を表しており

$$R_{\theta}^* = R_{\theta,0} + R_{\theta} \tag{2.B.45}$$

と書かれる。

通常、高分子溶液からの散乱では濃度揺らぎによる散乱が主たる対象になる。成分 0 の質量濃度 $c_0 = M_0 N_0 / N_A V (g/m\ell)$ を用いると、この濃度散乱 R_{θ} は

$$R_{\theta} = \frac{2\pi^2 \tilde{n}^2}{N_{\rm A} \lambda^4 c_0} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r m_i m_j \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_i}\right)_{T,p,m_k} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_j}\right)_{T,p,m_k} \frac{\psi^{ij}}{|\psi|} \quad (2.B.46)$$

と表すことができる。成分 i $(i=1, 2, \dots, r)$ の化学ポテンシャル μ_i は一般に

$$\mu_{i} = \mu_{i}^{0}(T, p) + kT \ln \gamma_{i} m_{i} \qquad (2.B.47)$$

と表される。ただし、 γ_i は活量係数である。稀薄溶液の場合は、 γ_i は

$$\ln \gamma_i = M_i \left(\sum_{j=1}^r B_{ij} m_j + \sum_{j=1}^r \sum_{k=1}^r B_{ijk} m_j m_k + \cdots \right)$$
(2.B.48)

と展開できる。 $m_1, m_2, \dots, m_r \longrightarrow 0$ の極限で、 $\gamma_i \longrightarrow 1$ である。式 (2.B.47)より,式(2.B.22)の ψ_{ij} を計算し,式(2.B.46)に代入すれば R_{θ} が求められる. 2.B 揺らぎと光散乱

[二成分系の場合]

成分 0を主溶媒、成分 1 を高分子溶質とする 2 成分系では、式 (2.B.46)中の $\psi^{ij}/\mid \pmb{\psi}\mid$ は

$$\frac{\psi^{ij}}{|\boldsymbol{\psi}|} = \frac{M_1 kT}{m_1^2} \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial m_1}\right)_{T,p}^{-1}$$
(2.B.49)

となり、 R_{θ} は

$$R_{\theta} = \frac{2\pi^2 \tilde{n}^2 M_1 kT}{N_A \lambda^4 c_0} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_1}\right)_{T,p}^2 \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial m_1}\right)_{T,p}^{-1}$$
(2.B.50)

となる。Gibbs-Duhem の式 (1.94) より、

$$\left(\frac{\partial\mu_1}{\partial m_1}\right)_{T,p} = -\frac{N_0}{N_1} \left(\frac{\partial\mu_0}{\partial m_1}\right)_{T,p}$$
(2.B.51)

である。質量濃度 $c (\equiv c_1)$ は

$$c = \frac{M_1 N_1}{N_A V} = \frac{M_0 N_0}{N_A V} m_1$$
(2.B.52)

であり、また、

$$m_1 = \frac{M_1 N_1}{M_0 N_0}, \qquad V = N_0 V_0 + N_1 V_1$$
 (2.B.53)

であるので

$$\left(\frac{\partial}{\partial m_1}\right)_{T,p} = \frac{c_0 N_0 V_0}{V} \left(\frac{\partial}{\partial c}\right)_{T,p}$$
(2.B.54)

と書ける。

したがって、式 (2.B.50) を書き換えると、

$$R_{\theta} = -\frac{2\pi^2 \tilde{n}^2 R T V_0 c}{N_{\rm A} \lambda^4} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial c}\right)_{T,p}^2 / \left(\frac{\partial \mu_0}{\partial c}\right)_{T,p}$$
(2.B.55)

となる。更に書き換えるとこの式は

$$\frac{Kc}{R_{\theta}} = -\frac{1}{V_0 RT} \left(\frac{\partial \mu_0}{\partial c}\right)_{T,p}$$
(2.B.56)

$$K \equiv \frac{2\pi^2 \tilde{n}^2}{N_{\rm A} \lambda^4} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial c}\right)_{T,p}^2 \tag{2.B.57}$$

と表される。ここで、K は光学定数と呼ばれる量である。 μ_0 は浸透圧 π と次の関係にある。

$$\mu_0 - \mu_0^{\circ} = -V_0^{\circ} \pi = -V_0^{\circ} RT \left(\frac{c}{M} + A_2 c^2 + A_3 c^3 + \cdots \right)$$
(2.B.58)

ここで、 A_2 は第 2 ビリアル係数、 A_3 は第 3 ビリアル係数である。したがって,

$$\left(\frac{\partial\mu_0}{\partial c}\right)_{T,p} = -V_0^{\circ} \left(\frac{\partial\pi}{\partial c}\right)_{T,p} = -V_0^{\circ} RT \left(\frac{1}{M} + 2A_2c + 3A_3c^2 + \cdots\right)$$
(2.B.59)

この式を式 (2.B.56) に代入すると、

$$\frac{Kc}{R_{\theta}} = \frac{1}{M} + 2A_2c + 3A_3c^2 + \dots$$
(2.B.60)

が得られる。ただし、 $V_0 \simeq V_0^\circ$ とした。この式は高分子の特性解析に用いられる基本式である。

[Flory-Huggins 理論を基礎とする光散乱式]

溶媒成分 0 と高分子成分 1 の 2 成分系に対して、Flory-Huggins 理論を 基礎とした現象論によると、成分 0 の化学ポテンシャル mu_0 と成分 1 の 化学ポテンシャル μ_1 はそれぞれ式 (2.50) と (2.51) で与えられる。それら は成分 1 の体積分率 ϕ_1 の函数として表されている。式 (2.B.56) において、 質量濃度 $c \ge \phi_1$ に変換すると、

$$\frac{K_{\phi}V_{0}\phi_{1}}{R_{\theta}} = -\frac{1}{RT} \left(\frac{\partial\mu_{0}}{\partial\phi_{1}}\right)_{T,p}$$
(2.B.61)

となる。ここで、 K_{ϕ} は

$$K_{\phi} = \frac{2\pi^2 \tilde{n}^2}{N_{\rm A} \lambda^4} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial \phi_1}\right)^2 \tag{2.B.62}$$

である。この式 (2.B.61) に式 (2.50) を代入すると、

$$\chi + \frac{1}{2}\phi_1 \frac{\partial \chi}{\partial \phi_1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \phi_1} + \frac{1}{P_1 \phi_1} - \frac{K_{\phi} V_0}{R_{\theta}} \right)$$
(2.B.63)



ℤ 2.21 Maurice Loyal Huggins (1897/9/19–1981/12/17)



☑ 2.22 Paul John Flory (1910/6/19−1985/9/8)

が得られる。

したがってこれらの式から、光散乱測定によって $(\partial \mu_0 / \partial \phi_1)_{T,p}$ (あるい は $(\partial \mu_1 / \partial \phi_1)_{T,p}$) および χ が求められることが解る。さらに相分離が起こる系では、 $(\partial^2 \Delta G / \partial \phi_1^2)_{T,p} = \partial \mu_1 / \partial \phi_1)_{T,p}$ が 0 になる温度として尖点 (Spinodal) 温度 $T_{\rm sp}$ が決定できる。 $T = T_{\rm sp}$ では、 $1/R_{\theta} = 0$ で、散乱光強度が無限大になる。具体的には、 ϕ_1 一定で T を変化させて R_{θ} を測定し, $(K_{\phi}V_0\phi_1/R_{\theta}) \longrightarrow 0$ へ外挿することにより, $T_{\rm sp}$ が決定できる.

2.C 関連する人々 (溶液論・光散乱理論)



Joseph & Mayer

☑ 2.23 Joseph Edward Mayer (1904/2/5−1983/10/15)



John J. Kirkwood

☑ 2.24 John Gamble Kirkwood (1907/5/30−1959/8/9)



Z 2.25 Walter Hugo Stockmayer (1914/4/7-2004/5/9)



☑ 2.26 Bruno Hasbrouck Zimm (1920/10/31−2005/11/26)

参考文献

- 1. 倉田道夫、「高分子工業化学 III」、朝倉書店、1975.
- R. Koningsveld, W. H. Stockmayer, and E. Nies, "Polymer Phase Diagrams," Oxford University Press, Oxford, 2001.
- 3. 斉藤信彦、「高分子物理学」改訂版、裳華房、1967.
- M. L. Huggins, J. Chem. Phys., 9, 440 (1941); Ann. New York Acad. Sci., 43, 1 (1942).
- 5. P. J. Flory, J. Chem. Phys., 9, 660 (1941); ibid., 10, 51 (1942).
- 6. A. R. Shultz and P. J. Flory, J. Am. Chem. Soc., 74, 4760 (1952).
- H. Fujita and Y. Einaga, Makromol. Chem., Macromol. Symp., 12, 75 (1987).
- H. Tompa, "Polymer Solutions," Butterworths Scientific Publications, London, 1956.
- 9. R. Koningsveld, J. Polym. Sci., Part A-2, 6, 325 (1968).
- R. Koningsveld, L. A. Kleintjens, and A. R. Shlutz, J. Polym. Sci., Part A-2, 8, 1261 (1970).
- 11. R. Koningsveld and L. A. Kleintjens, *Macromolecules*, 4, 637 (1971).
- Y. Einaga, S. Ohashi, Z. Tong, and H. Fujita, *Macromolecules*, 17, 527 (1984).
- 13. N. Takano, Y. Einaga, and H. Fujita, Polym. J., 17, 1123 (1985).
- 14. Y. Einaga, Z. Tong, and H. Fujita, *Macromolecules*, 18, 2258 (1985).

3章 高分子多成分溶液の相平衡

高分子は一般に分子量分布を持っているので、多種類の高分子と溶媒から 成る系は勿論のこと、1種類の高分子と溶媒から成る系も一般に多成分系 である。このうち、後者は化学的には2成分溶液と見なされるので、特に 準2成分系(quasibinary system)と呼ばれる。この章では、多成分系に対 する一般論を述べた後、準2成分高分子溶液を取り扱い、ついで同種の単 分散高分子2成分と溶媒から成る3成分系について説明する。

3.1 一般論

溶媒成分 0 と q 個の高分子成分 (成分 1、2、···、q) から成る系を考え る。前章と同様、高分子成分 i の相対鎖長 P_i をそのモル体積 V_i から V_i/V_0 で定義する。ここで、 V_0 は溶媒成分のモル体積である。 V_i 、 V_0 はいずれ も純状態の値をとることにする。また、それらは温度 T に依らないもの とする。(実際には、ある特定の温度の値を用いる。)系の体積 V は

$$V = V_0(n_0 + \sum_{i=1}^{q} P_i n_i)$$
(3.1)

と表せる。ただし、 $n_0 \ge n_i$ は成分 $0 \ge k$ 成分iの物質量 (単位はモル)である。系の組成は、成分iの体積分率 ϕ_i を

$$\phi_i \equiv \frac{V_i n_i}{V} \tag{3.2}$$

で定義して、q 個の $\phi_i(i=1,2,\cdots,q)$ で表せる。 ϕ_i はまた、

$$\phi_i = \frac{n_i P_i}{n_0 + \sum_{j=1}^q P_j n_j}$$
(3.3)

と書ける。溶液中の全溶質高分子の体積分率 ϕ は

$$\phi = \sum_{i=1}^{q} \phi_i \tag{3.4}$$

である。また、溶質混合物中の高分子成分iの体積分率 ξ_i は

$$\xi_i = \frac{\phi_i}{\phi} \tag{3.5}$$

と書ける。 $\sum_{i=1}^{q} \xi_i = 1$ である。溶液組成は q 個の ϕ_i の代わりに、 ϕ と q-1 個の ξ_i を用いて表すことができる。以下、前者を $[\phi_i]$ で、後者を $[\xi_i]$ でまとめて表すことにする。

いま、系が平衡2相から成っているとき、第1章の式(1.104)より、

$$\mu_i(T, p, [\phi'_i]) = \mu_i(T, p, [\phi''_i]) \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, q)$$
(3.6)

が成り立つ。この式はまた、

$$\mu_i(T, p, \phi', [\xi'_j]) = \mu_i(T, p, \phi'', [\xi''_j]) \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, q)$$
(3.7)

と書くことができる。系の Gibbs 自由エネルギー G あるいは各成分の化 学ポテンシャル $\mu_i(i - 0, 1, 2, \dots, q)$ が与えられればこれらの式から共存 組成が計算できる。

尖点は

$$J_{\rm sp} \equiv \begin{vmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1q} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1} & G_{q2} & \cdots & G_{qq} \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \cdots & \mu_{1q} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \cdots & \mu_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_{q1} & \mu_{q2} & \cdots & \mu_{qq} \end{vmatrix}$$
$$= 0$$

(3.8)

から求められる。ここで、

$$G_{ij} \equiv \left(\frac{\partial^2 G}{\partial \phi_i \partial \phi_j}\right)_{T, p, \phi_k (k \neq i, k \neq j)}$$
(3.9)

$$\mu_{ij} \equiv \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial \phi_j}\right)_{T,p,\phi_k(k\neq j)} \tag{3.10}$$

である。式 (3.8)の導出には系あるいは各相の安定性の考察¹を必要とする。詳細は補遺 3.B を参照されたい。

臨界点は式 (3.8) と次式から成る連立方程式を用いて求めることができる。

$$\begin{array}{ccccc} \frac{\partial J_{\rm sp}}{\partial \phi_1} & \frac{\partial J_{\rm sp}}{\partial \phi_2} & \cdots & \frac{\partial J_{\rm sp}}{\partial \phi_q} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1} & G_{q2} & \cdots & G_{qq} \end{array} = 0$$
(3.11)

以下では、図の助けを借りて多成分系の相平衡の特徴を述べる。なお、 多成分系は図示できないので、3 成分系の図を用いる。²図 3.1 は成分 0、 1、2 から成る 3 成分系の gibbs 自由エネルギー *G* の例である。一般に、 相分離を起こしている系では *G* の曲面には凹凸があり、鞍部を有する。図 の例は成分 0 と 2 の 2 成分系で 2 相分離が起こり、成分 0 と 1 および 1 と 2 の各 2 成分系では均一な 1 相が安定な場合を示している。いま、この *G* の曲面に下から平面を接せしめたとき、両者は 2 点 (この図では B' と D') で接する。これら 2 点の組成をそれぞれ (ϕ'_1, ϕ'_2)、(ϕ''_1, ϕ''_2) とする。底面 の三角形で、各純成分を表す頂点からの縦軸と上記の共通接平面との交点 はこれら 2 つの組成における各成分の化学ポテンシャル $\mu_i(i = 0, 1, 2)$ を 与える。前章の 2 成分系の場合と同様に、

$$\mu_i(\phi_1', \phi_2') = \mu_i(\phi_1'', \phi_2'') \quad (i = 0, 1, 2)$$
(3.12)

が成り立つ。この式は相平衡条件 (3.6) を満たしており、2 つの接点で与 えられる組成をもつ 2 相が平衡していることが解る。

共通接平面の傾きを変えていくと、共存する2つの相の組成は移動していく。それらの相を表す点を結んだ線(図中のA'B'C'D'E')が共存曲線



図 3.1 Gibbs 自由エネルギー面



図 3.2 3 次元相図

である。また、2 成分系の場合と同様、G の曲面における変曲点を結ぶ線 (図中 K'C'L')が尖点曲線である。共存曲線と尖点曲線はある点 C'で接す る。この点が臨界点である。2 成分系と異なる点は、共存曲線、尖点曲線、 臨界点が1つの温度でも定義されることである。これらの線および点を三 角相図の底面に射影した結果がその特定の温度における相図を与える。

温度 T の異なるそのような相図を積み重ねると図 3.2 に示すような 3 次元の相図が得られる。この図では、共存曲面と尖点曲面が示してある。線 CC_5C' は臨界点を結ぶ線、すなわち、臨界線 (critical line) である。いま、 成分 $1 \ge 2$ をある比率で混ぜた混合物の組成を点 X で表すことにする。この混合物溶液の曇点曲線は、濃度軸 $0X \ge 2$ 温度 T 軸から定義される面で共



図 3.3 アタクチックポリスチレン + シクロヘキサン系の曇点曲線と共存曲線

存曲面を切った線 (図では AA_2C_5B) で与えられる。点 A_2 は曇点(沈澱点) で、それに対する共存組成を表す点は陰点 B_2 である。また、曇点 A に 対する陰点は K である。(陰点は実測できない。) 通常、曇点曲線は濃 度軸 0X を横軸に、温度軸 T を縦軸にとり、2 次元グラフで表される。濃 度が点 Q で表される混合物溶液が相分離し、点 Q' と Q" で表される 2 相 が平衡状態で存在しているとする。このとき、一般に連結線 Q'Q" は濃度 軸 0X とは一致しない。横軸 0X、縦軸 T をとった 2 次元表記では、Q' あ るいは Q" のような相は図に示すようにそれらの点から線 0X に下ろした 垂線の足が与える点で表される。したがって、それらの点を結んだ共存曲 線と曇点曲線は一般には一致しない。

曇点曲線と共存曲線の実験結果の一例を挙げる。図 3.3 は、上で例示した3 成分系ではなく、次に述べる準2 成分系に属する系である。溶質は分子量分布が最確分布である多分散のアタクチックポリスチレンで、溶媒はシクロヘキサンである。³ この図では濃度変数として体積分率ではなく、 重量分率 w₂ を用いているが、それは重要ではない。図中の実線は曇点曲線を示す。その曲線上に具体的に数値を示している種々の濃度を持つ母溶 液 (mother solution) から相分離させて得た共存2相の組成から求めた共存曲線が図中の破線である。共存曲線は相分離前の母溶液の濃度によって大きく変わることが分かる。また、それらは曇点曲線から大きく離れている。温度を上げていくと共存曲線の半分は最終的に曇点曲線に至る。残る半分は、図には示していないが、陰点曲線(shadow curve)に到達する。なお、母溶液が臨界点に相当しているとき、共存曲線は臨界点を通って濃度の全領域で繋がっている。それ以外では、共存曲線の低濃度側と高濃度側の部分は曇点曲線と陰点曲線の間の間隙の部分だけ離れている。臨界点の温度は曇点曲線が極大になる温度ではないことに注意を要する。なお、2 成分系の場合は、曇点曲線、陰点曲線、共存曲線は全て一致して1本の曲線となる。また、臨界点の温度*T*。はその曲線の極大値に一致する。

3.2 準2成分系の相平衡

Flory-Huggns 理論に基く現象論では、溶媒成分 0 と溶質高分子成分 $j(j = 1, 2, \dots, q)$ から成る多成分系の Gibbs 自由エネルギー G は

$$G = n_0 \mu_0^{\circ} + \sum_{j=1}^q n_j \mu_j^{\circ} + RT \left\{ (1-\phi) \ln(1-\phi) + \sum_{j=1}^q \frac{\phi \xi_j}{P_j} \ln(\phi \xi_j) + g(T, p, \phi, [\xi_j]; [P_j]) \phi(1-\phi) \right\}$$
(3.13)

と表される。ここで、 $[P_j]$ は P_1,P_2,\cdots,P_q を表す。この式より、溶媒の 化学ポテンシャル μ_0 は

$$\mu_0 = \mu_0^\circ + RT \left[\ln(1-\phi) + \left(1 - \frac{1}{P_n}\right) \phi + \chi(T, p, \phi; f(P)) \phi^2 \right] \quad (3.14)$$

となる。ここで、f(P) は $[\xi_j]$ と $[P_j]$ で与えられる鎖長分布であり、 P_n は 数平均相対鎖長で、

$$\frac{1}{P_n} \equiv \sum_{j=1}^q \frac{\xi_j}{P_j} \tag{3.15}$$

で定義される。

溶質成分 i の化学ポテンシャル μ_i は

$$\mu_{i} = \mu_{i}^{\circ} + RT \left[\ln(\xi_{i}\phi) - (P_{i} - 1) + P_{i} \left(1 - \frac{1}{P_{n}}\right)\phi + P_{i}(1 - \phi) \left\{ (1 - \phi) \left[g + \left(\frac{\partial g}{\partial \phi}\right)\phi\right] + \phi \left[m_{i} \left(\frac{\partial g}{\partial \xi_{i}}\right) - \sum_{j=1}^{q-1} \xi_{j} \left(\frac{\partial g}{\partial \xi_{j}}\right)\right] \right\} \right]$$
(3.16)

と書ける。ただし、 $i \neq q$ のとき、 $m_i = 1$ であり、i = qのとき、 $m_i = 0$ とする。 χ は前章と同様、

$$\chi = g - (1 - \phi) \left(\frac{\partial g}{\partial \phi}\right)_{T,p}$$
(3.17)

と書ける。

 χ が f(P)に依らない場合、式 (3.8) と (3.13) から、尖点は次式で与えられる。

$$\frac{1}{1-\phi} + \frac{1}{P_w\phi} - 2\chi - \left(\frac{\partial\chi}{\partial\phi}\right)_{T,p}\phi = 0$$
(3.18)

ここで、Pw は重量平均相対鎖長で、

$$P_w \equiv \sum_{j=1}^q \xi_j P_j \tag{3.19}$$

と定義される。また、臨界点は式(3.18)と次式から求められる。

$$\frac{1}{(1-\phi)^2} - \frac{P_z}{(P_w\phi)^2} - 3\left(\frac{\partial\chi}{\partial\phi}\right)_{T,p} - \left(\frac{\partial^2\chi}{\partial\phi^2}\right)_{T,p}\phi = 0$$
(3.20)

ただし、 P_z は

$$P_z \equiv \frac{\sum_{j=1}^q \xi_j^2 P_j}{P_w} \tag{3.21}$$

である。

gあるいは χ が ϕ およびf(P)に依らない場合、臨界点の ϕ_c と $\chi(T_c)$ は

$$\phi_c = \frac{1}{1 + \frac{P_w}{P_z^{1/2}}} \tag{3.22}$$



図 3.4 アタクチックポリスチレン + シクロヘキサン系の尖点温度

$$\chi(T_c) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{P_z^{1/2}}{P_w} \right) \left(1 + \frac{1}{P_z^{1/2}} \right)$$
(3.23)

と与えられる。

式 (3.18) によると、 χ が鎖長あるいはその分布 f(P) に依らない場合、 尖点温度 $T_{\rm sp}$ 対 ϕ の尖点曲線は重量平均鎖長 P_w (すなわち重量平均分子 量 M_w) のみに依存し、 M_w が同一であれば分子量分布に依らず 1 本の曲 線になる筈である。これを確かめたのが図 3.4 である。⁴ この図で、試料 PS166 は $M_w = 1.66 \times 10^5$ の単分散ポリスチレンであり、試料 PSM5 は $M_w = 1.65 \times 10^5$ で z- 平均分子量 M_z と M_w の比 M_z/M_w が 3.68 の 2 成分ポリスチレン混合物である。両試料の M_w の値が実質的に同じであ るにも拘わらず、両者のシクロヘキサン溶液の尖点曲線は大きく異なって いる。この結果は χ パラメータが溶質高分子の分子量あるいは分子量分 布に依ることを示すものと云える。

3.2.1 分離因子

分離因子 (separation factor) σ_i は無次元量で、次式で定義される。

$$\sigma_i \equiv \frac{\ln(\phi_i''/\phi_i')}{P_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, q)$$
(3.24)

ここで、 $\phi'_i \geq \phi''_i$ はそれぞれ稀薄相と濃厚相における高分子成分 iの体積



図 3.5 Breitenbach-Wolf プロット (アタクチックポリスチレン + シクロヘキサン 溶液)

分率である。式 (3.24) は

$$\ln\left(\frac{W_i'}{W_i''}\right) = \ln r - \sigma_i M_i \tag{3.25}$$

と書き換えられる。ここで、 $W'_i \geq W''_i$ は成分 i の稀薄相と濃厚相における 重量、 M_i は成分 i の分子量である。また、r は ϕ_i から W_i への換算および P_i から M_i への換算に伴って生じる因子で、ここでは重要ではない。この式 に基く $\ln(W'_i/W''_i)$ 対 M_i のプロットを Breitenbach-Wolf プロットと云 う。⁵g が鎖長分布 f(P) に依らないとき、平衡条件 $\mu'_i = \mu''_i$ ($i = 1, 2, \dots, q$) より、

$$\sigma_i = \Delta \left[\ln(1-\phi) + 2(\phi-1)g - \phi(1-\phi) \left(\frac{\partial g}{\partial \phi}\right) \right]$$
(3.26)

となる。ただし、 ΔX は濃厚相と稀薄相の X の差 X'' - X' である。この 場合、g は $[\xi_i]$ には依らないので σ_i は i に依らず同一の値をとる。した がって、Breitenbach-Wolf プロットは直線を与えねばならない、この点を 確かめたのが図 3.5 である。図の溶質高分子は極めて多分散のポリスチレ ンで、 $M_n = 8.2 \times 10^4$ 、 $M_w = 4.10 \times 10^5$ 、 $M_z = 1.22 \times 10^6$ である。また、溶媒にはシクロヘキサンを使用している。図中の濃度の数値は母溶液の濃度を示す。いずれの濃度の母溶液からの相分離でもプロットは大きく下に湾曲した曲線を与えている。この結果は上の議論が成り立たず、gは鎖長分布 f(P) に依存することを示している。

gがf(P)に依るとき、式(3.26)は次式で置き換えられる。

$$\sigma_{i} = \Delta \left[\ln(1-\phi) + (2\phi-1)g - \phi(1-\phi) \left(\frac{\partial g}{\partial \phi} \right) - (1-\phi) \left\{ m_{i} \left(\frac{\partial g}{\partial \xi_{i}} \right) - \sum_{j=1}^{q-1} \xi_{j} \left(\frac{\partial g}{\partial \xi_{j}} \right) \right\} \right]$$
(3.27)

ここで、 $i \neq q$ では $m_i = 1$ 、i = qでは $m_i = 0$ である。鎖長分布f(P)は 稀薄相と濃厚相で異なると考えられるので、この式中の $\partial g/\partial \xi_i 2$ つの相で iに伴って異なる変化をすることになる。これが σ_i が P_i に依る原因であ り、湾曲した Breienbach-Wolf プロットが生じる要因である。^{7,8}

3.3 同種高分子3成分系の相平衡

準 2 成分高分子溶液のうち最も単純な系は鎖長の異なる高分子成分 1 と 2 および溶媒から成る 3 成分系である。いま、高分子成分 i の鎖長を $P_i(=V_i/V_0)$ 、体積分率を ϕ_i (i = 1, 2) とする。 V_i と V_0 は成分 i、0 のモ ル体積である。また、溶質高分子の全体積分率 ϕ は $\phi_1 + \phi_2$ である。第 2 章の 2.3 節で述べた van't Hoff 溶液を基準とする現象論を採用すると、こ の系における溶媒成分 0 の化学ポテンシャル μ_0 は

$$\mu_0 = \mu_0^\circ - RT\left(\frac{\phi}{P_n} + \Gamma(T, p, \phi_1, \phi_2; P_1, P_2)\phi^2\right)$$
(3.28)

と表される。ここで、 P_n は数平均相対鎖長で

$$P_n^{-1} = \frac{\phi_1 P_1^{-1} + \phi_2 P_2^{-1}}{\phi}$$
(3.29)

である。

Gibbs-Duhem の式は次式の関係を与える。

$$\frac{1-\phi}{V_0} \left(\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi_1}\right) + \frac{\phi_1}{V_1} \left(\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi_1}\right) + \frac{\phi_2}{V_2} \left(\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi_1}\right) = 0$$
(3.30)

$$\frac{1-\phi}{V_0} \left(\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi_2}\right) + \frac{\phi_1}{V_1} \left(\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi_2}\right) + \frac{\phi_2}{V_2} \left(\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi_2}\right) = 0$$
(3.31)

ここで、濃度変数 $\phi_1 \ge \phi_2$ に代えて、 $\phi \ge a$ 分子成分 1 の高分子混合物中における体積分率 $\xi (\equiv \phi_1/\phi)$ を用いると、これらの式は

$$(1-\phi)\left(\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi}\right) + \frac{\phi\xi}{P_1}\left(\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi}\right) + \frac{\phi(1-\xi)}{P_2}\left(\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi}\right) = 0$$
(3.32)

$$(1-\phi)\left(\frac{\partial\mu_0}{\partial\xi}\right) + \frac{\phi\xi}{P_1}\left(\frac{\partial\mu_1}{\partial\xi}\right) + \frac{\phi(1-\xi)}{P_2}\left(\frac{\partial\mu_2}{\partial\xi}\right) = 0$$
(3.33)

と表される。補遺 3.A に示すように、これらの式の積分から、成分 1 と 2 の化学ポテンシャル μ_1 、 μ_2 に対して

$$\mu_{1} = \mu_{1}^{\infty} + RT \left[\ln(\phi\xi) - \phi + \left(1 - \frac{P_{1}}{P_{2}}\right) (1 - \xi)\phi + \Gamma P_{1}\phi(1 - \phi) \right. \\ \left. + P_{1} \int_{0}^{\phi} \left\{ \Gamma + (1 - \xi) \left(\frac{\partial\Gamma}{\partial\xi}\right) \right\} d\phi \right]$$
(3.34)

$$\mu_{2} = \mu_{2}^{\infty} + RT \left[\ln[\phi(1-\xi)] - \phi + \left(\frac{P_{2}}{P_{1}} - 1\right) \xi \phi + \Gamma P_{2} \phi(1-\phi) + P_{2} \int_{0}^{\phi} \left\{ \Gamma - \xi \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial \xi}\right) \right\} d\phi \right]$$

$$(3.35)$$

が導かれる。ここで、

$$\mu_i^{\infty} \equiv \lim_{\phi \to 0} (\mu_i - RT \ln \phi_i) \tag{3.36}$$

である。これらの $\mu_i (i\,=\,1,2)$ と μ_0 から、この系の Gibbs 自由エネル ギーGは

$$G = (n_0 + n_1 P_1 + n_2 P_2) \left[(1 - \phi) \mu_0^{\circ} + \frac{\phi_1}{P_1} \mu_1^{\infty} + \frac{\phi_2}{P_2} \mu_2^{\infty} + RT \left\{ -\frac{\phi}{P_n} + \frac{\phi_1}{P_1} \ln \phi_1 + \frac{\phi_2}{P_2} \ln \phi_2 + \phi \int_0^{\phi} \Gamma(T, p, \phi_1, \phi_2; P_1, P_2) d\phi \right\} \right]$$
(3.37)



図 3.6 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の共存曲線

と表される。

第2章 2.3 節に記したように、 Γ に関係づけられる J を

$$J \equiv \Gamma + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \gamma}{\partial \phi} \right) \phi \tag{3.38}$$

で定義する。ここで対象にしている3成分系のJは

$$J = J_{c0} + J_{c1}\phi^2 + (J_{dil}^{\circ} - J_{c0})\exp(-\phi/b)$$
(3.39)

と書ける。この式中の変数は、(一部前章と重複するが)、ポリスチレン+ シクロヘキサン溶液に対して以下のように書ける。

$$J_{\rm c0} = 0.036 P^{*-1/3} - 0.23 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$
(3.40)

$$J_{\rm c1} = 0.47 - 3.5 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) \tag{3.41}$$

$$J_{\rm dil}^{\circ} = -0.26 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) - 4.6 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2 \tag{3.42}$$

$$b = P^{**-1/2} \tag{3.43}$$

ただし、P* と P** は

$$P^* \equiv [\xi P_1^{-1/3} + (1 - \xi) P_2^{-1/3}]^{-3}$$
(3.44)

$$P^{**} \equiv [\xi P_1^{-1/2} + (1-\xi)P_2^{-1/2}]^{-2}$$
(3.45)

で定義する。式 (3.44) と (3.45) は 3 成分系の *J*_{c0}、 *b* が各高分子成分と溶媒 からなる 2 成分系に対する値の体積平均で与えられることを示している。

これらの経験式を用いて計算した3成分系に対する共存曲線と対応す る実測値との比較を図3.6に示す。⁹ここに示した系は2つの単分散ポリ スチレン試料、(1つは $M_w = 43600(f_4)$ 、他は $M_w = 491000(f_{40})$)、とシ クロヘキサンからなる3成分溶液である。図中の丸印は共存組成、破線は 連結線の実測値である。温度25.0°Cでは試料 f_{40} と溶媒シクロヘキサン 2成分溶液は相分離する。それに対して、 f_4 と溶媒の2成分系は相分離し ない。その結果、連結線の向きは ϕ_{40} 軸と平行に近くなっている。一方、 14.0°Cでは f_{40} と溶媒の2成分溶液、 f_4 と溶媒の2成分溶液のいずれも が相分離する。それを反映して、母溶液中の f_{40} と f_4 混合物の組成に依っ て連結線の向きは ϕ_{40} 軸方向と ϕ_4 軸方向の間を変化していく。太い実線 で示す曲線は共存曲線、細い実線で示す線分は連結線の計算結果である。 計算結果はほぼ正確に実験結果を再現していると云える。

図 3.7 は同じ 3 成分系の曇点曲線である。 ξ_4 は高分子混合物中の試料 f_4 の体積分率を示す。また、図中の白丸は曇点、黒丸は共存組成の実測値 を示しており、曲線はそれらを結ぶ曇点曲線である。この図で特徴的なこ とは、高分子量成分 f_{40} が体積分率で僅か 0.01 加えられただけで、曇点曲 線は極めて顕著な変化を示していることである。この図に対応する計算結 果を図 3.8 に示す。この図において、実線は曇点曲線を、破線は陰点曲線 を、鎖線は臨界線である。なお、臨界点は

$$|G| \equiv G_{11}G_{22} - (G_{12})^2 = 0 \tag{3.46}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial |G|}{\partial \phi_1} & \frac{\partial |G|}{\partial \phi_2} \\ G_{21} & G_{22} \end{vmatrix} = 0 \tag{3.47}$$


図 3.7 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の曇点曲線



図 3.8 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の曇点曲線 (計算値)



図 3.9 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の曇点曲線 2(実測値と計算値)

から計算できる。図 3.8 の計算結果は図 3.7 の特徴をよく再現していると 云える。

もう1つの例を図 3.9 に示す。この系は同じく単分散ポリスチレン試料 $f_4 \ge M_w = 103000(f_{10})$ の2つの高分子成分と溶媒成分のシクロヘキサン からなる3成分系である。図中のシンボルおよび各曲線の意味は図 2.7 と 図 2.8 と同様である。この場合も計算結果は実測の結果をほぼ定量的に再 現している。

同じ2つの3成分ポリスチレン+シクロヘキサン系に対する臨界温度 T_c と臨界濃度 ϕ_c の高分子混合物の組成との関係を図3.10と3.11に示す。丸印が実測の結果、曲線が計算結果である。臨界濃度 ϕ_c には若干のずれが見られるが、臨界温度 T_c では実験値と計算結果はよく一致している。



図 **3.10** ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の臨界温度 *T_c* と高分子混合物の組成 *ξ*₄ との関係



図 3.11 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の臨界濃度 ϕ_c と高分子混合物 の組成 ξ_4 との関係



図 3.12 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の 3 相分離線と臨界線 (温度-高分子濃度面)



図 3.13 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の 3 相分離線と臨界線 (温度-混合物組成面)

3.3.1 3相平衡

Gibbs の相律によれば、3 成分溶液では温度 T と濃度 ϕ の条件により 3 つの相が平衡状態で存在し得る。Flory-Huggins 理論によると、同種高分 子 2 成分と溶媒の 3 成分系でこれが実現するためには 2 つの高分子成分の 鎖長の比が 9.9 以上でなければならないことが知られている。¹⁰ しかし、 現実には高分子溶液で 3 相平衡が観測されることは殆どない。これはその ような平衡状態が成り立つ温度と濃度の領域が極めて限定されていること によっている。

上述のポリスチレン+シクロヘキサン 3 成分系に対する J あるいは Γ を 用いて計算した 3 相平衡の状態を図 3.12 と 3.13 に示している。¹¹ 対象とし た 2 つのポリスチレンの分子量は M = 43600(f4) と M = 1260000(f128)である。図 3.12 は温度 T と全高分子濃度 ϕ の図で、図 3.13 は T と高分子 混合物の組成の図である。ただし、高分子混合物の組成は成分 f128 の体積 分率 ξ_2 で表している。図中の太い曲線が 3 相線、細い曲線が臨界点を結 んだ線である。3 相分離は狭い温度範囲、 T_u (=14.221 °C) と T_l (=13.765 °C) の間で起こることが分かる。例えば、温度 T' では S_d 、 S_m 、 S_c で 示す稀薄相、中間相、濃厚相に分かれる。また、3 相分離は濃度範囲が $\phi = 0.058 - 0.233$ で、組成範囲が $\xi_2 = 0 - 0.17$ の領域で起こる。稀薄相、 中間相、濃厚相の表れる範囲はそれぞれ図中の KL、LM、MN の部分で ある。いま、系の温度を下げていくと温度 T_u で溶液は L と N の 2 相に 分かれる。さらに温度を下げると、稀薄相 L から中間相が分離し、L と N の濃度 ϕ ならびに ξ_2 は低くなっていく。この状態は、濃厚相 N が中間相 M と一体となる温度 T_l まで続く。

この3相平衡の状況を三角相図で表したのが図 3.14 である。図中、曲線は共存曲線、直線は連結線、丸印は臨界点、三角印は平衡する3相を示す。(なお、破線は不安定な共存曲線である。) この図から3 相分離が発生し、消失していく様子が分かる。対応する実験結果を示したのが図 3.15 である。この図で、丸印は2相分離した各相の共存組成を、三角印は3 相分離した各相の組成を表している。直線は連結線である。3 相分離は極めて狭い組成範囲でしか起こらないことが分かる、また、図 3.14 で予想される $T = 13.8^{\circ}$ C で現実に3 相分離が生じている。



図 3.14 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の 3 相分離 (温度による変化)



図 3.15 ポリスチレン + シクロヘキサン 3 成分溶液の 3 相分離 (実験結果)



図 3.16 ポリスチレン+シクロヘキサン3成分溶液の3相分離付近における相図

図 3.16 は 3 相分離が起こる付近での曇点と 3 相線について実験値と計 算値を比較したものである。なお、 $\xi_2 = 0.05$ である。図中、黒丸は実測 の曇点、黒三角は実測の 3 相の濃度、白丸は臨界点である。また、計算に よる曇点曲線を太い実線で、陰点曲線を太い鎖線で、3 相線を細い実線で 表している。破線は表示の体積分率を持つ母溶液から相分離した各相の共 存曲線である。曇点曲線および 3 相線に対する計算結果はそれぞれの実測 結果とよく一致している。

3.4 同種高分子多成分系の現象論

上で述べた van't Hoff 溶液を基準とする現象論を同種の高分子成分 1、 2、...、*q* と溶媒成分 0 から成る多成分系に拡張する。Gibbs 自由エネル ギー*G* は

$$G = (n_0 + \sum_{i=1}^{q} n_i P_i) \left[(1 - \phi) \mu_0^{\circ} + \sum_{i=1}^{q} \frac{\phi_i}{P_i} \mu_i^{\infty} + RT \left\{ -\frac{\phi}{P_n} + \sum_{i=1}^{q} \frac{\phi_i}{P_i} \ln \phi_i + \phi \int_0^{\phi} \Gamma(T, p, \phi_1, \cdots, \phi_q; P_1, \cdots, P_q) \mathrm{d}\phi \right\} \right]$$
(3.48)

と表される。ここで、 P_n は

$$P_n \equiv [\sum_{i=1}^{q} \xi_i P_i]^{-1} \tag{3.49}$$

である。見かけの第2ビリアル係数 Γ は

$$\Gamma = \Gamma_{c0} + \frac{1}{2}\Gamma_{c1}\phi^{2} + 2(\Gamma_{d0} - \Gamma_{c0})\left[1 - e^{-\phi/\phi^{*}}\left(1 + \frac{\phi}{\phi^{*}}\right)\right]\left(\frac{\phi^{*}}{\phi}\right)^{2}$$
(3.50)

と書くことができる。この式中の鎖長に依る因子 Γ_{c0} と ϕ^* はそれぞれに 対する高分子成分 i の値 Γ_{c0i} 、 ϕ_i^* の平均をとって、

$$\Gamma_{\rm c0} = \sum_{i=1}^{q} \xi_i \Gamma_{\rm c0i} \tag{3.51}$$

$$\phi^* = \sum_{i=1}^{q} \xi_i \phi_i^* \tag{3.52}$$

と表される。

ポリスチレンのシクロヘキサン溶液の場合、

$$\Gamma_{\rm d0} = -0.26 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) - 4.6 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2 \tag{3.53}$$

$$\Gamma_{c0i} = \frac{0.03}{P_i^{1/3}} - 0.23 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$
(3.54)

$$\Gamma_{c1} = 0.47 - 3.5 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$
 (3.55)

$$\phi_i^* = \frac{1}{P_i^{1/2}} \tag{3.56}$$

である。

なお、溶媒成分0の化学ポテンシャル μ_0 は

$$\frac{\mu_0 - \mu_0^\circ}{RT} = -\frac{\phi}{P_n} - \Gamma \phi^2 \tag{3.57}$$

であり、高分子成分iの化学ポテンシャル μ_i は

$$\frac{\mu_i - \mu_i^{\infty}}{RT} = \ln(\xi_i \phi) - \frac{P_i}{P_n} \phi + P_i \phi (1 - \phi) \Gamma + P_i \int_0^{\phi} \Gamma d\phi + P_i \int_0^{\phi} \left[(1 - \xi_i) \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi_i} - \sum_{j \neq i}^{q-1} \xi_j \frac{\partial \Gamma}{\xi_j} \right] d\phi (i = 1, 2, \cdots, q - 1)$$
(3.58)

$$\frac{\mu_q - \mu_q^{\infty}}{RT} = \ln(1 - \sum_{i=1}^{q-1} \xi_i)\phi - \frac{P_q}{P_n}\phi + P_q\phi(1-\phi)\Gamma + P_q \int_0^{\phi} \Gamma d\phi - P_q \int_0^{\phi} \sum_{j=1}^{q-1} \xi_j \frac{\partial\Gamma}{\partial\xi_j} d\phi$$
(3.59)

と書ける。これらの式を用いると分離因子 σ_i は

$$\sigma_{i} = -\Delta \left[\Gamma \phi + \int_{0}^{\phi} \Gamma d\phi + \int_{0}^{\phi} \left\{ (1 - \xi_{i}) \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi_{i}} - \sum_{j \neq i}^{q-1} \xi_{j} \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi_{j}} \right\} d\phi \right]$$

$$(i = 1, 2, \cdots, q - 1)$$
(3.60)

$$\sigma_q = -\Delta \left[\Gamma \phi + \int_0^{\phi} \Gamma d\phi - \int_0^{\phi} \sum_{j=1}^{q-1} \xi_j \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi_j} d\phi \right]$$
(3.61)

と表される。ただし、 $\Delta[X]$ は濃厚相と稀薄相の X の差 X'' - X'を表す。 これらの式による分離因子 σ_i の計算値は実測の結果をよく表すことがで きる。⁸ ただし、分子量が 10000 以下の高分子成分が含まれている場合、 上の Γ の式には修正が必要である。 3.A 3 成分系の化学ポテンシャルと混合 Gibbs 自由エネルギー 113

3.A 3 成分系の化学ポテンシャルと混合 Gibbs 自由エネ ルギー

溶媒成分 0 の化学ポテンシャル μ_0 を見かけの第 2 ビリアル係数 Γ を用いて

$$\mu_0 = \mu_0^{\circ} - RT \left(\frac{\phi_1}{P_1} + \frac{\phi_2}{P_2} + \Gamma \phi^2 \right)$$
(3.A.1)

と書くことにする。 ϕ_i 、 P_i は高分子成分 iの体積分率と相対鎖長である。 また、 ϕ は全高分子の体積分率である。Gibbs-Duhem の式から

$$\frac{1-\phi}{V_0}\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi_1} + \frac{\phi_1}{V_1}\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi_1} + \frac{\phi_2}{V_2}\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi_1} = 0$$
(3.A.2)

$$\frac{1-\phi}{V_0}\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi_2} + \frac{\phi_1}{V_1}\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi_2} + \frac{\phi_2}{V_2}\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi_2} = 0$$
(3.A.3)

が成り立つ。ここで、 V_i は成分 i のモル体積である。いま、高分子混合物中の高分子成分 1 の体積分率を $\xi (\equiv \phi_1/\phi)$ とすると

$$\frac{\partial}{\partial \phi_1} = \frac{\partial}{\partial \phi} + \frac{1-\xi}{\phi} \frac{\partial}{\partial \xi}, \qquad \frac{\partial}{\partial \phi_2} = \frac{\partial}{\partial \phi} - \frac{\xi}{\phi} \frac{\partial}{\partial \xi}$$
(3.A.4)

の関係がある。この関係を利用すると、式 (3.A.2) は

$$\frac{1-\phi}{V_0}\phi\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi} + \frac{\xi}{V_1}\phi^2\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi} + \frac{1-\xi}{V_2}\phi^2\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi} \\
= -\frac{1-\phi}{V_0}(1-\xi)\frac{\partial\mu_o}{\partial\xi} - \frac{\phi}{V_1}\xi(1-\xi)\frac{\partial\mu_1}{\partial\xi} \\
-\frac{\phi}{V_2}(1-\xi)^2\frac{\partial\mu_2}{\partial\xi}$$
(3.A.5)

となり、式 (3.A.3) は

$$\frac{1-\phi}{V_0}\phi\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi} + \frac{\xi}{V_1}\phi^2\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi} + \frac{1-\xi}{V_2}\phi^2\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi} = \frac{1-\phi}{V_0}\xi\frac{\partial\mu_o}{\partial\xi} + \frac{\phi}{V_1}\xi^2\frac{\partial\mu_1}{\partial\xi} + \frac{\phi}{V_2}\xi(1-\xi)\frac{\partial\mu_2}{\partial\xi}$$
(3.A.6)

となる。これら2つの式の差をとると

$$\frac{1-\phi}{V_0}\frac{\partial\mu_0}{\partial\xi} + \frac{\phi}{V_1}\xi\frac{\partial\mu_1}{\partial\xi} + \frac{\phi}{V_1}(1-\xi)\frac{\partial\mu_2}{\partial\xi} = 0$$
(3.A.7)

となる。この式を式(3.A.5)あるいは(3.A.6)に代入すると、 $\xi \neq 0, \ \xi \neq 1$ のとき、

$$\frac{1-\phi}{V_0}\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi} + \frac{\phi}{V_1}\xi\frac{\partial\mu_1}{\partial\phi} + \frac{\phi}{V_2}(1-\xi)\frac{\partial\mu_2}{\partial\phi} = 0$$
(3.A.8)

が得られる。

式)(3.A.1) の ϕ による微分

$$\frac{1}{RT}\frac{\partial\mu_0}{\partial\phi} = -\frac{1}{P_n} - \left(2\Gamma\phi + \phi^2\frac{\partial\Gamma}{\partial\phi}\right)$$
(3.A.9)

を式 (3.A.8) に代入すると

$$\frac{\xi}{V_1} \frac{\partial \mu_1}{\partial \phi} + \frac{1-\xi}{V_2} \frac{\partial \mu_2}{\partial \phi} = \frac{RT}{V_0} \left[\frac{1}{P_n} \left(\frac{1}{\phi} - 1 \right) + \left(\frac{1}{\phi} - 1 \right) \frac{\partial \Gamma \phi^2}{\partial \phi} \right] \quad (3.A.10)$$

となる。この式を ϕ について積分すると

$$\frac{\xi}{P_1}\mu_1 + \frac{1-\xi}{P_2}\mu_2 = RT \left[C + \frac{1}{P_n} (\ln \phi - \phi) + \phi(1-\phi)\Gamma + \int_0^{\phi} \Gamma d\phi \right]$$
(3.A.11)

が得られる。ただし、Cは積分定数であり、 $P_i = V_i/V_0$ の関係を用いている。この式を ξ について微分すると

$$\frac{1}{RTP_2} \frac{\partial \mu_2}{\partial \xi} = -\frac{1}{RTP_1} \left[\frac{1}{(1-\xi)^2} \mu_1 + \frac{\xi}{1-\xi} \frac{\partial \mu_1}{\partial \xi} \right] + \frac{1}{P_1(1-\xi)^2} (\ln \phi - \phi) + \phi (1-\phi) \left[\frac{1}{(1-\xi)^2} \Gamma + \frac{1}{1-\xi} \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi} \right] + \frac{1}{(1-\xi)^2} \int_0^{\phi} \Gamma d\phi + \frac{1}{1-\xi} \int_0^{\phi} \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi} d\phi + \frac{1}{(1-\xi)^2} C + \frac{1}{1-\xi} \frac{\partial C}{\partial \xi}$$
(3.A.12)

となる。この式と式 (3.A.1) の ξ による微分

$$\frac{1}{RT}\frac{\partial\mu_0}{\partial\xi} = -\left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2}\right)\phi - \phi^2\frac{\partial\Gamma}{\partial\xi}$$
(3.A.13)

を式 (3.A.7) に代入すると

$$\frac{1}{RTP_1}\mu_1 = \frac{1}{P_1}(\ln\phi - \phi) - \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2}\right)(1-\xi)(1-\phi) + \phi(1-\phi)\Gamma$$
$$+ \int_0^\phi \left[\Gamma + (1-\xi)\frac{\partial\Gamma}{\partial\xi}\right] d\phi + \left[C + (1-\xi)\frac{\partial C}{\partial\xi}\right] \quad (3.A.14)$$

3.A 3成分系の化学ポテンシャルと混合 Gibbs 自由エネルギー 115

となる。この式を式 (3.A.11) に代入して、

$$\frac{1}{RTP_2}\mu_2 = \frac{1}{P_2}(\ln\phi - \phi) + \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2}\right)\xi(1-\phi) + \phi(1-\phi)\Gamma + \int_0^\phi \left[\Gamma - \xi\frac{\partial\Gamma}{\partial\xi}\right]d\phi + \left[C - \xi\frac{\partial C}{\partial\xi}\right]$$
(3.A.15)

を得ることができる。

 $\phi = 0$ の近傍では、高分子成分1と2の化学ポテンシャルを

$$\frac{\mu_1}{RT} = \frac{\mu_1^{\infty}}{RT} + \ln(y_1^{\infty}\phi_1)$$
(3.A.16)

$$\frac{\mu_2}{RT} = \frac{\mu_2^{\infty}}{RT} + \ln(y_2^{\infty}\phi_2)$$
(3.A.17)

と表す。ここで、 $y_1^{\infty} \ge y_2^{\infty}$ は $\phi \to 0$ で、 $y_1^{\infty} = 1$ 、 $y_2^{\infty} = 1$ となるように定義する。式 (3.A.14) \ge (3.A.15) のそれぞれについて、 $\phi \to 0$ の極限を とると

$$\frac{\mu_1^{\infty}}{RT} + \ln \phi_1 = \lim_{\phi \to 0} (\ln \phi) - \left(1 - \frac{P_1}{P_2}\right) (1 - \xi) + P_1 \left[C + (1 - \xi)\frac{\partial C}{\partial \xi}\right]$$
(3.A.18)

$$\frac{\mu_2^{\infty}}{RT} + \ln \phi_2 = \lim_{\phi \to 0} (\ln \phi) - \left(1 - \frac{P_2}{P_1}\right) \xi + P_2 \left[C - \xi \frac{\partial C}{\partial \xi}\right] \qquad (3.A.19)$$

である。これら2つの式から積分定数 C を求めると

$$C = \frac{\mu_1^{\infty}}{RTP_1}\xi + \frac{\mu_2^{\infty}}{RTP_2}(1-\xi) + \frac{\xi}{P_1}\ln\xi + \frac{1-\xi}{P_2}\ln(1-\xi) \qquad (3.A.20)$$

となる。この式を式 (3.A.14) と (3.A.15) に代入すると、

$$\frac{\mu_1 - \mu_1^{\infty}}{RTP_1} = \frac{1}{P_1} (\ln \phi_1 - \phi) + \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2}\right) (1 - \xi)\phi + \phi(1 - \phi)\Gamma + \int_0^{\phi} \left[\Gamma + (1 - \xi)\frac{\partial\Gamma}{\partial\xi}\right] d\phi$$
(3.A.21)

$$\frac{\mu_2 - \mu_2^{\infty}}{RTP_2} = \frac{1}{P_2} (\ln \phi_2 - \phi) + \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2}\right) \xi \phi + \phi (1 - \phi) \Gamma + \int_0^{\phi} \left[\Gamma - \xi \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi}\right] d\phi$$
(3.A.22)

が得られる。モル Gibbs 自由エネルギー差 ΔG は

$$\begin{split} \frac{\Delta G}{RT} &\equiv \frac{G - G^{\infty}}{RT} \\ &\equiv (1 - \phi) \frac{\mu_0 - \mu_0^{\circ}}{RT} + \frac{\phi_1}{P_1} \frac{\mu_1 - \mu_1^{\infty}}{RT} + \frac{\phi_2}{P_2} \frac{\mu_2 - \mu_2^{\infty}}{RT} \\ &= \frac{\phi_1}{P_1} \ln \phi_1 + \frac{\phi_2}{P_2} \ln \phi_2 - \frac{\phi}{P_n} + \phi \int_0^{\phi} \Gamma \mathrm{d}\phi \end{split} (3.A.23)$$

と与えられる。

混合のモル Gibbs 自由エネルギー ΔG_m を得るには無定形の純状態に おける μ_1° と μ_2° が必要である。式 (3.A.21) は $\phi = 1$ 、 $\xi = 1$ のとき、

$$\frac{\mu_1^{\circ}}{RTP_1} = \frac{\mu_1^{\infty}}{RTP_1} - \frac{1}{P_1} + \int_0^1 \Gamma(\xi = 1) \mathrm{d}\phi$$
(3.A.24)

である。同様に、式 (3.A.22) は $\phi = 1$ 、 $\xi = 0$ のとき、

$$\frac{\mu_2^{\circ}}{RTP_2} = \frac{\mu_2^{\infty}}{RTP_2} - \frac{1}{P_2} + \int_0^1 \Gamma(\xi = 0) \mathrm{d}\phi \qquad (3.A.25)$$

である。式(3.A.21)と(3.A.22)および式(3.A.24)と(3.A.25)より、 μ_1^∞ と μ_2^∞ を消去すると

$$\frac{\mu_1 - \mu_1^{\circ}}{RTP_1} = \frac{1}{P_1} (\ln \phi_1 - \phi) + \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2}\right) (1 - \xi)\phi + \phi(1 - \phi)\Gamma + \int_0^{\phi} \left[\Gamma + (1 - \xi)\frac{\partial\Gamma}{\partial\xi}\right] + \frac{1}{P_1} - \int_0^1 \Gamma(\xi = 1) d\phi \quad (3.A.26)$$

$$\frac{\mu_2 - \mu_2^\circ}{RTP_2} = \frac{1}{P_2} (\ln \phi_2 - \phi) - \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2}\right) \xi \phi + \phi (1 - \phi) \Gamma + \int_0^{\phi} \left[\Gamma - \xi \frac{\partial \Gamma}{\partial \xi}\right] + \frac{1}{P_2} - \int_0^1 \Gamma(\xi = 0) \mathrm{d}\phi \qquad (3.A.27)$$

と表される。これらの式と式(3.A.1)を用いると、混合のモル ${\rm Gibbs}$ 自由 エネルギー ΔG_m は

$$\frac{\Delta G_m}{RT} \equiv \frac{G - G^{\circ}}{RT}$$

3.A 3成分系の化学ポテンシャルと混合 Gibbs 自由エネルギー 117

$$= (1-\phi)\frac{\mu_0 - \mu_0^2}{RT} + \frac{\phi_1}{P_1}\frac{\mu_1 - \mu_1^2}{RT} + \frac{\phi_2}{P_2}\frac{\mu_2 - \mu_2^2}{RT}$$

$$= \frac{\phi_1}{P_1}\ln\phi_1 + \frac{\phi_2}{P_2}\ln\phi_2 + \phi\int_0^{\phi}\Gamma d\phi$$

$$-\phi_1\int_0^1\Gamma(\xi = 1)d\phi - \phi_2\int_0^1\Gamma(\xi = 0))d\phi \qquad (3.A.28)$$

と表すことができる。ここでの G° は各成分が純状態にあるときのモル Gibbs 自由エネルギーである。 G^{∞} と G° の間には

$$\frac{G^{\infty}}{RT} = \frac{G^{\circ}}{RT} + \frac{\phi}{P_n} - \phi_1 \int_0^1 \Gamma(\xi = 1) \mathrm{d}\phi - \phi_2 \int_0^1 \Gamma(\xi = 0) \mathrm{d}\phi \quad (3.A.29)$$
の関係がある。

3.B 系の安定性

温度 T と圧力 p を一定とし、系は q+1 成分系から成るとする。各成分の 物質量を n_0 、 n_1 、…、 n_q (単位は mol) で表す。全系の物質量 n は $\sum_{i=0}^{q} n_i$ で、n は一定とする。いま、系を微少領域 α と残りの領域 β に分ける。こ の系の特性函数 (母函数) は Gibbs 自由エネルギー G である。領域 α の G を G^{α} 、領域 β の G を G^{β} と表す。Gibbs 自由エネルギーは示量性状 態量であるので、系および各領域の大きさを規定するために、領域 α と β が含む主成分 0(溶媒成分) の物質量をそれぞれ n_0^{α} 、 n_0^{β} とする。当然、 $n_0^{\alpha} + n_0^{\beta} = n_0$ であり、これらはいずれも一定値をとる。また、

$$n^{\alpha} (\equiv \sum_{i=0}^{q} n_i^{\alpha}) \ll n^{\beta} (\equiv \sum_{i=0}^{q} n_i^{\beta})$$
 (3.B.1)

である。まず、q = 1 o 2 成分系を考える。

[2 成分系]

系は均一な1相から成るものとすると、この系が安定な平衡状態にある ためには第2章の始めに述べたように溶液組成に対する gibbs 自由エネル ギー G の曲線は下に凸でなければならない。いま、仮想微少変位として 領域 β から領域 α へ溶質成分1を微少量 δn_1^{α} だけ移すことを想定する。 これは上述の束縛条件の下で考えうる唯一の仮想微少変位である。系が安 定 (準安定を含む) な平衡状態であるためにはこの仮想微少変位に対して

$$(\delta^2 G)_{T,p,n_0,n_1} > 0 \tag{3.B.2}$$

が成り立たねばならない。 全系の $(\delta^2 G)_{T,p,n_0,n_1}$ は領域 α の $\delta^2 G^{\alpha})_{T,p,n_0^{\alpha}}$ と領域 β の $(\delta^2 G^{\beta})_{T,p,n_0^{\beta}}$ の和であり、式 (3.B.2) は

$$(\delta^2 G)_{T,p,n_0,n_1} = (\delta^2 G^{\alpha})_{T,p,n_0^{\alpha}} + (\delta^2 G^{\beta})_{T,p,n_0^{\beta}}$$
$$= \frac{1}{2} (\mu_{11}^{\alpha} + \mu_{11}^{\beta}) (\delta n_1^{\alpha})^2 > 0$$
(3.B.3)

と書ける。ここで、

$$\mu_{11}^{\alpha} \equiv \left(\frac{\partial^2 G^{\alpha}}{\partial n_1^{\alpha 2}}\right)_{T,p,n_0^{\alpha}} = \left(\frac{\partial \mu_1^{\alpha}}{\partial n_1^{\alpha}}\right)_{T,p,n_0^{\alpha}}$$

$$= \left[\frac{\partial}{\partial n_1^{\alpha}} \left(\frac{n_1^{\alpha}}{n_0^{\alpha} + n_1^{\alpha}}\right)\right] \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial x_1}\right)_{T,p}$$
$$= \frac{1 - x_1}{n^{\alpha}} \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial x_1}\right)_{T,p}$$
(3.B.4)

である。同様に、

$$\mu_{11}^{\beta} = \frac{1 - x_1}{n^{\beta}} \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial x_1} \right)_{T,p}$$
(3.B.5)

となる。これらの式中の x_1 は考えている系における成分 1 のモル分率で ある。なお、系は平衡状態にあるので $x_1 \ge \mu_1$ は領域 $\alpha \ge \beta$ で共通であ る。式 (3.B.1)、(3.B.4) および (3.B.5) より、

$$\mu_{11}^{\alpha} \gg \mu_{11}^{\beta}$$
 (3.B.6)

である。したがって、式 (3.B.3) は

$$(\delta^{2}G)_{T,p,n_{0},n_{1}} = \frac{1}{2}\mu_{11}^{\alpha}(\delta n_{1}^{\alpha})^{2}$$
$$= \frac{1-x_{1}}{2n^{\alpha}} \left(\frac{\partial\mu_{1}}{\partial x_{1}}\right)_{T,p} (\delta n_{1}^{\alpha})^{2} > 0 \qquad (3.B.7)$$

となる。この式より、この2成分1相系が安定である条件は

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial x_1}\right)_{T,p} > 0 \tag{3.B.8}$$

と表される。

一方、この系が安定に存在しえない場合、すなわち不安定である場合、

$$\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial x_1}\right)_{T,p} < 0 \tag{3.B.9}$$

である。系が平衡状態にある 2 相から成っているとき、式 (3.B.8) と式 (3.B.9) のそれぞれが成り立つ組成 x_1 の領域が μ_1 対 x_1 のグラフ上に隣 接して存在する。それらの境界となる点が尖点で、そこでは

$$\left(\frac{\partial\mu_1}{\partial x_1}\right)_{T,p} = 0 \tag{3.B.10}$$

である。一般に 2 成分 2 相系では式 (3.B.10) が成り立つ尖点の組成 x_1 は 2 つ存在する。いま、系の温度 T を変化させるとそれらの 2 つの x_1 の値 が同一になり、2 つの点が合体する場合がある。その点が臨界点、あるい は臨界共溶点と呼ばれる点であり、その温度が臨界温度 T_c である。臨界 点は x_1 に対する μ_1 の曲線の変曲点になるので、式 (3.B.10) と共に次式 が成り立つ。

$$\left(\frac{\partial^2 \mu_1}{\partial x_1^2}\right)_{T,p} = 0 \tag{3.B.11}$$

逆に、尖点は式 (3.B.10) から、臨界点は式 (3.B.10) と (3.B.11) から計算 することができる。これらの式を gibbs 自由エネルギー *G* で表すと

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial x_1^2}\right)_{T,p} = 0 \tag{3.B.12}$$

$$\left(\frac{\partial^3 G}{\partial x_1^3}\right)_{T,p} = 0 \tag{3.B.13}$$

となる。

[多成分系]

r+1成分系の安定平衡の条件式は

$$(\delta^2 G)_{T,p,n_0,\dots,n_q} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^q \mu_{ij}^\alpha \delta n_i^\alpha \delta n_j^\alpha > 0$$
(3.B.14)

と表される。ここで、 μ_{ij}^{α} は

$$\mu_{ij}^{\alpha} \equiv \left(\frac{\partial^2 G^{\alpha}}{\partial n_i^{\alpha} \partial n_j^{\alpha}}\right)_{T,p,n_0^{\alpha}} = \left(\frac{\partial \mu_i^{\alpha}}{n_j^{\alpha}}\right)_{T,p,n_0^{\alpha}}$$
(3.B.15)

である。如何なる微少変位 δn_i^{α} に対しても式 (3.B.14) が成立する必要十 分条件は

$$\mu_{ii}^{\alpha} > 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, q)$$
 (3.B.16)

および

$$\begin{vmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \cdots & \mu_{1q} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \cdots & \mu_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_{q1} & \mu_{q2} & \cdots & \mu_{qq} \end{vmatrix} > 0$$
(3.B.17)

である。前節の2成分系に対する議論と同様にして、尖点曲線を定める 式は

$$\begin{array}{ccccc} \mu_{11} & \mu_{12} & \cdots & \mu_{1q} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \cdots & \mu_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_{q1} & \mu_{q2} & \cdots & \mu_{qq} \end{array} = 0$$
 (3.B.18)

で与えられる。 μ_i の代わりにGを用いるとこの式は

$$|G| \equiv \begin{vmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots & G_{1q} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1} & G_{q2} & \cdots & G_{qq} \end{vmatrix} = 0$$
(3.B.19)

と書ける。ここで、

$$G_{ij} \equiv \left(\frac{\partial^2 G}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{T,p,x_k} \tag{3.B.20}$$

である。また、臨界点を決める条件式はこの式と

$$\begin{array}{c|cccc} \frac{\partial |G|}{\partial x_1} & \frac{\partial |G|}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial |G|}{\partial x_q} \\ G_{21} & G_{22} & \cdots & G_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1} & G_{q2} & \cdots & G_{qq} \end{array} = 0$$
(3.B.21)

で与えられる。ただし、

$$\frac{\partial |G|}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial |G|}{\partial x_i}\right)_{T,p,x_j(j\neq i)} \tag{3.B.22}$$

である。ここまで組成変数としてモル分率 x_i を用いてきたが、体積分率 ϕ_i を組成変数に用いる場合、単位体積あたりの Gibbs 自由エネルギー $G^{(\phi)}$ を

$$G^{(\phi)} \equiv \frac{G}{\sum_{i=0}^{q} n_i V_i^{\circ}} \tag{3.B.23}$$

で定義する。 V_i° は成分 i の純状態での部分モル体積である。 $G^{(\phi)}$ について

$$G_i^{(\phi)} \equiv \left(\frac{\partial G^{(\phi)}}{\partial \phi_i}\right)_{T,p,\phi_j}, \quad G_{ij}^{(\phi)} \equiv \left(\frac{\partial^2 G^{(\phi)}}{\partial \phi_i \partial \phi_j}\right)_{T,p,\phi_k}$$
(3.B.24)

とすると、式(3.B.19)
と(3.B.21)で G_{ij} を $G_{ij}^{(\phi)}$ で置き換えた式が成立する。



図 3.17 相分離現象の模式図

3.C 曇点、尖点、臨界点の決定

ここでは、曇点、尖点、および臨界点の実験的決定について記述する。系 は上限臨界共溶点 (UCST)を示す型の相分離をするものとする。

[曇点の決定]

UCST型の相分離が起こる場合、均一な1相から成る透明な溶液の温度 Tを下げていくと、図3.17に模式的に示すように、曇点に到達して、新た な相が出現する。このとき、溶液の濃度が臨界濃度より低い場合は濃厚な 相が、高い場合はより稀薄な相ができ始める。そのため、溶液は通常白濁 する。曇点温度はこの白濁の出現を目視で観測するか、あるいは溶液を透 過させた光(透過光)の強度が低下し始める温度として決定できる。溶液 の温度変化はできるだけゆっくりと行うことが肝要である。これは溶液の 温度を均一に保ちながら変化させるためであり、曇点温度として温度変化 の速度に依らない値を得るためである。図3.18に測定の1例を示す。こ の例の場合、曇点付近での温度低下は1時間当たり約0.6°Cとなってい る。曇点温度では透過光の強度が急激に減少しているのが見られる。

[尖点の決定]

尖点を決定する式 (3.8) に現れる行列式は光散乱における Rayleigh 比



図 3.18 透過光強度の温度(時間)変化(右から左へ)の例



図 3.19 散乱光強度の逆数 I_{30}^{-1} (散乱角 30°)の温度変化

を与える式 (2.B.46) の分母と同一である。これは尖点において散乱光の 強度が無限大になることを意味する。尖点温度の決定はこの現象を利用 する。与えられた高分子溶液について異なる種々の温度 T で散乱光強度 Iを測定し、その逆数 I^{-1} を T に対してプロットする。 I^{-1} が 0 になる 温度を外挿によって求めればその温度が尖点温度 T。である。ただし、通 常の光散乱測定は均一な1相領域に限られており、曇点曲線以上の温度に 限られる。このため、臨界点付近の濃度の溶液を除いて外挿は遠いものと なり、T。に誤差を伴う。尖点温度の決定に特化した光散乱測定装置とし て PICS (Pulse Induced Critical Scattering) と称する装置が開発されて いる。¹² この装置ではセルとして肉薄の毛細管を使用し、その中に高分 子溶液を密封する。あらかじめ準安定領域に温度を設定した槽にセルを浸 して溶液の温度を急激に設定温度にするとともに散乱光強度を測定し、そ の後すぐに温度を曇点以上に戻す。なお、入射光は毛細管の中を通るよう になっている。測定例を図 3.19 に示す。この例の測定試料は単分散ポリ スチレン (C、D) とポリスチレン混合物 (A、B) のシクロヘキサン溶液で ある。なお、*I*₃₀ は散乱角 30° における散乱光強度であり、縦軸の原点は 0 である。図中の T。が決定された尖点温度を示す。

[臨界点の決定]

臨界点の決定においてはまず曇点曲線をあらかじめ求めておく。ここで 取り上げる例として、ポリスチレン混合物のシクロヘキサン溶液の曇点曲 線と臨界点の結果を図 3.20 に示す。¹³ 測定の対象は単分散ポリスチレン 試料 $f_4(M_w = 45300) \ge f_{40} (M_w = 498000)$ の混合物で、図中の実線が曇 点曲線、四角が臨界点であり、 ξ_4 は混合物中の試料 f_4 の重量分率である。 いま、与えられた濃度の溶液を曇点以下の温度で相分離させ、平衡状態の 2 相の体積比 r(濃厚相の体積に対する稀薄相の体積の比)を決定する。ま た、その濃度における曇点温度と相平衡温度との差を ΔT とし、 $r \in \Delta T$ に対してプロットする。与えられた溶液濃度が臨界濃度である場合、相平 衡温度が曇点温度に近づけば、すなわち ΔT が 0 に近づけば、梃子の法則 により r は 1 に近づく。溶液濃度が臨界濃度より低ければ ΔT が 0 に接近 すると r は無限大に発散する。一方、溶液濃度が臨界濃度より高い場合、 ΔT が 0 の近づくと r は 0 に近づく。



図 3.20 ポリスチレン混合物 f₄($M_w = 45300$)+f₄₀($M_w = 498000$) のシクロヘキ サン溶液の曇点曲線と臨界点



図 3.21 相分離した 2 相の体積比 r の温度変化 (ξ = 0.500)



図 3.22 相分離した 2 相の体積比 r の温度変化 ($\xi = 0.950$)

測定の例を図 3.21 に示す。この結果から、臨界濃度 ϕ_c は 0.0791 と 0.0843 の間にあることが分かる。さらに測定濃度を増やせば望む精度での ϕ_c を 求めることができる。実際この例における ϕ_c は 0.082 と決定されている。

もう1つの臨界点決定の例を図 3.22 に示す。ここでは、いくつかの濃度 ϕ の溶液について rの ΔT に対する曲線を求める。それらの曲線から r = 1 となる ΔT を得て、r = 1 となる温度 T を決定する。このようにし て得た T 対 ϕ のプロットが与える曲線と曇点曲線との交点から、図 3.22 の挿入図に示すように、臨界点の濃度 ϕ_c と温度 T_c が決定できる。

以上の2つの方法で求めた臨界点が図3.20の四角で表す結果である。

参考文献

- 1. 倉田道夫、「高分子工業化学 III」、朝倉書店、1975.
- R. Koningsveld, W. H. Stockmayer, and E. Nies, "Polymer Phase Diagrams," Oxford University Press, Oxford, 2001.
- G. Rehage, D. Moeller, and O. Ernst, *Makromol. Chem.*, 88, 232 (2965).

- J. W. Kennedy, M. Gordon, and R. Koningsveld, J. Polym. Sci., C39, 71 (1972).
- J. W. Breitenbach and B. A. Wolf, *Makromol. Chem.*, **108**, 263 (1967).
- L. A. Kleintjens, R. Koningsveld, and W. H. Stockmayer, *Brit. Polym. J.*, 8, 144 (1976).
- H. Fujita and Y. Einaga, Makromol. Chem., Macromol. Symp., 12, 75 (1987).
- 8. Z. Tong, Y. Einaga, and H. Fujita, Macromolecules, 18, 2264 (1985).
- 9. Y. Einaga, Z. Tong, and H. Fujita, *Macromolecules*, **18**, 2258 (1985).
- 10. H. Tompa, Trans. Faraday Soc., 45, 1142 (1949).
- Y. Einaga, Y. Nakamura, and H. Fujita, *Macromolecules*, **20**, 1083 (1987).
- K. W. Derham, J. Goldsbrough, and M. Gordon, *Pure & Appl. Chem.*, 38, 97 (1974).
- 13. M. Tsuyumoto, Y. Einaga, and H. Fujita, Polym. J., 16, 229 (1984).

4章 異種高分子3成分溶液の相平衡

この章では、化学構造が異なる異種高分子2成分と溶媒1成分から成る3 成分系を取り扱う。この3成分系の相平衡挙動は各成分間の相互作用に極 めて敏感である。特に、異種高分子の相溶性および用いる溶媒に対する各 高分子の溶解性によって相図は多様な様相を呈する。¹

図 4.1 に典型的な相図の例を示す。この図はポリスチレン (PS) とポリ ブタジエン (PBD) 混合物のトルエン溶液の例である。² PS の重量平均分 子量 M_w は 87300、PBD の M_w は 130000 で、温度は 23 °C である。実線 は双交曲線、丸印は共存組成を表しており、破線は連結線である。なお、 三角は相分離前の母溶液の組成を示す。ポリスチレンとポリブタジエンは 非相溶であるため、相分離領域は溶媒頂点側から PS-PBD 軸の方向に向 かって開いている。均一な1相領域は溶媒頂点近傍の稀薄な部分にとどま る。溶媒のトルエンはポリスチレンとポリブタジエンの両方に対して良溶 媒であるので、連結線の向きは PS-PBD 軸と平行に近くなっている。異 種高分子の殆どは互いに非相溶であるので、それらの混合物溶液の相図は 図 4.1 の型になるのが一般的である。異種高分子の組が一般に非相溶性で あるのは、高分子の分子サイズが大きいために混合エントロピーが大きく ならないことに依っている。

特殊な例として、相溶性を持つ異種高分子の組み合わせでよく知られ たポリスチレン (PS) とポリビニルメチルエーテル (PVME) がある。そ れらの混合物溶液の相図を図 4.2 に示す。³ ここで、PS の M_w は 2100、 PVME の M_w は 14000 である。温度は白丸が 14 °C、半黒丸が 28 °C、 黒丸が 30 °C である。溶媒であるジクロロエチレン (C₂HCl₃) はポリスチ レンに対して貧溶媒であり、ポリビニルメチルエーテルに対して良溶媒で ある。このため、14 °C では PS+C₂HCl₃2 成分溶液で相分離が見られる。 28 °C と 30 °C では、この 3 成分系に含まれるどの 2 つの成分の組み合



図 4.1 ポリスチレン+ポリブタジエン混合物のトルエン溶液の相図



図 4.2 ポリスチレン+ポリビニルメチルエーテル混合物のトリクロロエチレン溶液の相図

わせから成る2成分混合物系においても相分離は見られないが、3成分混 合物系では半黒丸あるいは黒丸で囲まれた相分離領域が現れている。これ は相溶性をもつ高分子混合物溶液に見られる相図の特徴と云える。この型 の相分離は溶媒の各高分子に対する溶解性の差に起因する。同じような相 図は混合溶媒と単一高分子から成る3成分系においても見られることが ある。

4.1 曇点曲線と双交曲面

非相溶の 2 成分と溶媒 1 成分から成る 3 成分系の 3 次元相図を図 4.3 に 示す。⁴高分子成分はポリスチレン (PS) とポリイソプレン (PIP) で溶媒 はシクロヘキサン (CH) である。PS の M_w は 43900、PIP の M_w は 53300 である。図中、実線と破線で表す曲面が双交曲面である。この双交曲面の 高濃度側が相分離領域で、低濃度側が均一 1 相領域である。ポリスチレ ンとポリイソプレンの非相溶性を反映して、相分離領域は溶媒頂点側から PS-PIP 軸の方向に広がる型をとっている。温度が上昇するにつれて相分 離領域は少しづつ高濃度側に移動し、稀薄な均一 1 相領域が若干広くなる が、PS と PIP の非相溶性に基く相分離の特徴に目立った変化は無い。温 度が 15 °C で Φ_{PS} 軸と温度 T 軸の作る面に近いところで、双交曲面に棚 状の部分が現れている。これは溶媒のシクロヘキサンがポリスチレンに対 して貧溶媒であり、更に低温で図に示すように PS+CH2 成分溶液が相分 離を起こすことによるものである。なお、シクロヘキサンはポリイソプレ ンに対して良溶媒である。

いま、PS+PIP 混合物中における PS の体積分率を ξ_{PS} とする。溶媒頂 点 (原点)から PS-PIP 軸上で ξ_{PS} を表す点を結ぶ直線を引き、その直線 から垂直 (温度 T 軸方向)に立てた面で双交曲面を切ると曇点曲線が得ら れる。曇点曲線の結果が図 4.4 である。 ξ_{PS} が小さい (PS 含量が少ない) 場合、曇点曲線は全温度域で鉛直に近い曲線となっている。一方、 $\xi_{|rmPS}$ が大きい (PS 含量が多い)場合、高温領域ではやはり鉛直に近い曇点曲線 となっているが、温度が低下するにつれて曇点曲線は PS+CH2 成分溶液 の相分離を反映してその 2 成分系の双交曲線 (曇点曲線) に収斂する。

(実際には、図 4.3 の双交曲面は図 4.4 に示した曇点曲線の測定結果から



図 4.3 ポリスチレン+ポリイソプレン混合物のシクロヘキサン溶液の双交曲面



図 4.4 ポリスチレン+ポリイソプレン混合物のシクロヘキサン溶液の曇点曲線



図 **4.5** ポリスチレン+ポリイソブチレン混合物のシクロヘキサン溶液 (左) とベン ゼン溶液 (右) の曇点曲線

作成したもので、図中の丸印は曇点を表している。)

もう1つの例として、ポリスチレン (PS) とポリイソブチレン (PIB) 混 合物のシクロヘキサン (CH) 溶液およびベンゼン (Benzene) 溶液の曇点曲 線を図 4.5 に示す。⁵ ポリスチレンとポリイソブチレンも非相溶である。 ここで、 ξ_{PS} はそれぞれの混合物中のポリスチレンの体積分率である。各 高分子成分の重量平均分子量 M_w は図中に示している。なお、ポリイソブ チレンとベンゼンは屈折率の差が小さくその2成分系の曇点は実測できな い。したがって図中の破線は後で述べる曇点曲線の計算値である。種々の ξ_{PS} (PS 含量) の曇点曲線の特徴は図 4.4 の PS+PIP+CH 系の結果に類似 している。特筆すべき点は、PS+CH2 成分溶液にわずかの PIB が加わっ たとき、あるいは PIB+Benzene2 成分溶液にわずかの PS が加わったと き曇点曲線が大きく変化することである。

これらの曇点曲線から作成した双交曲面が図 4.6 である。PS+PIB+CH3 成分系と PS+PIB+Benzene3 成分系のいずれにおいても、相分離が PS と



図 4.6 ポリスチレン+ポリイソブチレン混合物のシクロヘキサン溶液 (左) とベン ゼン溶液 (右)の双交曲面

PIB の非相溶性を主たる起因で起こることを反映して、相分離領域は溶媒 頂点側から PS-PIB 軸方向に広がっている。この PS と PIB の反発的な 相互作用による相分離は温度が上昇してもあまり変化しない。一方低温領 域において、PS+PIB+CH3 成分系では CH が PS に対して貧溶媒であり PS+CH2 成分溶液が低温で相分離することのより、 Φ_{PS} 軸と温度 T 軸が 成す平面の近くで棚状の双交曲面が現れる。同様に、PS+PIB+Benzene3 成分系では Benzene が PIB に対して貧溶媒であり PIB+CH2 成分溶液が 低温で相分離することのより、 Φ_{PIB} 軸と温度 T 軸が成す平面の近くで棚 状の双交曲面が現れる。このように、相図の様相は異種高分子間の非相溶 性のみならず、溶媒の各高分子成分に対する溶解性の違いによっても大き く変化することが分かる。

これらの3成分溶液が30°Cで与える双交曲線(実線)と連結線(破線)



図 **4.7** ポリスチレン+ポリイソブチレン混合物のシクロヘキサン溶液とベンゼン 溶液の双交曲線と連結線

を図 4.7 に示す。実質的に同一の重量平均分子量 M_w を持つ PS と PIB 混 合物の溶液であるにも拘わらず、双交曲線の形および連結線の向きは溶媒 によって大きく異なることが分かる。PS+PIB+CH3 成分系では連結線の 方向は Φ_{PS} 軸に近く、PS をより豊富に含む相と PS の少ない相に分離す る。一方、PS+PIB+Benzene3 成分系では連結線は Φ_{PIB} 軸に近い方向を 向いており、PIB をより多く含む相と PIB の少ない相に分離することが 分かる。これらの結果は、更に低温になると PS+CH2 成分溶液、あるい は PIB+Benzene2 成分溶液が相分離する影響によるものである。

4.2 一般論

第2章と第3章では、van't Hoff 溶液を基準とし、相互作用函数として 見かけの第2ビリアル係数を採用することによって、2成分および準2成 分高分子溶液の相図が比較的簡単な形の相互作用函数で定量的に表しうる ことを述べた。しかし、その場合溶媒成分0の過剰化学ポテンシャル $\Delta\mu_0$ と溶質成分iの過剰化学ポテンシャル $\Delta\mu_i$ の式は非対称となる。また、高 分子混合物の濃度が高くなるにつれて van't Hoff 溶液と実在の溶液との差 が大きくなる。異種高分子のブレンドを含む広い濃度範囲の高分子混合物 溶液を扱う場合、Flory-Huggins 理論を基準とする現象論を採用するのが 有利と云える。

溶媒成分 $0 \ge 2$ つの高分子成分 1、 2 から成る 3 成分系の混合 Gibbs 自由エネルギー ΔG は一般に次式で表される。

$$\Delta G = RT(N_0 + \sum_{i=1}^2 N_i P_i) \left(\phi_0 \ln \phi_0 + \sum_{i=1}^2 \frac{\phi_i}{P_i} \ln \phi_i + h \right)$$
(4.1)

ここで、 N_i 、 $\phi_i \ge P_i$ はそれぞれ成分 i の分子数、体積分率と相対鎖長で ある。函数 h は実在溶液の Flory-Huggins 無熱溶液からのずれを全て含 む。古くには、h は

$$h = \chi_{01}\phi_0\phi_1 + \chi_{02}\phi_0\phi_2 + \chi_{12}\phi_1\phi_2 \tag{4.2}$$

と表された。 6,7 式中の χ_{ij} は成分 $i \geq j$ 間の相互作用を表すパラメータ である。第2章および第3章で述べてきたようにこれらのパラメータは温 度のみならず系の組成に依存するので、各成分間の相互作用を表すにはこ の式は適切とは云えない。これに対して、Koningsveld ら⁸ は h を

$$h = g_{01}(\phi_1, \phi_2) + g_{02}(\phi_1, \phi_2) + g_{12}(\phi_1, \phi_2)$$
(4.3)

と表した。この式は極めて一般的であると云える。しかしながら、各成分間の相互作用を表す3つの函数 *g_{ij}* はいずれも同じ組成の函数であり、実験的にそれらを分離評価する手段がない。

以下では、浸透圧のビリアル展開式から函数 h を導出する方法を示す。 ⁹前述と同様に溶媒の化学ポテンシャル μ₀の式によって相互作用パラメー

4.2 一般論

9χ を定義する。

$$\frac{\mu_0 - \mu_o^{\circ}}{RT} = \ln \phi_0 + \left(1 - \frac{1}{P_n}\right) + \chi \phi^2 \tag{4.4}$$

ここで、 $\phi = \phi_1 + \phi_2$ であり、数平均相対鎖長 P_n は

$$\frac{1}{P_n} = \frac{\xi_1}{P_1} + \frac{\xi_2}{P_2} \tag{4.5}$$

で与えられる。 $\xi_i = \phi_i / \phi$ である。相互作用パラメータ χ は式 (4.1) の函数 h と

$$\chi = -\left[\frac{\partial(h/\phi)}{\partial\phi}\right]_{T,p,\xi_1} \tag{4.6}$$

のように関係づけられる。式 (4.4) より、Gibbs-Duhemの関係から溶質成 分 i の化学ポテンシャル μ_i は

$$\frac{\mu_i - \mu_i^{\infty}}{RT} = \ln \phi_i + P_i \left(1 - \frac{1}{P_n} \right) \phi$$
$$-P_i \left\{ \chi \phi_0 \phi + \int_0 \phi \left[\chi + (1 - \xi_i) \left(\frac{\partial \chi}{\partial \xi_i} \right)_{T, p, \phi} \right] \mathrm{d}\phi \right\}$$
$$(i = 1, 2) \tag{4.7}$$

と導かれる。なお、

$$\mu_i^{\infty} = \lim_{\phi \to 0} (\mu_i - RT \ln \phi_i) \quad (i = 1, 2)$$
(4.8)

である。式 (4.7) は溶質成分 i の無限稀釈状態を標準状態とした μ_i の表現 である。これらの式を用いると h は

$$h = -\phi \int_0^\phi \chi d\phi + \phi \sum_{i=1}^2 \xi_i \left[\frac{\mu_i^\infty - \mu_0^\circ}{P_i RT} - \frac{1}{P_i} + 1 \right]$$
(4.9)

と表される。 μ_i^{∞} および μ_0° は溶液の組成にはよらない温度のみの函数で ある。ここで、注意すべき点は元来の Flory-Huggins 理論とは異なって、 この定式化は成分 1 と 2 の無限稀薄溶液を参照状態にとっていることで ある。 温度 T を一定、溶媒の化学ポテンシャル μ_0 を一定としたとき、この 3 成分溶液の浸透圧 π は次式のように展開できる。¹¹

$$\frac{\pi}{RT} = -\frac{\mu_0 - \mu_0^2}{V_0 RT}$$
$$= \sum_{i=1}^2 \frac{c_i}{M_i} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 B_{ij} c_i c_j$$
$$+ \frac{1}{3} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 B_{ijk} c_i c_j c_k + \cdots$$
(4.10)

この式と式 (4.4) から、補遺 4.A に示すように相互作用パラメータ χ は

$$\chi = \xi_1^2 \chi_{11}(\phi_1) + \xi_2^2 \chi_{22}(\phi_2) + 2\xi_1 \xi_2 \chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$$
(4.11)

と書けることが分かる。ここで、 χ_{ii} および χ_{12} は

$$\chi_{ii}(\phi_i) = E_{ii} + E_{iii}\phi_i + E_{iiii}\phi_i^2 + \cdots \quad (i = 1, 2)$$
 (4.12)

$$\chi_{12}(\phi_1, \phi_2) = E_{12} + \frac{3}{2}(E_{112}\phi_1 + E_{122}\phi_2) + \cdots$$
 (4.13)

である。なお、EとBは

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{V_0 B_{ij}}{v_i v_j} \right), \quad E_{ijk} = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{V_0 B_{ijk}}{v_i v_j v_k} \right), \quad \dots \quad (4.14)$$

と関係づけられる。ここで、 v_i は成分 i の部分比容である。式 (4.11) 中の $\chi_{ii}(\phi_i)$ は式 (4.12) から解るように、溶媒成分 0 と溶質成分 i の 2 成分系 に対する量であり、溶媒中における溶質成分間の相互作用を表している。 したがって、それらの函数は 2 成分溶液の浸透圧測定、光散乱測定等から 決定することができる。これに対して、相互作用函数 $\chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$ は未知 である。しかし、 $\chi_{11}(\phi_1) \ge \chi_{22}(\phi_2)$ が分かっておれば、当該の 3 成分系 に対する熱力学測定から $\chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$ を求めることができる。

函数 χ_{ij} は見かけの第 2 ビリアル係数と同様、稀薄溶液における分子分 布函数に基く理論で現れるクラスター積分と関係づけることができる。式 (4.14) 中の 1/2、1/3、… は体積 V_0 の剛体セグメントに対するクラスター 積分から生じる。したがって、式 (4.11) の χ は分断されたセグメント間 の剛体ポテンシャルを基準として溶質間の相互作用を表しているものと考 えられる。
4.3 3 成分系の光散乱

前節の式 (4.4) と (4.7) を用いると、第2章の補遺 2.B の式 (2.B.46) よ リ、補遺 4.B に示すように 3 成分溶液に対する光散乱関係式が最終的に以 下のように表される。¹⁰ 3 成分溶液の前方散乱に対する過剰 Rayleigh 比 Δ*R*₀ は

$$\frac{KV_0\phi}{\Delta R_0} = \frac{1 + \phi(1 - \phi)^{-1}P_w - \phi(P_wL + Y)}{WX}$$
(4.15)

と表される。ここで、Kは光学定数 $2\pi n^2/N_A \lambda_0^4$ (n は溶液の屈折率、 λ_0 は真空中の入射光波長)である。式中のW、X、Y は

$$W = \frac{\tilde{\gamma}_1^2 P_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2^2 P_2 \xi_2}{(1-\phi)^2}$$
(4.16)

$$X = 1 + \frac{\xi_1 \xi_2}{\tilde{\gamma}_1^2 P_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2^2 P_2 \xi_2} \left\{ (\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)^2 P_1 P_2 \left[1 + \left(\frac{1}{P_n} - 1 \right) \phi \right] \phi - 2(\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)(\tilde{\gamma}_1 P_1 - \tilde{\gamma}_2 P_2) \phi - (\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)^2 P_1 P_2 (1 - \phi)^2 \phi L + 2(\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)(\tilde{\gamma}_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2 \xi_2) P_1 P_2 (1 - \phi) \phi Q + (\tilde{\gamma}_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2 \xi_2)^2 P_1 P_2 S \right\}$$

$$(4.17)$$

$$Y = \xi_1 \xi_2 \left[2(P_1 - P_2)Q - P_1 P_2 \left(\frac{1}{1 - \phi} + \frac{1}{P_n \phi} - L \right) S + P_1 P_2 \phi Q^2 \right]$$
(4.18)

と表される量である。ここで、

$$P_w = P_1 \xi_1 + P_2 \xi_2 \tag{4.19}$$

$$\tilde{\gamma}_i = \gamma_i - \sum_{j=1}^2 \phi_j \gamma_j \tag{4.20}$$

$$\gamma_i = \left(\frac{\partial n}{\partial \phi_i}\right)_{\phi_k} \tag{4.21}$$

$$L = 2\chi + \phi \left(\frac{\partial \chi}{\partial \phi}\right)_{\xi_1} \tag{4.22}$$

$$Q = \left(\frac{\partial \chi}{\partial \xi_1}\right)_{\phi} \tag{4.23}$$

$$S = -\int_0^\phi \left(\frac{\partial^2 \chi}{\partial \xi_1^2}\right) \mathrm{d}\phi \tag{4.24}$$

である。なお、 γ_i は体積分率を用いたときの屈折率増分を表す。また、式 (4.15) は χ の表現には依らない一般式である。

前節の χ の式 (4.11) を式 (4.15) に代入すると、3 成分系の過剰 Rayleigh 比 ΔR_0 は 3 つの函数 $\chi_{11}(\phi_1), \chi_{22}(\phi_2),$ および $\chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$ で表されるこ とになる。先に述べたように、これらの函数のうち $\chi_{11}(\phi_1) \geq \chi_{22}(\phi_2)$ は 溶媒と成分 1 の 2 成分系および溶媒と成分 2 の 2 成分系に対する量であり、 それらは対応する 2 成分溶液についての熱力学測定から決定できる。した がって、 ΔR_0 に対する式 (4.15) は函数 $\chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$ についての微積分方程 式となる。ただし、 ΔR_0 の測定結果から、その式を解いて $\chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$ を 求めるのは容易ではない。後述のように、 $\chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$ に対して適切な函 数を仮定し、3 成分系の ΔR_0 の実測値に対する式 (4.15) による ΔR_0 の 計算値とのフィッティングから $\chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$ を求めるしかない。

溶媒成分0と成分iの2成分系に対して、式(4.15)は

$$\frac{KV_0\gamma_i}{\Delta R_0} = \frac{1}{1-\phi} + \frac{1}{P_i\phi} - L_{ii}$$
(4.25)

となる。ここで、 L_{ii} は $\chi_{ii}(\phi_i)$ と

.

$$\chi_{ii}(\phi_i) = \frac{1}{\phi_i^2} \int_0^{\phi_i} L_{ii}\phi_i \mathrm{d}\phi_i$$
(4.26)

の関係がある。したがって、2成分溶液の光散乱から直接求められるのは χ_{ii} ではなく、 L_{ii} である。

式 (4.15) を ϕ について冪級数展開すると

$$\frac{KV_0\phi}{\Delta R_0} = \frac{1}{\bar{P}} + \frac{1}{\bar{P}} \left[(\gamma_1 P_1 \xi_1 + \gamma_2 P_2 \xi_2)^2 (1 - 2\chi_0) -2\xi_1 \xi_2 (\gamma_1 P_1 \xi_1 + \gamma_2 P_2 \xi_2) (\gamma_1 P_1 - \gamma_2 P_2) \left(\frac{\partial \chi_0}{\partial \xi_1} \right) -(\xi_1 \xi_2)^2 (\gamma_1 P_1 - \gamma_2 P_2)^2 \left(\frac{\partial^2 \chi_0}{\partial \xi_1^2} \right) \right] \phi + \cdots$$
(4.27)

4.3 3 成分系の光散乱

となる。ここで、

$$\bar{P} \equiv \gamma_1^2 P_1 \xi_1 + \gamma_2^2 P_2 \xi_2 \tag{4.28}$$

であり、 χ_0 は展開式

$$\chi(\phi,\xi_1) = \chi_0(\xi_1) + \chi_1(\xi_1)\phi + \cdots$$
(4.29)

の第1項である。

"光学的シータ (Θ) 条件"、¹² すなわち $\gamma_1 P_1 \xi_1 + \gamma_2 P_2 \xi_2 = 0$ の下では 式 (4.27) は

$$\frac{KV_0\phi}{\Delta R_0} = \frac{1}{\bar{P}} - \frac{(\xi_1\xi_2)^2(\gamma_1 P_1 - \gamma_2 P_2)^2}{\bar{P}^2} \left(\frac{\partial^2 \chi_0}{\partial \xi_1^2}\right) \phi + \cdots$$
(4.30)

となる。この式は式 (4.2) のように χ が $\chi = \chi_{01}\xi_1 + \chi_{02}(1-\xi_1) + \chi_{12}\xi_1(1-\xi_1)$ のように表せる場合、異種高分子間の相互作用パラメータ χ_{12} が直接 求められることを示す。

.

以下、ここで述べた方法の具体例を先に示したポリスチレン (PS) とポ リイソプレン (PIP) 混合物のシクロヘキサン (CH) 溶液を例として説明す る。溶媒を成分 0、ポリスチレンを成分 1、ポリイソプレンを成分 2 とす る。第 2 章に示したように $L_{11}(\phi_1)$ (第 2 章の Z に対応する。 $2Z = L_{11}$ である。) は

$$L_{11}(\phi_1) = 2 \left[\chi_{conc}^{\circ} + \frac{\phi_1}{2} + \frac{A\phi_1^4}{1 + B\phi_1^2} + (\chi_{dil}^{\circ} - \chi_{conc}^{\circ}) R(P_1^{1/2}\phi_1) \right]$$
(4.31)

ここで、

$$\chi_{conc}^{\circ} = 0.4930 + 0.345 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + \left(-\frac{0.075}{P_1^{1/2}} - \frac{45}{P_1^2} + 0.007\right) \\ \times \exp\left[-\left(40 - \frac{520}{P_1^{2/3}}\right) \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right]$$
(4.32)



図 4.8 ポリイソプレン+シクロヘキサン溶液の相互作用パラメータ

$$\chi_{dil}^{\circ} = 0.5 + 0.26 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + 4.6 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2$$
(4.33)

$$A = 1.4P_1^{1/3} \tag{4.34}$$

$$B = 7P_1^{1/3} \exp\left[-18\left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right] \tag{4.35}$$

$$R(x) = \exp(-x - 0.3x^3) \tag{4.36}$$

である。

ポリイソプレン $(M_w = 53300)$ のシクロヘキサン 2 成分溶液について の光散乱結果を示したのが図 4.8 である。¹⁰ ポリスチレンのシクロヘキ サン 2 成分溶液の場合と同様に、この図の結果は $L_{22}(\phi_2)$ が 2 つの函数 $L_{22,dil}(\phi_2) \ge L_{22,conc}(\phi_2)$ の和

$$L_{22}(\phi_2) = L_{22,dil}(\phi_2) + L_{22,conc}(\phi_2) \tag{4.37}$$

で表せることを示している。これら2つの函数は次の式でよく表される。

$$L_{22,dil}(\phi_2) = 0.170 \exp(-47\phi_2) \tag{4.38}$$



図 4.9 ポリスチレン+ポリイソプレン混合物+シクロヘキサン溶液の光散乱結果

$$L_{2,conc}(\phi_2) = 0.68 + \left(-0.88 + \frac{680}{T}\right)\phi_2 \tag{4.39}$$

図 4.8 の実線はこれらの式による計算値であり、実測値をよく表している。 式 (4.26) により $\chi_{22}(\phi_2)$ を求めると

$$\chi_{22}(\phi_2) = 0.34 + \frac{2}{3} \left(-0.44 + \frac{340}{T} \right) \phi_2 + \frac{0.17[1 - (1 + 47\phi_2)\exp(-47\phi_2)]}{(47\phi_2)^2}$$
(4.40)

となる。(PIP+CH系については単一の分子量のPIPに対しての結果のみであるので、分子量の函数としては議論できない。)

図 4.9 は PS+PIP+CH3 成分溶液の 3 つの組成 $\xi_{PS}(=\xi_1)=0.0867, 0.458, 0.885$ における光散乱結果である。¹⁰ シンボルの違いは温度の違いを表している。同じ濃度 ϕ では温度が低いほど $KV_0\phi/\Delta R_0$ は小さくなっている。なお、縦軸上の点は \bar{P}^{-1} の計算値である。

函数 $\chi_{12}(\phi,\xi_1)$ について、 ϕ に関する展開式で ϕ の1次の項までをとる

最も簡単な式

$$\chi_{12}(\phi,\xi_1) = k_0 + (k_1\xi_1 + k_2\xi_2)\phi \tag{4.41}$$

を採用する。 k_0 、 k_1 、 k_2 は未知の係数である。式 (4.31)、(4.40) と (4.41) を用いると、式 (4.15) の $KV_0\phi/\Delta R_0$ はこれら 3 つの係数の函数となる。 図 4.9 の実線は試行錯誤により実測値と最もよく合うように k_0 、 k_1 、 k_2 を求めて得た $KV_0\phi/\Delta R_0$ の計算値である。計算値と実測値の一致は完全 ではないが、前者は後者をよく表していると云える。係数 k_0 、 k_1 、 k_2 に 対する結果は

$$k_0 = 0.44, \quad k_1 = -6.1 + \frac{2000}{T}, \quad k_2 = -4.8 + \frac{1300}{T}$$
(4.42)

である。

これまでに得られている $L_{ii}(\phi_i)$ あるいは $\chi_{ii}(\phi_i)$ と $\chi_{12}(\phi,\xi_1)$ を補遺 4.C に纏めている。これらは 1 つの系を除いていずれも光散乱測定によっ て求められたものである。それらのうち、ポリスチレン+シクロヘキサン 2 成分系およびポリイソプレン+ジオキサン 2 成分系の $L_{ii}(=2Z)$ がそれ ぞれの 2 成分系の相図をよく表すことを第 2 章で示した。

図 4.10 と 4.11 に、ポリスチレン (PS)+ポリイソプレン (PIP)+シクロ ヘキサン (CH)3 成分系と PS+ポリイソブチレン (PIB)+CH 3 成分系にお ける χ_{ii} の濃度変化および χ_{12} の濃度 ϕ と高分子混合物の組成 $\xi_1(=\xi_{PS})$ による変化を示した。実線は χ_{11} と χ_{22} であり、破線は χ_{12} の $\xi_{PS}(=\xi_1)$ が 0 と 1 の両極端の場合を示しており χ_{12} は ξ_{PS} によってそれらの間で ϕ とともに変化する。

これらの図から、良溶媒系である PIP+CH2 成分系および PIB+CH2 成 分系の χ_{22} は貧溶媒系である PS+CH2 成分系の χ_{11} に比べて小さい値を 持ち、より極端に下に湾曲した曲線にしたがうことが分かる。濃度 $\phi=0$ の とき、 χ_{12} は χ_{11} と χ_{22} の間の値を持つ。有限濃度における χ_{12} は $\xi_{PS} = 0$ では PIP+CH2 成分系あるいは PIB+CH2 成分系の χ_{22} に近い値をとり、 ξ_{PS} が大きくなるにつれて PS+CH2 成分系に対する χ_{11} の値に近づいて いく。



図 4.10 ポリスチレン+ポリイソプレン混合物+シクロヘキサン溶液の相互作用パ ラメータ



図 4.11 ポリスチレン+ポリイソブチレン混合物+シクロヘキサン溶液の相互作用 パラメータ

4.4 現象論による相図の表現

3成分系において、相分離した共存する2相の組成は平衡条件

$$\mu_0'(\phi,\xi_1) = \mu_0''(\phi,\xi_1) \tag{4.43}$$

と

$$\mu_i'(\phi,\xi_1) = \mu_i''(\phi,\xi_1) \quad (i=1,2)$$
(4.44)

から計算できる。式 (4.44) の条件は分離因子 σ_i

$$\sigma_i = \frac{1}{P_i} \ln \left(\frac{\phi_i''}{\phi_i'} \right) \quad (i = 1, 2) \tag{4.45}$$

を用いてより便利に表すことができる。式 (4.4) と (4.7) から、 σ_i は

$$\sigma_i = \Delta \left\{ \ln(1-\phi) + \chi\phi + \int_0^\phi \left[\chi + (1-\xi_i) \left(\frac{\partial\chi}{\partial\xi_i}\right)_{T,p,\phi} \right] \mathrm{d}\phi \right\} \quad (4.46)$$

と書ける。ここで Δ {*X*} は濃厚相と稀薄相の *X* の差 *X''* - *X'* を表す。式 (4.43) と (4.45) は温度 *T* と 4 つの未知の量 ϕ'_i 、 ϕ''_i (*i* = 1,2)、すなわち (ϕ', ξ'_1) と (ϕ'', ξ''_1) に対して 3 つの方程式を与える。したがって、与えら れた *T* と任意の組成変数の 1 つに対して残る 3 つの組成変数がそれらの 方程式から求められる。温度一定でのそれらの組成変数に対する一連の解 からその温度における双交曲線が得られる。さらに、温度を変化させたそ れらの双交曲線から、3 次元の双交曲面を作成することができる。

図4.12 はポリスチレン $(M_w = 43900) +$ ポリイソプレン $(M_w = 53300) +$ シクロヘキサン系の双交曲線と連結線に対する実測値と計算値の比較である。⁴ 白丸と黒丸はそれぞれ 30 °C と 15 ° における共存組成の実測値、破線は連結線の実測結果を表している。実線の曲線は双交曲線に対する計算結果であり、実線の直線は計算による連結線である。双交曲線の計算結果は実験値をかなりよく表している。また、連結線の計算結果は実測の連結線の向きとほぼ一致しており、連結線の方向が温度によって変化する様子をよく再現している。

図 4.13 は同じポリスチレン+ポリイソプレン+シクロヘキサン系の曇点 曲線に対する計算結果である。破線はそれらの曲線に対する共存組成曲



図 **4.12** ポリスチレン+ポリイソプレン混合物+シクロヘキサン溶液の双交曲線と 連結線



図 **4.13** ポリスチレン+ポリイソプレン混合物+シクロヘキサン溶液の曇点曲線 (計算結果)

線、つまり陰点曲線を表す。また、図中の数字はポリスチレン+ポリイソ プレン混合物の組成 ξ_{PS} (= ξ_1)を示す。この図の曇点曲線は図 4.4 に示し た曇点曲線の実験結果の特徴をよく表している。実測結果、計算結果とも に、曇点温度は濃度 ϕ の増加とともに急激に上昇している。また、曇点曲 線は高分子混合物中のポリスチレン含量が減少、すなわち ξ_{PS} が小さくな るにつれて、低濃度側に移動し、 $\xi_{PS} \simeq 0.50$ 付近で最低の濃度 ϕ の位置 をとり、さらに ξ_{PS} が小さくなるのにつれて再び高濃度側に移動する。こ の特徴も実測結果と計算結果で共通している。

ポリスチレン $(M_w=53600)+$ ポリイソブチレン $(M_w=154000)+$ シクロ ヘキサン系の双交曲線と連結線に対する実験結果と計算結果の比較を図 4.14 に、ポリスチレン $(M_w=53600)+$ ポリイソブチレン $(M_w=152000)+$ ベンゼン系の双交曲線と連結線に対する実験結果と計算結果の比較を図 4.15 に示す。⁵ これらの図において、白丸はT=30 °C、黒丸はT=20 °C の共存組成の実測値であり、破線は連結線に対する実験結果である。実線 の曲線は計算による双交曲線を、実線の直線は連結線に対する計算結果を 表している。双交曲線の計算結果は実測の共存組成とほぼ一致している。 連結線も計算結果と実験結果はほぼ一致している。特に、連結線の向きが 溶媒の種類によって大きく変わる実験結果、および温度によっても変化す る実験結果は計算によってよく再現されている。しかし詳しく観ると、臨 界点付近 (連結線が双交曲線に近づく領域)において、計算による双交曲線 は実験結果に比べてより大きく湾曲した形になっている。これは臨界現象 によって、実際の双交曲線はかなり平坦な曲線になることによるもので、 ここで採用している古典論では再現し得ない。

参考までに、混合溶媒2成分と単一高分子から成る3成分系の例として、ポリスチレン+シクロヘキサン+N,N'ジメチルホルムアミド3成分系についての結果¹⁶を補遺4.Dに述べる。



図 **4.14** ポリスチレン+ポリイソブチレン混合物+シクロヘキサン溶液の双交曲線 と連結線



図 **4.15** ポリスチレン+ポリイソブチレン混合物+ベンゼン溶液の双交曲線と連 結線

4.A 3成分系に対する相互作用函数の導出

温度 T を一定、溶媒の化学ポテンシャル μ_0 を一定としたとき、浸透圧 π は

$$V_0 \pi = -(\mu_0 - \mu_0^\circ) \tag{4.A.1}$$

で与えられる。一般に、3 成分溶液の浸透圧 π は次式のように展開することができる。¹¹

$$\frac{\pi}{RT} = \sum_{i=1}^{2} \frac{c_i}{M_i} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} B_{ij} c_i c_j + \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \sum_{k=1}^{2} B_{ijk} c_i c_j c_k + \cdots$$
(4.A.2)

高分子成分1と2の部分比容が溶液の組成に依存しないとき、この式は

$$\frac{V_0 \pi}{RT} = \frac{\phi}{P_n} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 D_{ij} \phi_i \phi_j + \frac{1}{3} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 D_{ijk} \phi_i \phi_j \phi_k + \cdots$$
(4.A.3)

と書き直せる。ここで、

$$D_{ij} = \frac{V_0 B_{ij}}{v_i v_j}, \quad D_{ijk} = \frac{V_0 B_{ijk}}{v_i v_j v_k}, \quad \cdots$$
 (4.A.4)

本文中の式(4.4)と式(4.A.1)および(4.A.3)から、相互作用パラメータ χ は

$$\chi = \phi^{-1} \left(\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} E_{ij} \phi_i \phi_j + \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \sum_{k=1}^{2} E_{ijk} \phi_i \phi_j \phi_k + \cdots\right)$$
(4.A.5)

と表せる。ただし、

$$E_{ij} = \frac{1}{2}(1 - D_{ij}), \quad E_{ijk} = \frac{1}{3}(1 - D_{ijk}), \quad \cdots$$
 (4.A.6)

である。 E_{ij} 、 E_{ijk} 、… は添え字の交換について不変であるので、式 (4.A.5) は次式のように書くことができる。

$$\chi = \xi_1^2 (E_{11} + E_{111}\phi_1 + E_{1111}\phi_1^2 + \cdots) + \xi_2^2 (E_{22} + E_{222}\phi_2 + E_{2222}\phi_2^2 + \cdots) + 2\xi_1\xi_2 [E_{12} + \frac{3}{2}(E_{112}\phi_1 + E_{122}\phi_2) + 2E_{1112}\phi_1^2 + 3E_{1122}\phi_1\phi_2 + 2E_{1222}\phi_2^2 + \cdots]$$
(4.A.7)

 $\xi = 1$ のとき、系は成分 1 と溶媒の 2 成分系となり、 χ は $\chi_{11}(\phi_1)$ で表される。式 (4.A.7) より、

$$\chi_{11}(\phi_1) = E_{11} + E_{111}\phi_1 + E_{1111}\phi_1^2 + \cdots$$
 (4.A.8)

となる。同様に、 $\xi_2 = 1$ のとき、系は溶媒と成分 2 の 2 成分系であり、 $\chi = \chi_{22}(\phi_2)$ は

$$\chi_{22}(\phi_2) = E_{22} + E_{222}\phi_2 + E_{2222}\phi_2^2 + \cdots$$
 (4.A.9)

と書ける。式 (4.A.7 から $\xi_1^2 \chi_{11}(\phi_1) + \xi_2^2 \chi_{22}(\phi_2)$ を差し引き、残った部分 を $2\xi_1\xi_2\chi_{12}(\phi_1,\phi_2)$ と書くと、 $\chi_{12}(\phi_1\phi_2)$ は

$$\chi_{12}(\phi_1\phi_2) = E_{12} + \frac{3}{2}(E_{112}\phi_1 + E_{122}\phi_2) + 2E_{1112}\phi_1^2 + 3E_{1122}\phi_1\phi_2 + 2E_{1222}\phi_2^2 + \dots (4.A.10)$$

と表せる。

以上を整理して

$$\chi = \xi_1^2 \chi_{11}(\phi_1) + \xi_2^2 \chi_{22}(\phi_2) + 2\xi_1 \xi_2 \chi_{12}(\phi_1, \phi_2)$$
(4.A.11)

が得られる。

4.B 3 成分系に対する光散乱式の導出

温度 T 一定および圧力 p 一定における多成分溶液の前方散乱に対する過 剰 Rayleigh 比 ΔR_0 は一般に次式で表される。¹¹ (第 2 章の補遺 2.B の式 (2.B.46) 参照)

$$\Delta R_0 = K v_M RT \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_i}\right)_{T,p,m_k} \left(\frac{\partial \tilde{n}}{\partial m_j}\right)_{T,p,m_k} \frac{\psi^{ij}}{|\boldsymbol{\psi}|} \qquad (4.B.1)$$

ここで、K は光学定数 ($K = 2\pi^2 n^2/N_A \lambda_0^4$)、 m_i は成分 i の質量モル濃度 であり、 v_M は溶媒の単位質量あたりの溶液の体積で

$$v_M = \frac{V_0(n_0 + \sum_{i=1}^r n_i P_i)}{n_0 M_0}$$

= $\frac{V_0}{M_0(1 - \phi)}$ (4.B.2)

と表される。 n_i は成分 i の物質量 (単位はモル) である。また、| ψ |は $\mu_{ij} = (\partial \mu_i / \partial m_j)_{m_k}$ を要素に持つ行列式で、 ψ^{ij} はこの行列式の要素 ψ_{ij} に対する余因子である。

3成分系の場合、成分iの体積分率 ϕ_i は質量モル濃度 m_i と

$$\phi_i = \frac{M_0 m_i P_i}{1 + M_0 \sum_{i=i}^2 m_i P_i}$$
(4.B.3)

の関係がある。この式から、以下の式が導ける。

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial m_i} = M_0 P_i (1 - \phi_i) (1 - \phi) \tag{4.B.4}$$

$$\frac{\partial \phi_j}{\partial m_i} = -M_0 P_i \phi_j (1 - \phi) \tag{4.B.5}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial m_i}\right)_{m_k} = M_0(1-\phi)P_i\left[\left(\frac{\partial}{\partial \phi_i}\right)_{\phi_k} - \sum_{j=1}^2 \phi_j\left(\frac{\partial}{\partial \phi_j}\right)_{\phi_k}\right] \quad (4.B.6)$$

最後の関係式は

$$\left(\frac{\partial n}{\partial m_i}\right)_{T,p,m_k} = M_0(1-\phi)P_i\left[\left(\frac{\partial n}{\partial \phi_i}\right)_{\phi_k} - \sum_{j=1}^2 \phi_j\left(\frac{\partial n}{\partial \phi_j}\right)_{\phi_k}\right]$$
$$= M_0(1-\phi)P_i\tilde{\gamma}_i \tag{4.B.7}$$

を与える。ここで、 $\tilde{\gamma}_i$ は

$$\tilde{\gamma}_i = \gamma_i - \sum_{j=1}^2 \gamma_j \phi_j \tag{4.B.8}$$

$$\gamma_i = \left(\frac{\partial n}{\partial \phi_i}\right)_{\phi_k} \tag{4.B.9}$$

である。

式 (4.B.2) と (4.B.7) を式 (4.B.1) に代入すると、

$$\Delta R_0 = KRTM_0 V_0 (1 - \phi) \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \tilde{\gamma}_i \tilde{\gamma}_j P_i P_j \frac{\psi^{ij}}{|\psi|}$$
(4.B.10)

が得られる。

組成変数を (ϕ_1, ϕ_2) から (ϕ, ξ_1) に変えると式 (4.B.6) は

$$\left(\frac{\partial}{\partial m_1}\right)_{m_2} = M_0(1-\phi)P_1\left[(1-\phi)\left(\frac{\partial}{\partial \phi}\right)_{\xi_1} + \frac{1-\xi_1}{\phi}\left(\frac{\partial}{\partial \xi_1}\right)_{\phi}\right]$$
(4.B.11)

$$\left(\frac{\partial}{\partial m_2}\right)_{m_1} = M_0(1-\phi)P_2\left[(1-\phi)\left(\frac{\partial}{\partial\phi}\right)_{\xi_1} - \frac{\xi_1}{\phi}\left(\frac{\partial}{\partial\xi_1}\right)_{\phi}\right] \quad (4.B.12)$$

となる。これらの関係を用いると、本文中の式 (4.7) から μ_{ij} に対して以下の式が得られる。

$$\frac{\mu_{11}}{RT} = M_0 P_1^2 (1-\phi) \left[\frac{1-\phi_1}{P_1 \phi_1} + \left(1-\frac{1}{P_1}\right) - \left(1-\frac{1}{P_n}\right) \phi - (1-\phi)^2 L - 2(1-\phi)(1-\xi_1)Q + \frac{(1-\xi_1)^2}{\phi} S \right]$$
(4.B.13)

$$\frac{\mu_{22}}{RT} = M_0 P_2^2 (1-\phi) \left[\frac{1-\phi_2}{P_2 \phi_2} + \left(1 - \frac{1}{P_2}\right) - \left(1 - \frac{1}{P_n}\right) \phi - (1-\phi)^2 L + 2(1-\phi)\xi_1 Q + \frac{\xi_1^2}{\phi} S \right]$$
(4.B.14)

$$\frac{\mu_{12}}{RT} = \frac{\mu_{21}}{RT}$$

$$= M_0 P_1 P_2 (1-\phi) \left[1 - \frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_2} - \left(1 - \frac{1}{P_n} \right) \phi - (1-\phi)^2 L - (1-\phi)(1-2\xi_1)Q - \frac{\xi_1 (1-\xi_1)}{\phi} S \right] (4.B.15)$$

ここで、

$$L \equiv -\left(\frac{\partial^2 h}{\partial \phi^2}\right)_{\xi_1} = 2\chi + \phi \left(\frac{\partial \chi}{\partial \phi}\right)_{\xi_1}$$
(4.B.16)

$$Q \equiv \frac{1}{\phi^2} \left[\left(\frac{\partial h}{\partial \xi_1} \right)_{\phi} - \phi \left(\frac{\partial^2 h}{\partial \phi \partial \xi_1} \right) \right] = \left(\frac{\partial \chi}{\partial \xi_1} \right)_{\phi}$$
(4.B.17)

$$S \equiv \frac{1}{\phi} \left(\frac{\partial^2 h}{\xi_1^2} \right)_{\phi} = -\int_0^{\phi} \left(\frac{\partial^2 \chi}{\partial \xi_1^2} \right)_{\phi} d\phi \qquad (4.B.18)$$

である。

式 (4.B.13)、(4.B.14)、(4.B.15) を式 (4.B.10) に代入すると ΔR_0 に対 する本文中の式

$$\frac{KV_0\phi}{\Delta R_0} = \frac{1+\phi(1-\phi)^{-1}P_w - \phi(P_wL+Y)}{WX}$$
(4.B.19)

$$W = \frac{\tilde{\gamma}_1^2 P_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2^2 P_2 \xi_2}{(1-\phi)^2}$$
(4.B.20)

$$X = 1 + \frac{\xi_1 \xi_2}{\tilde{\gamma}_1^2 P_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2^2 P_2 \xi_2} \left\{ (\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)^2 P_1 P_2 \left[1 + \left(\frac{1}{P_n} - 1 \right) \phi \right] \phi - 2(\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)(\tilde{\gamma}_1 P_1 - \tilde{\gamma}_2 P_2) \phi - (\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)^2 P_1 P_2 (1 - \phi)^2 \phi L + 2(\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)(\tilde{\gamma}_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2 \xi_2) P_1 P_2 (1 - \phi) \phi Q + (\tilde{\gamma}_1 \xi_1 + \tilde{\gamma}_2 \xi_2)^2 P_1 P_2 S \right\}$$
(4.B.21)

$$Y = \xi_1 \xi_2 \bigg[2(P_1 - P_2)Q - P_1 P_2 \bigg(\frac{1}{1 - \phi} + \frac{1}{P_n \phi} - L \bigg) S + P_1 P_2 \phi Q^2 \bigg] \quad (4.B.22)$$
が得られる。

4.C 3 成分系に含まれる各 2 成分系の相互作用函数の経験式

ここでは、3 成分系に含まれる各 2 成分の組に対する相互作用函数 L_{ii} あるいは χ_{ii} と χ_{12} の結果を纏める。簡単のため、 $L \equiv L_{ii}$ 、 $\chi \equiv \chi_{ii}$ と記す。ポリイソブチレンのベンゼン溶液の結果が浸透圧測定によるものである他は、いずれも光散乱測定の結果である。

- (A) L **あるいは** χ
 - (i) ポリスチレン+シクロヘキサン系¹³

$$L = 2 \left[\chi_{conc}^{\circ} + \frac{\phi}{2} + \frac{A\phi_1^4}{1 + B\phi^2} + (\chi_{dil}^{\circ} - \chi_{conc}^{\circ}) R_{\phi}(P_1^{1/2}\phi) \right]$$
(4.C.1)

$$\chi_{conc}^{\circ} = 0.4930 + 0.345 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + \left(-\frac{0.075}{P_1^{1/2}} - \frac{45}{P_1^2} + 0.007\right) \\ \times \exp\left[-\left(40 - \frac{520}{P_1^{2/3}}\right) \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right]$$
(4.C.2)

$$\chi_{dil}^{\circ} = 0.5 + 0.26 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + 4.6 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2$$
 (4.C.3)

$$A = 1.4P_1^{1/3} \tag{4.C.4}$$

$$B = 7P_1^{1/3} \exp\left[-18\left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)\right] \tag{4.C.5}$$

$$R_{\phi} = \exp(-P^{1/2}\phi - 0.3P^{3/2}\phi^3) \tag{4.C.6}$$

 $\Theta=307.65 {\rm K}$

(ii) ポリスチレン (M_w =53600)+ベンゼン系 5

$$L = 0.82 + 0.48\phi + 5\phi^2 + (-0.36 + 0.00136T)\exp(-26\phi) \qquad (4.C.7)$$

(iii) ポリイソプレン (M_w =53300)+シクロヘキサン系 ¹⁰

$$L = 0.68 + \left(-0.88 + \frac{680}{T}\right)\phi + 0.170\exp(-47\phi)$$
(4.C.8)

(iv) ポリイソプレン+ジオキサン系¹⁴

$$L = 2\chi_{conc}^{\circ} + \phi + \frac{2A\phi^4}{1 + B\phi^2} + 2(\chi_{conc}^{\circ} - \chi_{dil}^{\circ})R_{\phi}(P^{1/3}\phi)$$
(4.C.9)

$$\chi_{conc}^{\circ} = 0.5 - \frac{0.19}{P^{1/2}} + 0.35 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)$$
(4.C.10)

$$\chi^{\circ}_{dil} = 0.5 + 0.33 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) + 4.1 \left(\frac{\Theta}{T} - 1\right)^2$$
 (4.C.11)

$$A = 2P^{1/3} \tag{4.C.12}$$

$$B = 8.73P^{1/3} - 600\left(\frac{\Theta}{T} - 1\right) \tag{4.C.13}$$

$$R_{\phi} = \exp(-3.3P^{1/3}\phi) \tag{4.C.14}$$

$$\Theta = 307.15$$
K

(B) χ_{12}

すべての $\chi_{12}(\phi,\xi_1)$ は次式で表す。

$$\chi_{12} = k_0 + (k_1\xi_1 + k_2\xi_2)\phi \tag{4.C.17}$$

(vii) ポリスチレン (M_w =53600)+ポリイソプレン (M_w =53300)+シクロヘキサン系 ¹⁰

$$k_0 = 0.44, \quad k_1 = -6.1 + \frac{2000}{T}, \quad k_2 = -4.8 + \frac{1300}{T}$$
(4.C.18)

(viii) ポリスチレン (M_w =447000)+ポリイソプレン (M_w =53300)+シク ロヘキサン系 ¹⁵

$$k_0 = 0.455, \quad k_1 = -6.1 + \frac{2000}{T}, \quad k_2 = -4.8 + \frac{1300}{T}$$
(4.C.19)

(ix) ポリスチレン (M_w =53600)+ポリイソブチレン (M_w =154000)+シ クロヘキサン系 ⁵

$$k_0 = 0.348 + \frac{30}{T}, \quad k_1 = -4.5 + \frac{1507}{T}, \quad k_2 = -0.9$$
 (4.C.20)

(x) ポリスチレン (M_w =53600)+ポリイソブチレン (M_w =152000)+ベンゼン系 ⁵

$$k_0 = 0.454, \quad k_1 = -0.7, \quad k_2 = 0.1$$
 (4.C.21)



図 4.16 ポリスチレン+N, N'ジメチルホルムアミド+シクロヘキサン溶液の双交 曲線

4.D 混合溶媒と高分子から成る3成分系の相平衡

ここでは、ポリスチレン $(M_w=51000)$ (PS)+N, N'ジメチルホルムアミド (DMF)+シクロヘキサン (CH)3 成分系の相平衡を取り扱う。¹⁶ CH を成分 0、PS を成分 1、DMF を成分 2 とする。この系の混合溶媒である CH+DMF2 成分系は低分子の溶液であるにも拘わらず、46 °C 以下において相分離を起こす珍しい系である。(図 4.16 参照) この 3 成分系に含まれている PS+CH2 成分系に対する相互作用函数 $\chi_{11}(\phi_1)$ は補遺 4.C の式 (4.C.1) から求めることができる。

CH+DMF2成分系に対する相互作用パラメータ χ_{22} は、浸透圧や光散 乱測定から決定することができない。そこで、相図をデータからそれを決 定する。このため、Renon と Prausnitz¹⁷が提唱した次式を用いる。

$$\frac{\mu_0 - \mu_0^{\circ}}{RT} = \ln(1 - x_2) + x_2^2 \bigg\{ \frac{\tau_{10} U_1^2}{[(1 - x_2) + x_2 U_1]^2} \bigg\}$$

4.D 混合溶媒と高分子から成る3成分系の相平衡

$$+\frac{\tau_{01}U_0}{[x_2+(1-x_2)U_0]^2}\bigg\}$$
(4.D.1)

$$\frac{\mu_2 - \mu_2^{\circ}}{RT} = \ln x_2 + (1 - x_2)^2 \left\{ \frac{\tau_{01} U_0^2}{[x_2 + (1 - x_2) U_0]^2} + \frac{\tau_{10} U_1}{[(1 - x_2) + x_2 U_1]^2} \right\}$$
(4.D.2)

 $U_0 = \exp(-\alpha \tau_{01}), \quad U_1 = \exp(-\alpha \tau_{10})$ (4.D.3)

ここで、 x_2 は成分 2(DMF) のモル分率、 α は定数である。式 (4.D.1) を 本文の式 (4.4) に代入すると χ_{22} に対して

$$\chi_{22}(\phi_2) = \frac{1}{\phi_2^2} \ln \frac{P_2}{(1-\phi_2)P_2 + \phi_2} - \left(1 - \frac{1}{P_2}\right) \frac{1}{\phi_2} + \frac{\tau_{01}U_0^2}{[P_2(1-\phi_2) + U_0\phi_2]^2} + \frac{\tau_{10}U_1}{[P_2U_1(1-\phi_2) + \phi_2]^2} (4.D.4)$$

が得られる。この式は2つの未知のパラメータ τ_{10} と τ_{01} を含んでいる。 それらは相平衡状態にある2相の組成に対する実験データを式 (4.D.1)と (4.D.2)を用いて解析することによって求めることができる。結果は

$$\alpha = -1, \quad \tau_{10} = 1.417 - \frac{187}{T}, \quad \tau_{01} = -1.020 + \frac{601}{T}$$
(4.D.5)

となる。

相互作用函数 χ_{12} は PS+DMF+CH3 成分溶液についての光散乱測定か ら決定する。採用する式は

$$\chi_{12} = k_0 + (k_1\xi_1 + k_2\xi_2)\phi + (k_3\xi_1^2 + k_4\xi_1\xi_2 + k_5\xi_2^2)\phi^2$$
(4.D.6)

である。結果のみを記すと、得られた係数 $k_i(i = 1, 2, 3, 4, 5)$ は

$$k_0 = 0.020T - 5.25, \quad k_1 = -0.068T + 21.67,$$

 $k_2 = -0.091T + 27.10, \quad k_3 = 0.026T - 7.55,$
 $k_4 = 0.104T - 30.85, \quad k_5 = 0.080T - 22.39$ (4.D.7)

と表される。



図 4.17 ポリスチレン+N, N' ジメチルホルムアミド+シクロヘキサン溶液の双交 曲線と連結線

以上の相互作用函数を用いて計算した双交曲線と連結線に対する結果と 対応する実験結果を図 4.17 に示す。温度 T は 40 °C である。図中の実線 で示した曲線が双交曲線、直線が連結線の計算結果である。丸印が共存組 成でそれらを結んだ破線の曲線が実測の双交曲線、破線の直線が実測の連 結線である。また、三角は相分離前の母溶液の組成を表している。計算結 果と実験結果との一致はあまりよくないが、計算結果は実際の相分離領域 の位置および相図の特徴をよく表している。

参考文献

- 1. Y. Einaga, Prog. Polym. Sci., 19, 1 (1994)
- V. Narasimhan, R. Y.M. Huang, and C. M. Burns, J. Polym. Sci., Polym. Symp., 74, 265 (1986)
- 3. A. Robard and D. Patterson, Macromolecules, 10, 1021 (1977)

- Z. Tong, Y. Einaga, H. Miyashita, and H. Fujita, *Macromolecules*, 20, 1888 (1987)
- Z. Tong, Y. Einaga, T. Kitagawa, and H. Fujita, *Macromolecules*, 22, 450 (1989)
- 6. R. L. Scott, J. Chem. Phys., 17, 268 (1949), ibid, 17, 279 (1949)
- 7. H. Tompa, "Polymer Solutions," Butterworth, London (1956)
- R. Koningsveld, H. A. G. Chemin, and M. Gordon, *Proc. Roy. Soc.*, London, A319, 331 (1970)
- 9. Y. Einaga, Z. Tong, and H. Fujita, Macromolecules, 20, 2027 (1987)
- Z. Tong, Y. Einaga, H. Miyashita, and H. Fujita, *Macromolecules*, 20, 1883 (1987)
- 11. 倉田道夫、「高分子工業化学 III」、朝倉書店、1975.
- 12. T. Fukuda and H. Inagaki, *Macromolecules*, **12**, 1229 (1979)
- Y. Einaga, S. Ohashi, Z. Tong, and H. Fujita, *Macromolecules*, 17, 527 (1984)
- 14. N. Takano, Y. Einaga, and H. Fujita, Polym. J., 10, 1123 (1985)
- 15. Z. Tong, Y. Einaga, and H. Fujita, Polym. J., 19, 965 (1987)
- 16. Y. Einaga, Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ., 66, 140 (1988)
- 17. H. Renon and J. M.=Prausnitz, A. I. Ch. E. J., 14, 135 (1968)

索 引

陰点曲線95
エンタルピー 10
エントロピー7
外界 2
外的束縛条件3
開放系2
化学ポテンシャル16
可逆過程6
拡散平衡の条件 24
下限臨界共溶点38
重なり濃度 53
完全微分 5

Gibbs 自由エネルギー 10
Gibbs-Duhem の式18
Gibbs の相律 3
Gibbs-Helmholtz の関係12
共存曲線37
均一系3

Clausius の等式………7 Clausius の不等式………7

系………1

孤立系2
混合エネルギー43
混合エンタルピー43
混合エントロピー 42
混合 Gibbs 自由エネルギー ·43
シータ温度 45
示強性状態量2
質量濃度22
質量モル濃度21
自発過程6
shadow curve 95
自由度3
重量分率20
主溶媒 14
準安定 37
準静的過程6
準2成分系 89
上限臨界共溶点38
状態変数3
状態量2
示量性状態量2
spinodal ······ 38
成分2

索 引

尖点34	不可逆過程 6
尖点曲線38	不完全微分 ······5
	不均一系3
相3	部分比容
双交曲線37	部分モル体積21
相図37	部分モル量 15
体積分率20	Breitenbach-Wolf プロット…98
体積モル濃度21	Flory-Huggins 理論 39
多相系3	分離因子97
単相系3	平均場近似 41
沈澱占	平衡系3
	平衡状態3
定圧過程5	平衡判定条件 8
梃子の法則 37	閉鎖系2
特性函数11	Helmholtz 自由エネルギー…9
曇点37	母函数11
曇点曲線37	母溶液95
内部エネルギー 4	Maxwell の関係13
++	Maxwell 方程式 69
飘4	
熱エネルギー4	モル Gibbs 自由エネルギー ·20
熱的状態方程式14	モル 質量20
熱力学恒等式8	モル体積20
熱力学第一法則 4	モル 分率20
熱力学第二法則6	揺らぎ
binodal······37	臨界共溶点 37
非平衡系3	臨界線
比容20	
	Kayleigh CL
van't Hoff の式64	連結線37